

วงจรอิเล็กทรอนิกส์กำลังสำหรับการเตรียมฟิล์มบางบนวัสดุรองรับโดยใช้เทคนิค
พัลส์ ดีซี แมกนีตรอน สปีดเตอริง

A Power Electronics Circuit for Thin Films Preparation Using
Pulses DC Magnetron Sputtering Technique

โดย

นาย กฤติน สมานวงษ์

นาย กัณฑ์ณ อยู่ยืนพัฒนา

นางสาว ทิวาพร ขอพิมาย

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีการศึกษา 2555

วงจรอิเล็กทรอนิกส์กำลังสำหรับการเตรียมฟิล์มบางบนวัสดุรองรับโดยใช้เทคนิค
พัลส์ ดีซี แมกนีตรอน สปีดเตอริง

A Power Electronics Circuit for Thin Films Preparation Using
Pulses DC Magnetron Sputtering Technique



ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2555

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับใช้เพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มิให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแบบลงนอกรับรองของฉบับนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเราทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

A Power Electronics Circuit for Thin Films Preparation Using Pulses DC Magnetron Sputtering Technique



KRITTIN SAMANWONG
KANTAPON YOUYUENPATHANA
TIWAPORN KHOPIMAI

A PAPER SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENT FOR
THE DEGREE OF BACHELOR OF ELECTRICAL ENGINEERING

เอกสารนี้เป็นเอกสารของ DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING FACULTY OF ENGINEERING การค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อี KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG ให้นำไปใช้

2012

๕

วงจรอิเล็กทรอนิกส์กำลังสำหรับการเตรียมฟิล์มบางบนวัสดุรองรับโดยใช้เทคนิค
พัลส์ ดีซี แมกนีตรอน สปีดเตอร์ริง

A Power Electronics Circuit for Thin Films Preparation Using
Pulses DC Magnetron Sputtering Technique



อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร. ศิริเดช บุญแสง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ปริญญาานิพนธ์ปีการศึกษา 2555

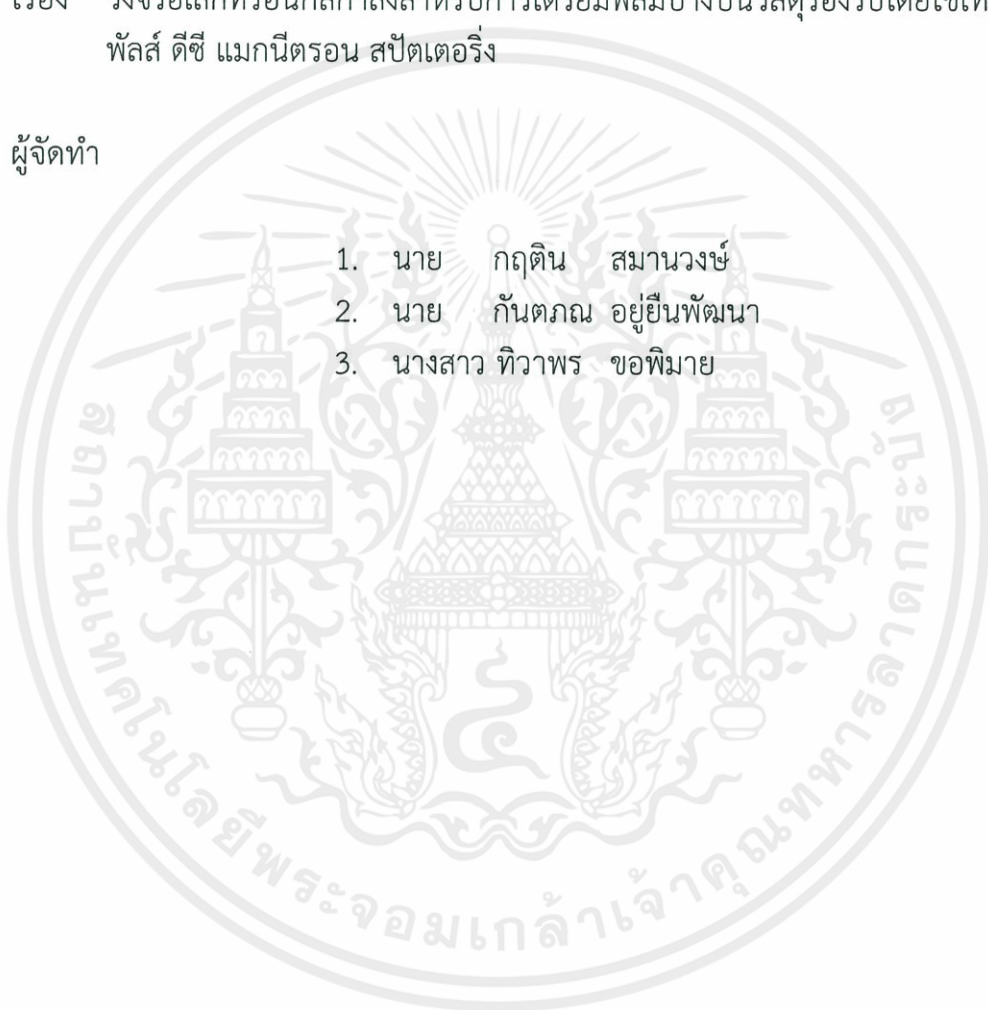
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง วงจรอิเล็กทรอนิกส์กำลังสำหรับการเตรียมฟิล์มบางบนวัสดุรองรับโดยใช้เทคนิค
พัลส์ ดีซี แมกนีตรอน สปีดเตอริง

ผู้จัดทำ

1. นาย กฤติน สมานวงษ์
2. นาย กันตภณ อยู่ยืนพัฒนา
3. นางสาว ทิวาพร ขอพิมาย



..... อาจารย์ที่ปรึกษา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริเดช บุญแสง)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

วงจรถ่ายฟิล์มบางสำหรับการเตรียมฟิล์มบางบนวัสดุรองรับโดยใช้เทคนิค
ฟิล์ม ดีซี แมกนีตรอน สปีดเตอริง

นาย กฤติน สมานวงษ์
นาย กัณฑ์ณ อยู่ยืนพัฒนา
นางสาว ทิวาพร ขอพิมาย
ผศ. ดร. ศิริเดช บุญแสง อาจารย์ที่ปรึกษา
ปีการศึกษา 2555

บทคัดย่อ

บทความฉบับนี้เป็นรายงานผลการออกแบบสร้างแหล่งจ่ายไฟฟ้าดีซีฟิล์ม สำหรับประยุกต์ใช้ในเครื่องเคลือบฟิล์มบางชนิดดีซีแมกนีตรอนสปีดเตอริง ออกแบบโดยใช่วงจรฟูลบริดจ์ อินเวอร์เตอร์เฟสเดียวมาแบ่งจ่ายแยกแต่ละกึ่งด้วยแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันสูงแบบปรับค่าได้ และนำเสนอการเคลือบฟิล์มบางโดยใช้เทคนิคดีซีฟิล์ม สร้างขบวนการดีซีฟิล์มด้วยการโปรแกรม ไมโครคอนโทรลเลอร์และจัดให้สามารถสั่งการควบคุมได้จากหน้าจอบริการคอมพิวเตอร์ ซึ่งขบวนการแรงดันที่ออกมาจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าดีซีฟิล์มนั้นจะต้องปรับแรงดันได้ด้วยการปรับแรงดันของชุดแหล่งจ่ายแรงดันปรับค่าได้ และสามารถปรับค่าความกว้างฟิล์มได้ตามต้องการ ทดสอบชิ้นงานด้วยการนำไปเคลือบฟิล์มบางบนวัสดุรองรับด้วยวิธีดีซีฟิล์ม จากผลการทดสอบพบว่า การเคลือบฟิล์มบางบนผิววัสดุรองรับด้วยเทคนิคดีซีฟิล์มนั้นจะไม่ทำให้วัสดุรองรับมีอุณหภูมิสูงเกินไป เหมาะสมสำหรับใช้เคลือบผิววัสดุที่ทนความร้อนได้ไม่มาก และเหมาะสมกับการนำไปใช้งานจริง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

A Power Electronics Circuit for Thin Films Preparation Using Pulses DC Magnetron Sputtering Technique

KRITTIN SAMANWONG
KANTAPON YOUYUENPATHANA
TIWAPORN KHOPIMAI
ASST.PROF. SIRIDECH BOONSAENG Supervisor
Year 2012

ABSTRACT

This paper presents a design and construction of a DC Pulse Power Supply for DC magnetron sputtering thin film coating applications. The power electronics part is designed and constructed by using two variable voltage power supply feed on single phase full bridge inverter separately each branch. The technique presented for thin film coating is DC pulse technique. The DC pulse controlled signal is generated by digital signal peripheral interface controller and provided the computer LCD as control panel. The well designed DC pulse power supply must have voltage and period adjustable. The performance of the DC pulse power supply has been examined by real thin film coating with DC Pulse technique. The test results show that the DC pulse technique gave a better thermal characteristic of coating. So the DC pulse technique is more suitable for the substrate that cannot bared high temperature and it is the most suitable technique for all thin film coating application today.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

กิตติกรรมประกาศ

ปริญญาบัตรฉบับนี้ได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี คณะผู้จัดทำได้ศึกษาค้นคว้าอย่างทุ่มเท และรู้สึภาคภูมิใจกับความสำเร็จ หากแต่ความสำเร็จไม่ได้ลุล่วงมาด้วยตัวคนเดียว ทางผู้จัดทำจึงขอขอบพระคุณบุคคลเหล่านี้เพื่อตอบแทนความเมตตา ความช่วยเหลือ และความรู้ที่ได้จากบุคคลเหล่านี้

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าทุกท่านที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อุปกรณ์การทดลองต่างๆ

ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริเดช บุญแสง อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ซึ่งประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ความรู้ คำแนะนำ และแง่คิดในการทำงาน ตลอดจนให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ จนโครงการวิจัยสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ขอขอบคุณ คุณศิวพล จันทร์คุณภาส (พีปาล์ม) และ คุณหทัยจิต อิศระบุตร (พีโบว์) ที่ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ถึงขั้นหามรุ่งหามค่ำ

ขอขอบคุณเพื่อนร่วมกลุ่มคณะผู้จัดทำทุกคน มิตรภาพของเพื่อนทำให้พวกเราทำสำเร็จได้ในวันนี้ เมื่อแยกย้ายกันไป เราจะไม่ลืมกัน

ขอขอบคุณ ดร.ราชศักดิ์ (อาจารย์ฉิน) และ คุณพิจิตร (พี่ยอ) ที่สละเวลาและเอื้อเฟื้ออุปกรณ์การทดลองพร้อมคำแนะนำต่างๆ ซึ่งเป็นพระคุณกับผู้จัดทำอย่างมาก

สุดท้าย ขอขอบพระคุณ บิดา มารดา ผู้ให้กำเนิด ที่คอยให้คำปรึกษา คำแนะนำต่างๆ และให้กำลังใจอยู่เสมอไม่ห่างทำให้ลูกต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ได้โดยไม่ย่อท้อ วันนี้ลูกสำเร็จแล้ว ลูกจะไม่ทำให้ท่านผิดหวัง ลูกจะตอบแทนพระคุณให้ถึงที่สุด

คุณค่า คุณประโยชน์ที่มีจากปริญญาบัตรฉบับนี้ ขอมอบแด่ผู้มีพระคุณทุกท่าน

คณะผู้จัดทำ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อ	I
ABSTRACT	II
กิตติกรรมประกาศ	III
สารบัญ	IV
สารบัญรูป	VI
สารบัญตาราง	VIII
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย	1
1.3 ขอบเขตและข้อกำหนดของโครงการ	1
1.4 วิธีการใช้ในโครงการ	1
1.5 แผนการดำเนินโครงการ	2
1.6 ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย	2
บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	3
2.1 ทฤษฎีและหลักการพื้นฐานของการเคลือบผิวด้วยฟิล์มบาง	3
2.1.1 สเปคเตอรืง	3
2.1.2 ทฤษฎีการสเปคเตอรืง	3
2.1.3 Precursor Gas	3
2.1.4 กลไกการเกิดการสเปคเตอรืง (Sputtering Mechanism)	3
2.1.5 อัตราการเกิดสเปคเตอรืง (Sputtering Rate)	4
2.1.6 แมกนีตรอน สเปคเตอรืง (Magnetron Sputtering)	5
2.1.7 การก่อตัวของฟิล์มบางบนวัสดุรองรับ (Thin Film Growth)	5
2.1.8 พัลส์ดีซี สเปคเตอรืง	6
2.2 แหล่งจ่ายไฟฟ้าดีซีพัลส์ (DC Pulses Power Supply)	6
2.2.1 อุปกรณ์สวิตช์ (MOSFET)	7
2.2.2 แหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูงปรับค่าได้ (High Voltage Variable Power Supply)	10
2.2.3 ห้องสุญญากาศ (Vacuum Chamber)	11
2.2.4 ขบวนรูปคลื่น ดีซี พัลส์ (DC Pulses Train)	11
2.2.5 การสวิตชิงของวงจร H-Bridge	15
2.3 ไมโครคอนโทรลเลอร์ (dsPIC30F4011)	15
2.3.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์	15
2.3.2 สถาปัตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร์	16
2.3.3 หน่วยประมวลผลกลาง หรือซีพียู นั้น ไม่นิยามให้นำไปใช้	17
2.3.4 หน่วยความจำ	17
2.3.5 หน่วยความจำพิเศษ	18

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หากมีการนำเอกสารนี้ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตให้ถือว่าผิดกฎหมายและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีโอกาสให้นำไปใช้

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
2.3.6 การทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์	19
2.4 โครงสร้างและสถาปัตยกรรมของ dsPIC30F4011	20
2.5 พอร์ตอนุกรม	21
บทที่ 3 การออกแบบและสร้างวงจรดิจิทัลเพาเวอร์ซัพพลาย	23
3.1 การจำลองวงจร (Simulation)	23
3.2 การสร้างวงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้าดิจิทัล	24
3.2.1 การสร้างวงจรกำลัง	24
3.2.2 การสร้างวงจรควบคุม	26
3.2.3 การสร้างสัญญาณขับเคลื่อนขั้วเกตดิจิทัลด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์	29
3.3 การสร้างการควบคุมผ่านคอมพิวเตอร์ (Computer Control Panel)	35
3.4 ลายปรี้นของวงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้าดิจิทัล	38
บทที่ 4 ผลการทดลอง	42
4.1 ผลการทดสอบแหล่งจ่ายไฟฟ้าดิจิทัล	42
4.2 ผลการทดสอบแหล่งจ่ายไฟฟ้าดิจิทัลเมื่อทดลองเคลือบฟิล์มบาง	45
4.3 สรุปผลการทดลอง	48
บทที่ 5 บทสรุปผลการทดลอง ข้อเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนา	49
5.1 บทสรุป	49
5.2 ข้อเสนอแนะและข้อควรระวัง	49
5.3 ปัญหาที่พบในการทำโครงงาน	49
5.4 แนวทางการพัฒนาโครงงาน	50
เอกสารอ้างอิง	51
ภาคผนวก	54
ประวัติผู้เขียน	66

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
2.1 ภายในห้องสุญญากาศเมื่อเตรียมการสปีดเตอร์ริง	3
2.2 อัตราการเกิดสปีดเตอร์ริง	4
2.3 แมกนีตรอนสปีดเตอร์ริง	5
2.4 การก่อดัวของฟิล์มบางบนผิววัสดุรองรับ	5
2.5 วงจร DC Pulses Power Supply	7
2.6 โครงสร้างของมอสเฟตแบบ N และ P ชนิดดีฟิซิลัน	8
2.7 โครงสร้างของมอสเฟตแบบ N และ P ชนิดเอานฮานซ์เมนต์	9
2.8 กราฟคุณลักษณะในการถ่ายโอนของอีมอสเฟตแบบแชลแนล N และคุณลักษณะเอาท์พุทของอีมอสเฟตแบบแชลแนล N	9
2.9 รูปคลื่นแรงดันในการสวิตช์ของแรงดันเกท	10
2.10 โหมดการทำงานแบบ Asymmetric Bipolar	13
2.11 รูปคลื่นแรงดันขาออกแบบอะซิมเมตริกไปโพล่า	13
2.12 รูปคลื่นขาออกแบบอะซิมเมตริกไปโพล่าที่มีหลายพัลส์ต่อชั่ว	14
2.13 โครงสร้างและส่วนประกอบหลักเบื้องต้นของไมโครคอนโทรลเลอร์	15
2.14 โครงสร้างสถาปัตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร์แบบพรีนซ์ตัน หรือ ฟอน นิวแมน	16
2.15 โครงสร้างสถาปัตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร์แบบฮาร์วาร์ด	16
2.16 ส่วนประกอบหลักของซีพียูในไมโครคอนโทรลเลอร์	17
2.17 ตัวถังของ dsPIC30F4011 และตำแหน่งขาสัญญาณต่างๆ	20
2.18 การเชื่อมต่ออุปกรณ์อุปกรณ์ภายนอกเข้ากับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย DB9	21
2.19 การต่ออุปกรณ์ภายนอกผ่าน DB9 แบบ 3 เส้น	22
3.1 Block Diagram ของระบบ	23
3.2 การจำลองแหล่งจ่ายไฟฟ้าดีซีพัลส์ด้วยโปรแกรม MATLAB Simulink	23
3.3 แรงดันขาออกจากวงจรที่ได้จากการจำลองด้วยโปรแกรม MATLAB Simulink	24
3.4 รูปแบบวงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้าดีซีพัลส์	25
3.5 วงจรกำลังที่สร้างขึ้นจริง	25
3.6 มอสเฟตกำลัง 2SK1317	25
3.7 แหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูงปรับค่าได้ที่ใช้ในการทำการทดลอง	26
3.8 วงจรไฟเลี้ยงกระแสตรง 15 V เพื่อเป็นไฟเลี้ยงบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์	26
3.9 วงจรไฟเลี้ยงที่สร้างขึ้นจริง	26
3.10 บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ รุ่น dsPIC30F4011	27
3.11 หลักการทำงานของออปโตคัปเปิล	27
3.12 วงจรขับเคลื่อนและแยกกราวด์งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า	28
3.13 ภาพรวมของวงจรควบคุม	28
3.14 รูปวงจรขับเคลื่อนและวงจรออปโตไอโซเลเตอร์ที่สร้างขึ้นจริง	29

สารบัญรูป(ต่อ)

รูปที่	หน้า
3.15 วงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้าดีซีฟิลส์ต้นแบบที่สร้างขึ้นจริง	29
3.16 โฟลวชาร์ตของโปรแกรมหลัก	30
3.17 โฟลวชาร์ตของวงจรรย่อย	31
3.18 สัญญาณข้อผิดพลาดของมอสเฟต S1 (บน) และมอสเฟต S2 (ล่าง)	32
3.19 สัญญาณข้อผิดพลาดของมอสเฟต S3 (บน) และมอสเฟต S4 (ล่าง)	32
3.20 สัญญาณข้อผิดพลาดของมอสเฟต S2 (บน) และมอสเฟต S3 (ล่าง)	33
3.21 สัญญาณข้อผิดพลาดของมอสเฟต S1 (บน) และมอสเฟต S3 (ล่าง)	33
3.22 สัญญาณข้อผิดพลาดของมอสเฟต S2 (บน) และมอสเฟต S4 (ล่าง)	34
3.23 สัญญาณแรงดันขาออกของวงจรกำลังแบบซิมเมตริกไบโพล่า	34
3.24 พอร์ตอนุกรมของบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์	35
3.25 การเชื่อมต่ออนุกรมระหว่างคอมพิวเตอรืและไมโครคอนโทรลเลอร์	35
3.26 อินเตอร์เฟสเพื่อควบคุมแหล่งจ่ายไฟฟ้าดีซีฟิลส์	37
3.27 รูปคลื่นฟิลส์ที่ถูกควบคุมผ่านโปรแกรม Visual Basic 6.0	37
3.28 ก) ลายวงจร H-Bridge ด้านบน ข) ลายวงจร H-Bridge ด้านล่าง	38
3.29 ก) ลายวงจรข้อผิดพลาดด้านบน ข) ลายวงจรข้อผิดพลาดด้านล่าง	39
3.30 ก) ลายวงจรไฟเลี้ยงด้านบน ข) ลายวงจรไฟเลี้ยงด้านล่าง	40
4.1 แรงดันขาออกในโหมด Positive DC	42
4.2 แรงดันขาออกในโหมด Negative DC	42
4.3 แรงดันขาออกในโหมด Positive Unipolar	43
4.4 แรงดันขาออกในโหมด Negative Unipolar	43
4.5 แรงดันขาออกในโหมด Symmetric Bipolar	44
4.6 แรงดันขาออกในโหมด Asymmetric Bipolar	44
4.7 ชิ้นงานที่ต้องการจะเคลือบภายในห้องสุญญากาศก่อนทำการเคลือบ	45
4.8 ตู้ควบคุมห้องสุญญากาศ	46
4.9 ต่อแหล่งจ่าย Pinnacle 2/2 kW เข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้าดีซีฟิลส์	46
4.10 รูปคลื่นอะซิมเมตริกไบโพล่าที่ใช้ในการเคลือบฟิล์มบาง	47
4.11 ภายในห้องสุญญากาศขณะเกิดปฏิกิริยาสปีดเตอริง	47
4.12 ชิ้นงานที่ถูกเคลือบฟิล์มอะลูมิเนียมเรียบร้อยแล้ว	48

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
1.1	แผนการดำเนินโครงการ	2
2.1	โหมดการทำงานของวงจร H-Bridge ในแหล่งจ่ายไฟฟ้าดีซีพัลส์	11



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ฟิล์มบางสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้มากมาย เช่น ฟิล์มบางชนิด อินเดียมทินออกไซด์ ถูกนำมาใช้ประโยชน์มากมาย ไม่ว่าจะเป็นขั้วไฟฟ้าโปร่งแสงสำหรับจอภาพแสดงผล เซลล์แสงอาทิตย์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆอีกมากมาย ฟิล์มที่ดีจะต้องมีค่าสภาพต้านทานต่ำ ในปัจจุบันได้มีการเตรียมฟิล์มบางลงบนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ที่มีน้ำหนักเบา และจอภาพ (Touch Panel Display) อย่างไรก็ตามวัสดุรองรับที่เป็นพลาสติกจะทนความร้อนได้ไม่สูง และเทคนิคในการเตรียมฟิล์มบางที่เรียกว่า ดีซี แมกนีตรอน สเปตเตอริง (DC Magnetron Sputtering) หรือ ดีซี สMOOTH (DC Smooth) นั้นจะทำให้เกิดความร้อนสูงบนวัสดุรองรับ ซึ่งส่งผลเสียต่อวัสดุรองรับ ในปริญญา นินท์นี้จึงได้นำเสนอเทคนิคการเคลือบฟิล์มบางที่เรียกว่า ดีซี พัลส์ (DC Pulses) ซึ่งเทคนิคนี้นั้นสามารถจะควบคุมกำลังไฟฟ้าขาออกที่จ่ายไปยังห้องเคลือบฟิล์มได้ ซึ่งเราสามารถกำหนดค่ากำลังไฟฟ้าที่เหมาะสมต่อการเคลือบฟิล์มบางได้

เทคนิคดีซีสMOOTHและดีซีพัลส์นั้นให้คุณลักษณะการเคลือบวัสดุรองรับต่างกัน เช่น แรงดันการเคลือบกระแสพลาสมา เป็นต้น การใช้เทคนิคดีซีพัลส์เหมาะกับวัสดุรองรับที่ทนอุณหภูมิได้ไม่สูงนัก เนื่องจากการเคลือบนั้นไม่มีความต่อเนื่อง และผลของความต่างศักย์ในการเคลือบนั้นต่ำกว่า เทคนิคดีซีสMOOTHถึง 160 ถึง 170 โวลต์ ซึ่งส่งผลต่อพลังงานในการสเปตเตอริงอะตอมและอุณหภูมิของวัสดุรองรับ

ดังนั้น ปริญญา นินท์เล่มนี้จึงได้นำเสนอการเคลือบฟิล์มบางบนวัสดุรองรับด้วยเทคนิคดีซีพัลส์เพื่อนำเสนอการศึกษา การทดลองซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยต่อไปในอนาคต

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์กำลังที่เหมาะสมสำหรับการเคลือบฟิล์มบาง
2. เพื่อศึกษาคุณลักษณะของการเคลือบฟิล์มบางด้วยเทคนิคดีซีพัลส์
3. เพื่อศึกษาวิธีการเคลือบฟิล์มบางด้วยเทคนิคดีซีพัลส์
4. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเคลือบฟิล์มบาง

1.3 ขอบเขตและข้อกำหนดของโครงการ

1. ออกแบบสร้างวงจรอิเล็กทรอนิกส์กำลังสำหรับการเคลือบฟิล์มบาง
2. ศึกษาผลของการเคลือบฟิล์มบางด้วยเทคนิคดีซีพัลส์
3. ออกแบบสร้างระบบควบคุมที่เหมาะสมสำหรับการเคลือบฟิล์มบาง

1.4 วิธีการที่ใช้ในโครงการ

1. ออกแบบและสร้างวงจรอินเวอร์เตอร์เฟสเดียวแบบฟูลบริดจ์เพื่อใช้เป็นวงจรที่ส่งผ่านกำลังไฟฟ้าเข้าสู่ห้องเคลือบฟิล์มบาง
2. ออกแบบการควบคุมแหล่งจ่ายไฟฟ้าดีซีพัลส์โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์
3. ควบคุมกระบวนการทั้งหมดโดยใช้การควบคุมผ่านพอร์ตอนุกรม

1.5 แผนการดำเนินโครงการ

แผนดำเนินโครงการ / เดือน พ.ศ. 2555	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.
1) ศึกษาทำความเข้าใจวิธีการเคลือบฟิล์มบางด้วยวิธีแมกนีตรอนสปัตเตอริง	↔							
2) ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์กำลังสำหรับการเคลือบฟิล์มบาง		↔						
3) สร้างวงจรตามที่ได้ออกแบบไว้			↔					
4) สร้างรูปขบวนคลื่นดีซีพัลส์ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ และทำให้สามารถควบคุมพารามิเตอร์ได้ด้วยคอมพิวเตอร์			↔					
5) นำ Hardware และ Software ที่สำเร็จแล้วไปทดลองเคลือบแผ่นฟิล์มบาง					↔			
6) บันทึกและสรุปผลการทดลอง							↔	
7) สำเร็จปริญญาโท								↔

ตารางที่ 1.1 แผนการดำเนินโครงการ

1.6 ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

1. ได้ศึกษาเทคนิคการเคลือบฟิล์มบางด้วยเทคนิคดีซีพัลส์
2. ได้ค้นคว้างานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องจนสามารถคิดค้น สร้าง และควบคุมการเคลือบผิววัสดุด้วยฟิล์มบาง
3. การวิจัยก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมได้
4. การวิจัยก่อให้เกิดการพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถให้มีความสามารถและทักษะมากยิ่งขึ้นเพื่อป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมการเคลือบฟิล์มบาง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1 ทฤษฎีและหลักการพื้นฐานของการเคลือบผิวด้วยฟิล์มบาง

การเคลือบฟิล์มบางด้วยวิธีแมกนีตรอนสปัตเตอริงเป็นวิธีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมานานมากแล้ว นักวิจัยในยุคสมัยต่างๆ ต่างเห็นพ้องต้องกันว่าวิธีการเคลือบฟิล์มบางด้วยวิธีแมกนีตรอนสปัตเตอริงนั้นเป็นวิธีที่เหมาะสมทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติมากที่สุด

2.1.1 สปัตเตอริง คือ การทำให้อะตอมแตกตัวออกจากผิวด้วยพลังงานจากไอออนปรากฏการณ์สปัตเตอริงนั้นถูกค้นพบครั้งแรกโดย เซอร์ วิลเลียม โรเบิร์ต โกรฟ (Sir William Robert Grove) ผู้ซึ่งสร้างเซลล์เชื้อเพลิง

2.1.2 ทฤษฎีการสปัตเตอริง การสปัตเตอริงนั้นคือกระบวนการที่เรียกว่า “Physical Vapor Deposition” โดยในห้องสุญญากาศ (Vacuum Chamber) นั้น จะมีสารเคลือบ (Source of Coating Material) หรือที่เรียกกันว่า “Target” ติดตั้งอยู่ตรงข้ามกับวัสดุรองรับ หรือ “Substrate” ห้องสุญญากาศจะถูกปรับให้มีความดัน 10^{-6} ถึง 10^{-10} ทอร์ (10^{-4} ถึง 10^{-8} ปาสคาล) รูปภาพภายในห้องสุญญากาศแสดงดังรูป



รูปที่ 2.1 ภายในห้องสุญญากาศเมื่อเตรียมการสปัตเตอริง

2.1.3 Precursor Gas คือ ก๊าซที่ใช้ในการให้พลังงานไอออนแก่ทาร์เกต ก๊าซที่เป็นที่นิยมคือก๊าซอาร์กอน (Argon) เนื่องจากมีมวลที่พอเหมาะและราคาสมเหตุสมผล ก๊าซอาร์กอนจะถูกฉีดเข้าไปในห้องสุญญากาศด้วยความดัน 1 ถึง 100 มิลลิทอร์ (0.1 ถึง 1 ปาสคาล) เมื่อก๊าซถูกป้อนด้วยกำลังไฟฟ้าลบประมาณ 0.5 ถึง 5 กิโลโวลต์ ก๊าซอาร์กอนจะเกิดการแตกตัวเป็นไอออนและพลาสมา ไอออนบวกจะพุ่งขึ้นไปหาขั้วลบซึ่งมีทาร์เกตรองรับอยู่ทำให้อะตอมของทาร์เกตหลุดออกมา

2.1.4 กลไกการเกิดการสปัตเตอริง (Sputtering Mechanism) เมื่อไอออนได้พุ่งเข้าชนขั้วแคโทดซึ่งเป็นที่อยู่ของทาร์เกตแล้ว จะเกิดปฏิกิริยา Back scattering , X-Ray Emission , Photon Generation , Secondary Electron Emission และ Gas Atom Desorption ขึ้นที่ผิวสารเคลือบ (Target) เมื่ออนุภาคไอออนได้พุ่งเข้าชนผิวทาร์เกตด้วยพลังงานที่สูงพอ จะทำให้พันธะ

อะตอมทาร์เกตสลายตัวและอนุภาคจะแตกกระจายออกมาจากผิวทาร์เกตอะตอมที่กระจายออกเหล่านี้จะเรียกว่า “สปัตเตอร์อะตอม” (Sputtered Atom)

การสปัตเตอร์สามารถแบ่งออกได้เป็นสี่ระดับพลังงาน ตั้งแต่ระดับใกล้เคียงค่าพลังงานยึดเหนี่ยวจนถึงระดับหลายเมกกะอิเล็กตรอนโวลต์

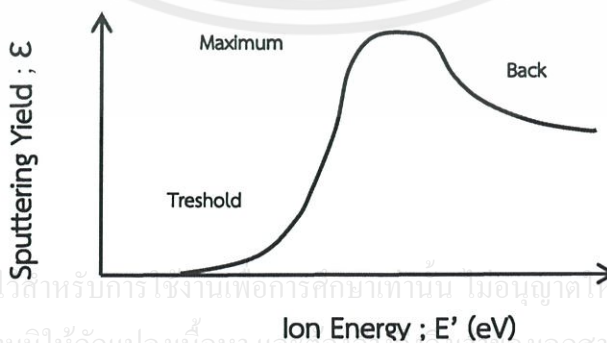
2.1.4.1 ระดับพลังงานต่ำมาก (Very Low Energy) มีระดับพลังงานน้อยกว่า 30 ถึง 50 eV ในระดับนี้จะมีสปัตเตอร์อะตอมน้อยมาก และมีหลายพื้นที่บนผิวที่ได้รับพลังงานไม่ถึงระดับเริ่มแรกของการแตกตัว (Sputter Treshold)

2.1.4.2 ระดับพลังงานแบบชนเดี่ยว (Single Knock-on Energy) มีระดับพลังงานต่ำกว่า 1 keV พลังงานระดับนี้ยังถือว่าต่ำอยู่ แต่ก็เพียงพอที่จะทำให้เกิดการแตกตัวของอะตอมในรูปแบบ Single Knock-on ซึ่งเมื่อไอออนพุ่งมาชนอะตอมของทาร์เกตแล้วอะตอมบนผิว Target ที่ถูกชนก็จะกระเด็นไปชนอะตอมบนผิวตัวอื่นจนเกิดสปัตเตอร์อะตอมขึ้นมา อะตอมที่ถูกชนจากตัวแรกไปจนตัวสุดท้ายจะมีโมเมนตัมมากพอทำให้พันธะสลายตัว โดยอย่างน้อยอะตอมต้องชนกันถึงสี่ทอดจึงจะมีโมเมนตัมมากพอที่จะเกิดสปัตเตอร์อะตอม ระดับพลังงานระดับนี้ถูกนำไปใช้ในการประยุกต์ทางด้านสปัตเตอร์ริงมากที่สุด

2.1.4.3 ระดับพลังงานแบบโคลิชั่น-คาสเคด (Collision-Cascade Sputtering) เกิดขึ้นที่ระดับพลังงาน ระหว่าง 1 keV จนถึง 50 keV อนุภาคไอออนที่ได้รับพลังงานระดับนี้เมื่อพุ่งมาปะทะกับผิว Target จะมีพลังงานมากพอที่จะทำให้พันธะของกลุ่มอะตอมในบริเวณที่ถูกชนนั้นถูกทำลายทั้งหมด ในขณะที่ชนนั้น อะตอมบนผิวจะชนต่อกันไปเป็นลูกโซ่แผ่เป็นวงกว้าง และเกิดการแทนที่อะตอมเดิมโดยอะตอมที่ถูกชนมาไปเรื่อยๆ อะตอมที่ถูกแทนที่ก็จะไปแทนที่อะตอมอื่นไปเรื่อยๆ จึงเรียกว่าการชนแบบคาสเคด (Collision-Cascade) อย่างไรก็ตาม ในระดับพลังงานนี้ไม่เหมาะกับการนำมาใช้กับการประยุกต์ทางด้านเมกนีตรอนสปัตเตอร์ริงเท่าใดนัก

2.1.4.4 ระดับพลังงานสูง (High Energy Implantation) เกิดขึ้นที่ระดับพลังงานสูงกว่า 50 keV ในระดับนี้ อนุภาคไอออนซึ่งมีพลังงานสูงมากจะพุ่งชนผิวทาร์เกตอย่างแรง จนทำให้สามารถเข้าไปอยู่ในเนื้อสารเคลือบทาร์เกตได้ก่อนที่พลังงานจะหมด สปัตเตอร์อะตอมที่ได้จะน้อยเพราะการคายพลังงานส่วนใหญ่ของอนุภาคไอออนจะเกิดขึ้นในเนื้อสารเคลือบซึ่งอยู่ไกลจากพื้นผิวเกินไป ระดับพลังงานนี้จะใช้กับการประยุกต์ด้านการสร้างอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ (Semiconductor Device Fabrication)

2.1.5 อัตราการเกิดสปัตเตอร์ริง (Sputtering Rate) การเกิดสปัตเตอร์ริงนั้นขึ้นอยู่กับพลังงานในตัวไอออนของอนุภาคส่งผ่านพลังงาน (Bombardment Particle) ซึ่งก็คือก๊าซอาร์กอน

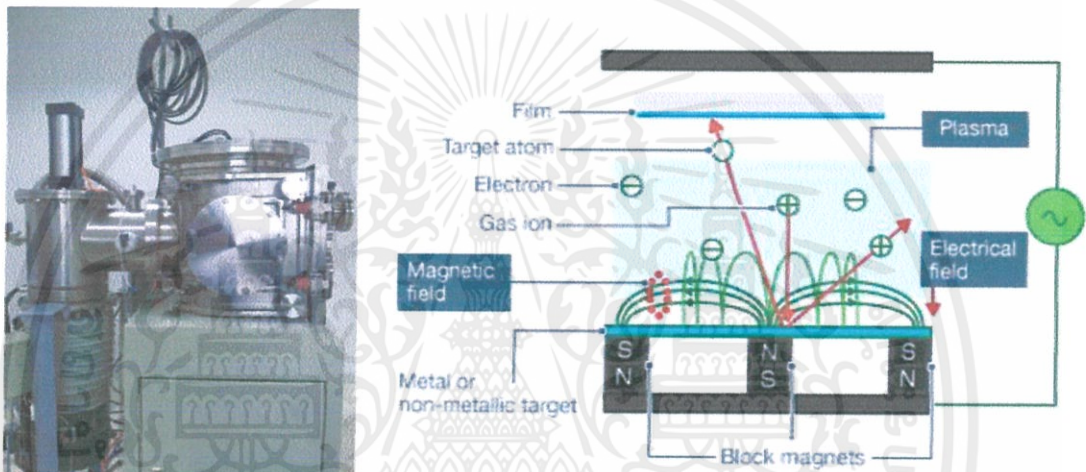


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

รูปที่ 2.2 อัตราการเกิดสปัตเตอร์ริง

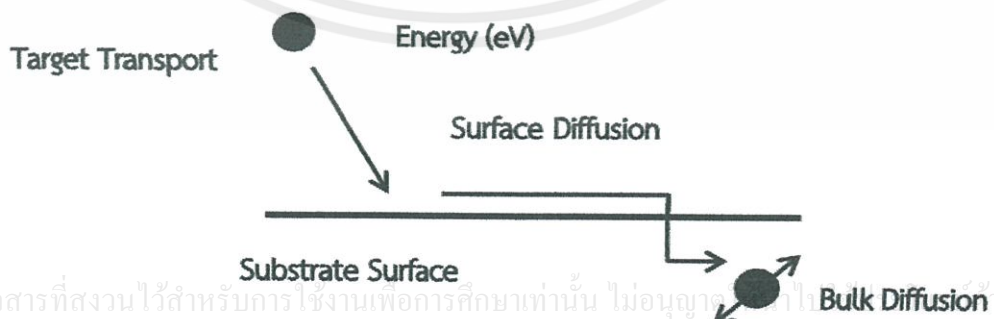
2.1.6 แมกนีตรอน สเปตเตอริง (Magnetron Sputtering) คือ การสเปตเตอริงด้วยการนำสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Crossed Field) เพิ่มเข้าไปเพื่อช่วยดักจับอิเล็กตรอนอิสระทำให้เกิดกระแสพลาสมามากขึ้น แมกนีตรอนสเปตเตอริงนั้นจะให้อัตราการเคลือบฟิล์มบางที่สูงกว่า ได้พื้นที่ในการเคลือบวัสดุมากกว่า แรงดันในการเคลือบต่ำกว่า และอุณหภูมิที่วัสดุรองรับต่ำกว่าวิธีอื่นอนแมกเนติกดีซีสเปตเตอริงในพลังงานที่เท่ากัน

แมกนีตรอนสเปตเตอริงนั้นจะมีแม่เหล็กจัดวางอย่างเป็นระบบอยู่ใต้ห้องสุญญากาศ เพื่อเพิ่มพลังงานให้แก่อนุภาคอิสระ ทำให้เกิดอนุภาคความหนาแน่นสูง เพิ่มความน่าจะเป็นในการชนอิเล็กตรอนของไอออน ดังนั้น อิเล็กตรอนความหนาแน่นสูงจะทำให้เกิด พลาสมาหนาแน่นสูงขึ้นใกล้กับขั้วแคโทด ทำให้อัตราการเคลือบผิวสูงขึ้น



รูปที่ 2.3 แมกนีตรอนสเปตเตอริง

2.1.7 การก่อตัวของฟิล์มบางบนวัสดุรองรับ (Thin Film Growth) การก่อตัวของฟิล์มบางบนวัสดุรองรับเกิดขึ้นในสามขั้นตอน ขั้นตอนแรกคือการพาสารที่จะใช้เคลือบ (Coating Species) ไปสู่วัสดุรองรับ (Substrate) ขั้นตอนที่สองคือ การดูดซึมสารเคลือบเข้าสู่ผิวของวัสดุรองรับ และขั้นตอนสุดท้าย คือ การเคลื่อนที่เข้าสู่ตำแหน่งที่เหมาะสมของสารเคลือบบนผิววัสดุรองรับ



รูปที่ 2.4 การก่อตัวของฟิล์มบางบนผิววัสดุรองรับ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้เผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดลอกหรือทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต ทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ในกรณีการเคลือบผิววัสดุรองรับด้วยวิธีการสปัตเตอร์ริงนั้น ตัวแปรที่ส่งผลต่อคุณสมบัติของกระบวนการนิวเคลียสเอชัน (Nucleation) พลังงานจลน์ในการก่อตัวของฟิล์ม และโครงสร้างของการก่อตัวของฟิล์มคือ วัสดุที่ใช้เป็นฟิล์ม (สารเคลือบ) พลังงานของอนุภาคฟิล์ม พลังงานจลน์ของอนุภาคฟิล์มที่ผิวของวัสดุรองรับ อุณหภูมิในการก่อตัว พลังงานของสิ่งเจือปน และความสะอาดบนผิวของวัสดุรองรับ (Substrate)

หากผู้อ่านต้องการข้อมูลเรื่องการก่อตัวของแผ่นฟิล์มบางโดยละเอียด สามารถสืบค้นอ้างอิงได้ที่ [1]

2.1.8 พัลส์ดีซี สปัตเตอร์ริง การเคลือบฟิล์มบางโดยวิธีอื่น เช่น RF Sputtering นั้นจะมีปัญหาคือ เมื่อวัสดุรองรับถูกเคลือบ จะมีอะตอมของวัสดุรองรับบางส่วนหลุดออกมาจากผิว ถูกชาร์จโดยไอออนบวกผ่านพลาสมาและพุ่งเข้ามาเกาะที่ผิวของทาร์เกตก่อตัวเป็นชั้น ถ้าหากชั้นของวัสดุรองรับนั้นสามารถทนความเครียดสนามไฟฟ้าได้เป็นค่านันต์ ศักย์ของชั้นวัสดุนั้นจะมีค่าเท่ากับศักย์ของแหล่งจ่ายไฟตรงที่ป้อนเข้ามาทำให้ไม่มีความต่างศักย์ระหว่างไอออนและอิเล็กตรอน ซึ่งจะส่งผลให้กระบวนการทางพลาสมาหยุดลง แต่ในความเป็นจริงนั้นชั้นของวัสดุรองรับที่ก่อตัวบนทาร์เกตนั้นจะสามารถทนความเครียดสนามไฟฟ้าได้เพียง 1-10 MV/cm จะทำให้เกิดการเบรกดาวน์และเกิดอาร์คขึ้นในที่สุด หลังจากเกิดอาร์คนั้นจะมีอนุภาคเล็กๆที่แตกตัวออกมาพุ่งเข้าไปเจือปนชั้นฟิล์มที่ได้เคลือบไปแล้วของวัสดุรองรับทำให้คุณสมบัติของฟิล์มที่เคลือบไปแล้วเสื่อมลง

ปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขโดยเปลี่ยนไปใช้ดีซีพัลส์เพาเวอร์ซัพพลาย เนื่องจากแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงชนิดนี้นั้นสามารถเคลือบฟิล์มในอัตราที่สูงกว่าขณะที่สร้างสารเจือปนให้ฟิล์มน้อยกว่า และสามารถป้องกันการเกิดอาร์คได้อีกด้วย เพราะแหล่งจ่ายไฟฟ้าชนิดนี้จะสร้างพัลส์ด้านลบให้กับวัสดุรองรับและสร้างพัลส์ด้านบวกเล็กๆในด้านของทาร์เกตเพื่อให้ทาร์เกตคายประจุออกมาจึงเป็นเหตุให้ไม่มีการอาร์คเกิดขึ้น การหาค่าความถี่ที่เหมาะสมของพัลส์นั้นหาได้จากความสัมพันธ์

$$F = \left(\frac{J}{\epsilon \cdot \epsilon_0} \right) t \quad (2.1)$$

$$\begin{aligned} F &= \text{ความถี่ของพัลส์ (Hz)} \\ J &= \text{ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้า (A/cm}^2\text{)} \\ t &= \text{เวลาสูงสุดในการดิสชาร์จ (sec)} \end{aligned}$$

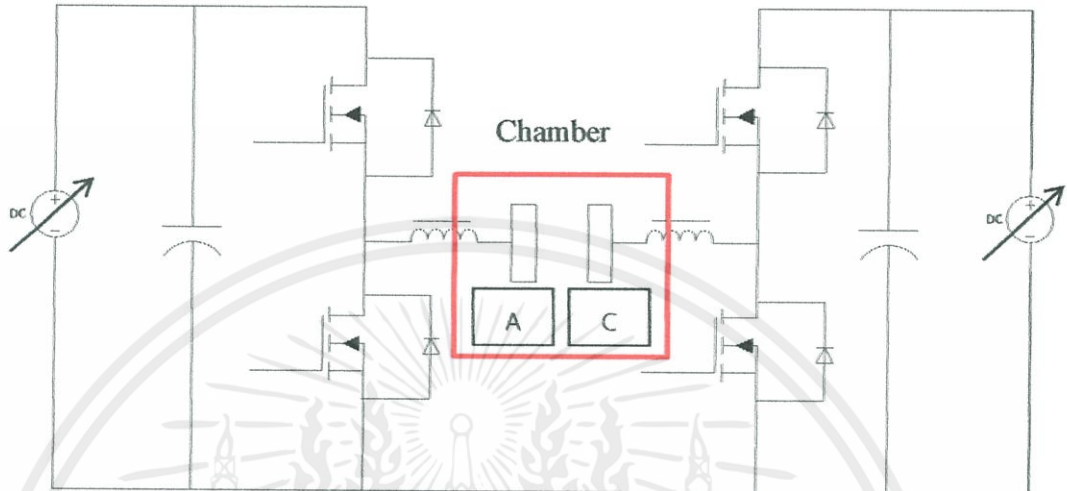
2.2 แหล่งจ่ายไฟฟ้าดีซีพัลส์ (DC Pulses Power Supply)

ในโลกของเราได้มีการนำพลังงานจากแหล่งกำเนิดที่ได้ถูกแปลงรูปด้วยการประยุกต์เข้ากับรูปคลื่นพัลส์ หรือที่เราเรียกกันว่า พัลส์ เพาเวอร์ (Pulses Power) มานานแล้ว ซึ่งได้มีการพัฒนามาใช้กับศาสตร์หลายแขนง เช่น กระบวนการผลิตอาหาร (Food Processing) การแพทย์ (Medical Treatment) เครื่องกำเนิดโอโซน (Ozone Generation) และอื่นๆ อีกมากมาย

กระบวนการทางพลาสมาส่วนใหญ่ เช่น การสปัตเตอร์ริง นั้นต้องการแหล่งจ่ายไฟฟ้าดีซีพัลส์เพื่อกำเนิดรูปคลื่นที่เหมาะสมกับการใช้งาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารลิขสิทธิ์สงวนไว้สำหรับใช้ในการวิจัยและพัฒนาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

แหล่งจ่ายไฟฟ้าดิซิจัลส์ประกอบด้วยแหล่งจ่ายแรงสูงปรับค่าได้สองชุด และ อินเวอร์เตอร์เฟสเดียว ซึ่งการสวิตช์ของอินเวอร์เตอร์จะขึ้นอยู่กับขบวนการดิซิจัลส์ วงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้า ดิจัลส์ได้จัดแสดงไว้ในรูป



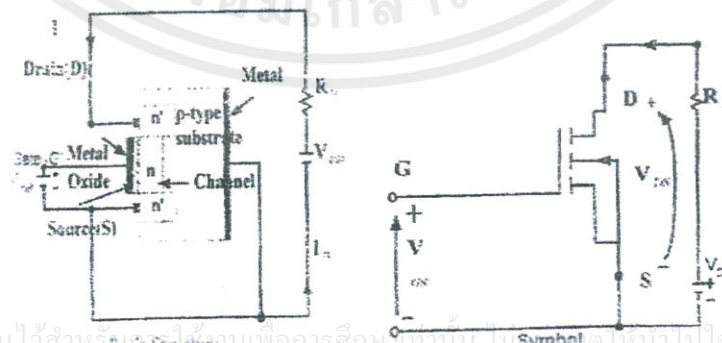
รูปที่ 2.5 วงจร DC Pulses Power Supply

2.2.1 อุปกรณ์สวิตช์ (MOSFET)

มอสเฟตเป็นอุปกรณ์แรงดันในการควบคุมกล่าวคือต้องใช้แรงดัน V_G ควบคุมการไหลของกระแสเดรน (i_d)

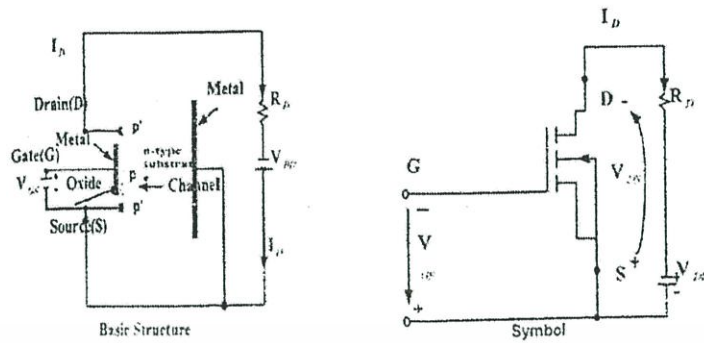
2.2.1.1 ประเภทของมอสเฟต

มอสเฟตเป็นอุปกรณ์ที่มีสามขั้วคือ ขั้วซอร์ส (source ; s) เดรน (Drain ; D) และเกท (Gate ; G) แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ มอสเฟตแบบดีพลีชัน (Depletion MOSFET) เรียกสั้นๆว่า ดิมอสเฟตและมอสเฟตแบบเอนฮานซ์เมนต์ (Enhancement MOSFET) หรือเรียกอีกชื่อ มอสเฟต แต่ละประเภทยังแบ่งออกเป็น 2 แบบคือ แชนแนล N (N-channel) และแชนแนล p (p-Channel)



(a) N-channel depletion-type Mosfet

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับครูใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่สงวนลิขสิทธิ์ให้ไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดลอกไปเผยแพร่และอ้างว่าเป็นงานของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



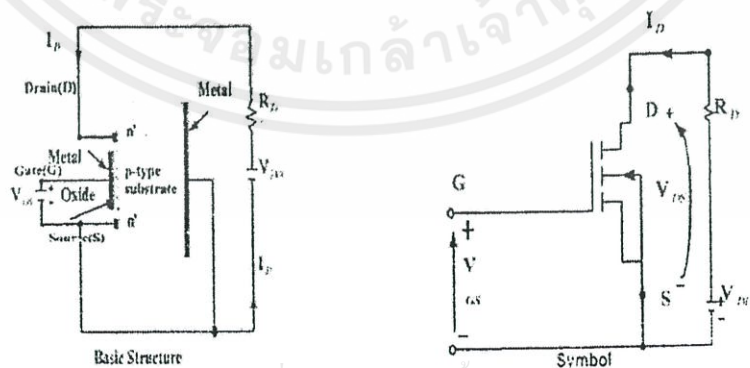
(b) P-channel depletion-type Mosfet

รูปที่ 2.6 โครงสร้างของมอสเฟตแบบ N และ p ชนิดดีพลีชัน

โครงสร้างของดีมอสเฟตแบบแชนแนล N ในรูปที่ 2.1 ประกอบด้วยสารกึ่งตัวนำชนิด p ซึ่งสร้างขึ้นจากซิลิกอนและเรียกว่าแผ่นพนักฐาน p (p-type substrate) โดยขั้ว D และขั้ว S ต่อกับบริเวณที่มีการกระตุ้นหรือโด๊ปให้เป็นบริเวณสารกึ่งตัวนำ N (N-Doped Region : N) บริเวณสารกึ่งตัวนำ N ทั้งสองส่วนนี้ต่อกับวัสดุผิวนอกที่เป็นโลหะ โดยมีซิลิกอนไดออกไซด์กั้นระหว่างแชนแนล N กับขั้ว G ซิลิกอนไดออกไซด์เป็นฉนวนประเภทไดอิเล็กตริก ถ้าแรงดันเกตซอร์ส (V_{GS}) มีค่าเป็นลบ อิเล็กตรอนบางส่วนใน แชนแนล N สร้างบริเวณปลอดพาหะ(Depletion Region) ภายในขั้วออกไซด์ทำให้แชนแนลแคบลงความต้านทานจากขั้วเดรนไปซอร์ส R_{DS} เริ่มมีค่าสูงเมื่อ V_{GS} มีค่าเพียงพอ แชนแนลจะหายไป R_{DS} จึงมีค่าสูงมากและไม่มีกระแสไหลจากขั้วเดรนไปซอร์ส นั่นคือ I_{DS} เท่ากับศูนย์ระดับ V_{GS} นี้เรียกว่า แรงดันพินชออฟ (Pinch-Off Voltage: V_p)

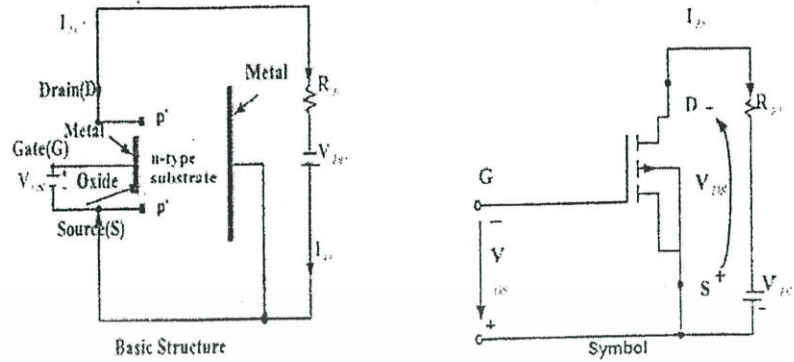
ในทางตรงกันข้าม ถ้า V_{GS} เป็นบวกแชนแนลจะกว้างขึ้นเป็นผลให้ I_{DS} มีค่าเพิ่มขึ้นเนื่องจาก R_{DS} มีค่าลดลง

หลักการที่กล่าวมานี้ใช้ได้กับมอสเฟตแบบแชนแนล P โดยขั้วของ V_{DS} , I_{DS} และ V_{GS} เปลี่ยนเป็นขั้วตรงข้ามกับกรณีดีมอสเฟตแบบแชนแนล N



(a) n-channel enhancement-type Mosfet

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลใดๆทั้งสิ้นของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



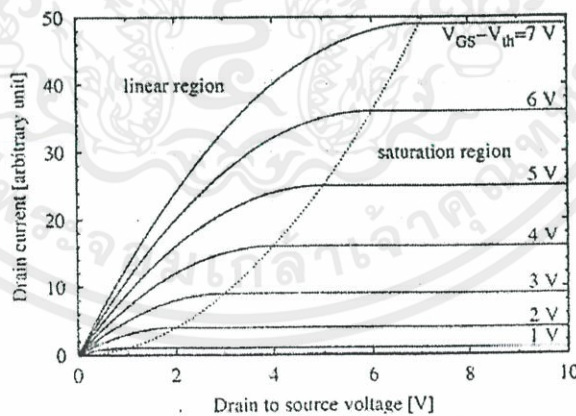
(b) p-channel enhancement-type Mosfet

รูปที่ 2.7 โครงสร้างของมอสเฟตแบบ N และ p ชนิด Enhancement

อิมอสเฟตแบบ Enhancement N ดังรูปที่ 2.4 ถ้า V_{GS} เป็นบวกแรงดันเหนี่ยวนำจะดึงดูดอิเล็กตรอนจากแผ่นพินิกฐาน p และรวบรวมไว้ที่ผิวในชั้นออกไซด์ ถ้า V_{GS} มากกว่าหรือเท่ากับค่าแรงดันเทรชโฮลด์ (Threshold Voltage: V_T) จึงมีกระแสไหลจากเดรนไปซอร์ส หลักการที่กล่าวมานี้ใช้ได้กับอิมอสเฟตแบบ Enhancement p โดยข้อของ V_{DS} , I_{DS} และ V_{GS} เปลี่ยนเป็นขั้วตรงข้ามกับกรณีอิมอสเฟตแบบ Enhancement N

2.2.1.2 คุณสมบัติของมอสเฟต (MOSFET Characteristic)

ได้กล่าวไว้ตอนต้นแล้วว่ามอสเฟตเป็นอุปกรณ์ใช้แรงดัน ในการควบคุมอิมพีแดนซ์อินพุตสูงมากจากขั้วเกตจะดึงกระแสรั่วไหลต่ำมาก และเราทราบว่าทรานส์คอนดักแตนซ์ (Transconductance : gm)



รูปที่ 2.8 กราฟคุณสมบัติในการถ่ายโอนของอิมอสเฟตแบบ Enhancement N และคุณสมบัติเอาต์พุตของอิมอสเฟตแบบ Enhancement N

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์ในการถ่ายโอนของอิมอสเฟตแบบ Enhancement N และแบบ Enhancement P การค้า
ไม่ว่ากรณีใด แสดงดังรูป แสดงคุณสมบัติของอิมอสเฟตแบบ Enhancement N ซึ่งมีทั้งสามบริเวณคือ

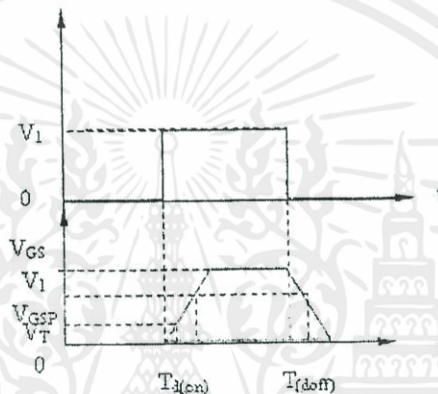
- 1). บริเวณคัตออฟ เกิดขึ้นเมื่อแรงดัน V_{GS} น้อยกว่าหรือเท่ากับ V_T

2). บริเวณพินช์ออฟ หรือบริเวณอิ่มตัว (Pinch-off or saturation Region) เกิดขึ้นเมื่อ V_{DS} มากกว่าหรือเท่ากับ $V_{GS} - V_T$

3). บริเวณที่เป็นเชิงเส้น (Linear Region) เกิดขึ้นเมื่อ V_{DS} น้อยกว่าหรือเท่ากับ $V_{GS} - V_T$ ในบริเวณเชิงเส้น I_D จะเปลี่ยนแปลงตามสัดส่วนของ V_{DS} และเนื่องจากมี I_D สูงขณะที่ V_D มีค่าต่ำ อิมอสเฟตจึงใช้บริเวณที่เป็นเชิงเส้นแสดงปฏิกิริยาในการสวิตช์ สำหรับอิมอสเฟตแรงดันเกต (หรือแรงดันอินพุท) อาจเป็นบวกหรือลบก็ได้แต่อิมอสเฟตตอบสนองกับแรงดันที่เป็นบวกอย่างเดียวตามปกติอิมอสเฟตกำลังประเภทอิมอสเฟต

2.2.1.3 คุณสมบัติในการสวิตช์ (Switching Characteristics)

ผลกระทบที่เกิดจากคาปาซิเตอร์ บริเวณรอยต่อของสารกึ่งตัวนำในอิมอสเฟต ทำให้เขียนรูปคลื่นในการสวิตช์ได้ดังรูปที่



รูปที่ 2.9 รูปคลื่นแรงดันในการสวิตช์ของแรงดันเกต

เมื่อป้อนแรงดันเกตเพิ่มจากศูนย์ถึง V_1 เวลาที่ใช้ในการอัดประจุคาปาซิเตอร์ (ภายในตัวของอิมอสเฟต) ให้มีค่าถึงระดับแรงดันเทรชโฮลด์ V_R ซึ่งเรียกว่าช่วงเวลาดีเลย์ในการเปิด (Turn - on Delay Time, t_d (ON)) และช่วงเวลาขาขึ้น (t_r) เป็นเวลาอัดประจุจากระดับ (V_R) จนกระทั่งมีค่าถึงระดับแรงดันเกตเต็มที่ (Full Gate voltage; V_{GSP}) ซึ่งใช้ในการขับมอสเฟตไปสู่บริเวณเชิงเส้น

เวลาที่คาปาซิเตอร์คายประจุจาก V_1 ไปจนถึงบริเวณพินช์ออฟ เรียกว่า ช่วงเวลาดีเลย์ในการเปิด (Turn - on Delay Time, t_d (ON)) และช่วงเวลาขาลง (t_f) เป็นเวลาที่คาปาซิเตอร์ใช้ในการคายประจุจากบริเวณพินช์ออฟถึง V_R ถ้า $V_{GS} < V_R$ มอสเฟตจะปิด

2.2.1.4 ประโยชน์และการใช้งานมอสเฟตกำลัง

เนื่องจากมอสเฟตกำลังมีความเร็วในการสวิตช์สูงมากเป็นนาโนวินาทีจึงเหมาะกับการแปลงผันที่มีความถี่และมีกำลังไฟฟ้าต่ำ แต่อย่างไรก็ตามอิมอสเฟตจะมีปัญหาในการคายประจุภายในตัวเองจึงต้องดูแลรักษาเป็นพิเศษ นอกจากนี้การป้องกันมอสเฟตขณะที่เกิดฟลัดด์แบบลัดวงจรทำได้ค่อนข้างยาก

เอกสารนี้เป็นเอกสาร 2.2.2 แหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูงปรับค่าได้ (High Voltage Variable Power Supply) ก้านการค่า

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้ง แหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูงปรับค่าได้จะนำมาเป็นแรงดันขาเข้าของวงจร H-Bridge

แหล่งจ่ายที่ใช้จะมีสองชุด ชุดแรกคือ V_{DC1} จะเป็นแรงดันที่ใช้ในโหมดแรงดันบวก และ V_{DC2} จะเป็น

แรงดันที่ใช้ในโหมดแรงดันลบ แหล่งจ่ายทั้งสองชุดจะสามารถปรับค่าได้เพื่อปรับอัตราการเคลือบผิวของฟิล์มบาง

2.2.3 ห้องสุญญากาศ (Vacuum Chamber)

ห้องสุญญากาศ คือ ห้องที่ใช้ในการเคลือบฟิล์มบางบนผิววัสดุรองรับ ภายในประกอบด้วยอิเล็กโทรดสองขั้ว อาโนด และแคโทด สารเคลือบ (Target) จะถูกติดตั้งไว้ที่ขั้วแคโทด และวัสดุรองรับจะติดตั้งไว้ที่ขั้วอาโนด ด้านล่างของขั้วอาโนดจะมีขั้วแม่เหล็กวางเรียงให้มีสนามแม่เหล็กวนรอบพื้นของห้องซึ่งเรียกว่า “Race Track” ใช้เป็นแหล่งกำเนิดพลาสมาเพื่อเร่งปฏิกิริยาการเคลือบผิว

2.2.4 การสวิตช์ของวงจร H-Bridge

จากรูปคลื่นดิซีพัลส์ที่ได้แสดงไว้ในหัวข้อก่อนหน้านี้ เมื่อนำมาควบคุมการสวิตช์ของมอสเฟตจะได้โหมดการทำงานทั้งหมดโหมดดังตารางต่อไปนี้

โหมดการทำงาน	ลำดับการสวิตช์	แรงดันขาออก
Positive DC	S1&S4	$V_{DC1} > 0, V_{DC2} = 0$
Negative DC	S2&S3	$V_{DC1} = 0, V_{DC2} > 0$
Positive Unipolar	S1&S4, S2&S4	$V_{DC1} > 0$
Negative Unipolar	S2&S3, S2&S4	$V_{DC2} > 0$
Symmetric Bipolar	S1&S4, S2&S4, S2&S3, S2&S4	$V_{DC1} = V_{DC2}$ $P = N$
Asymmetric Bipolar	S1&S4, S2&S4, S2&S3, S2&S4	$V_{DC1} \neq V_{DC2}$ $P \neq N$

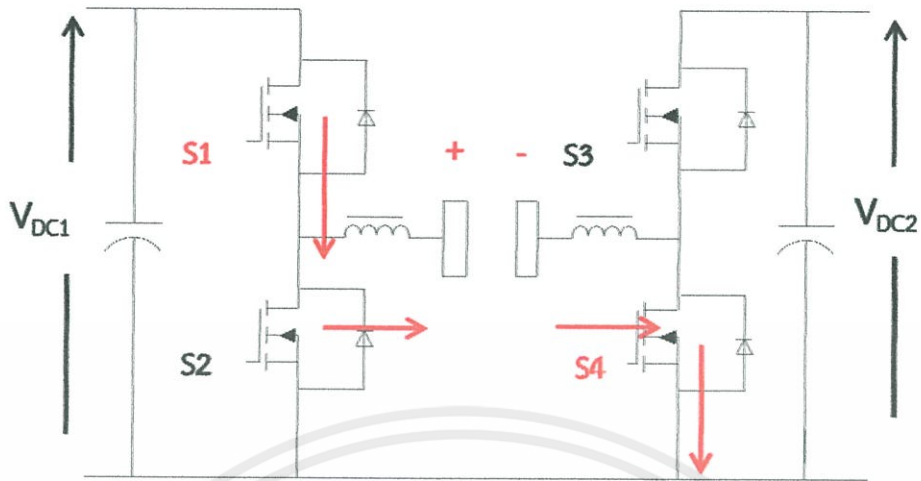
ตารางที่ 2.1 โหมดการทำงานของวงจร H-Bridge ในแหล่งจ่ายไฟฟ้าดิซีพัลส์

2.2.4.1 การสวิตช์แบบบออะซิมเมตริกไบโพล่า (Asymmetric Bipolar)

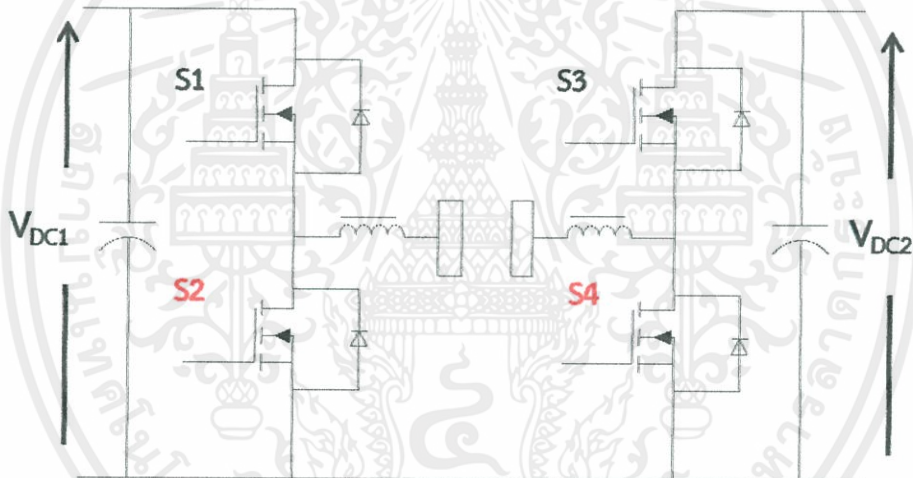
การสวิตช์แบบบออะซิมเมตริกไบโพล่านั้นจะมีคุณลักษณะพัลส์บวกและพัลส์ลบ โดยความกว้างพัลส์ของพัลส์บวกจะน้อยกว่าของพัลส์ลบ ระหว่างพัลส์บวกและพัลส์ลบจะมีช่วงเวลาหยุดทำงาน และขนาดแรงดันของพัลส์บวกนั้นจะน้อยกว่าของพัลส์ลบเนื่องจากช่วงเวลาพัลส์ลบนั้นจะเป็นช่วงที่เกิดปฏิกิริยาการสปัดเตอร์ขึ้น และเมื่อถึงช่วงเวลาหยุดทำงานแล้วอาจมีประจุตกค้างอยู่ที่ผิวของทาร์เกต ดังนั้นจึงต้องมีพัลส์บวกเล็กน้อยเพื่อดิสชาร์จประจุบนผิวทาร์เกตออกทำให้มีโอกาสเกิดไมโครอาร์คน้อยลงและทำให้การเคลือบผิวนั้นสะอาดขึ้นอีกด้วย ในระหว่างการเกิดพัลส์บวกเพื่อดิสชาร์จจะไม่มีสปัดเตอร์เกิดขึ้น โดยปกติแล้วแรงดันพัลส์บวกจะกำหนดให้เป็นหนึ่งในสิบของแรงดันพัลส์ด้านลบ

ต่อไปนี้เป็นรูปตัวอย่างการทำงานของการสวิตช์แบบบออะซิมเมตริกไบโพล่า

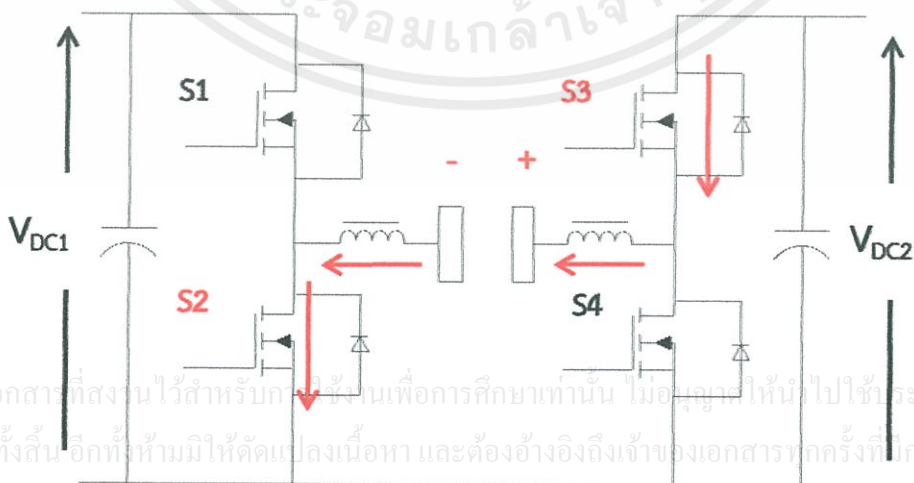
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ก) S1&S4

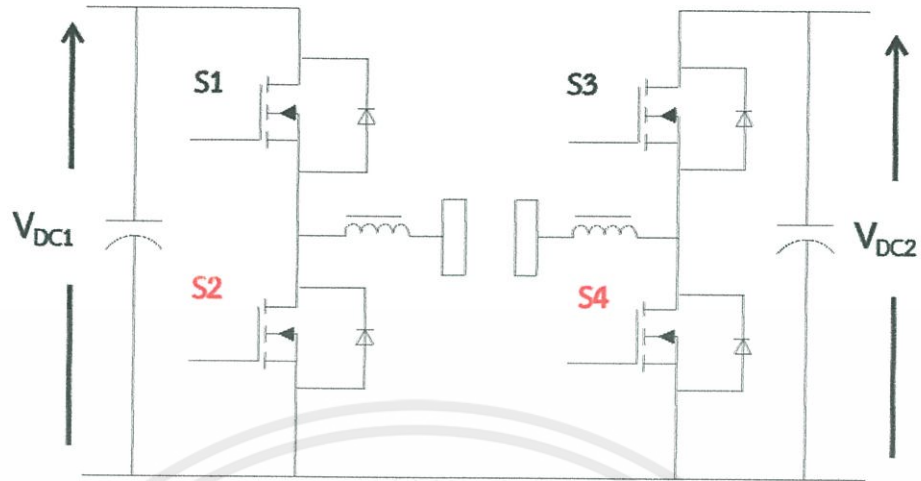


ข) S2&S4



ค) S2&S3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับก... ใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาติให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

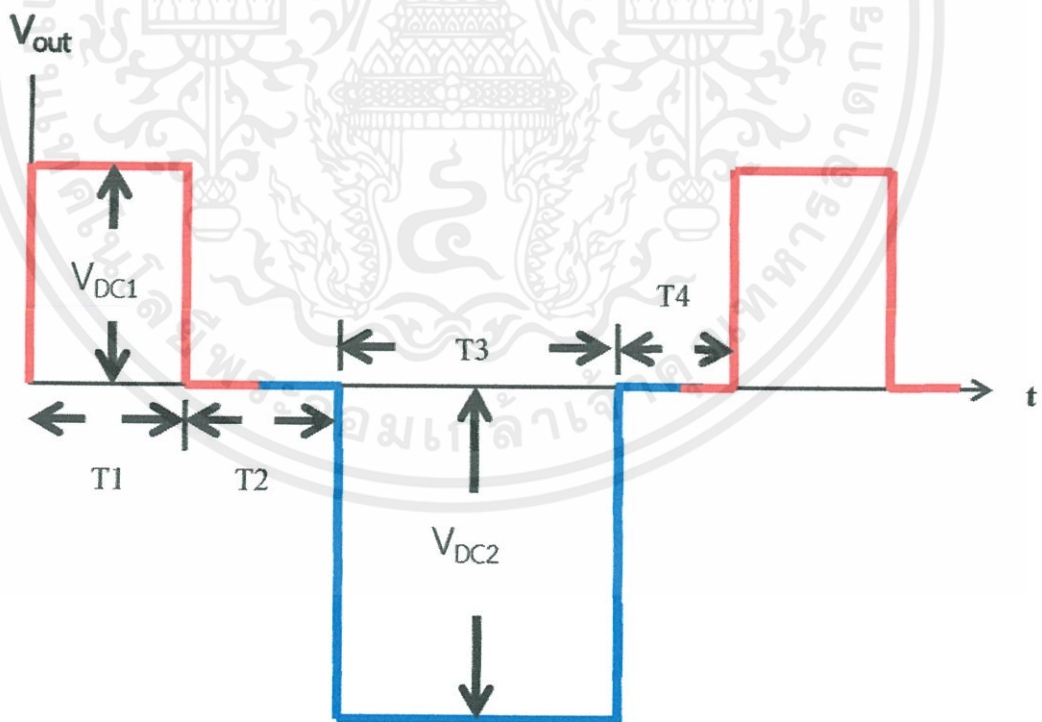


ง) S2&S4

รูปที่ 2.10 โหมดการทำงานแบบ Asymmetric Bipolar

2.2.4.2 ขบวนการคลื่นพัลส์แบบอะซิมเมตริกไบโพลาร์ (Asymmetric Bipolar DC Pulses Train)

จากการทำงานของวงจรแบบอะซิมเมตริกไบโพลาร์ในหัวข้อ 2.2.4.1 จะได้รูปคลื่นที่แรงดันขาออกของวงจรดังนี้

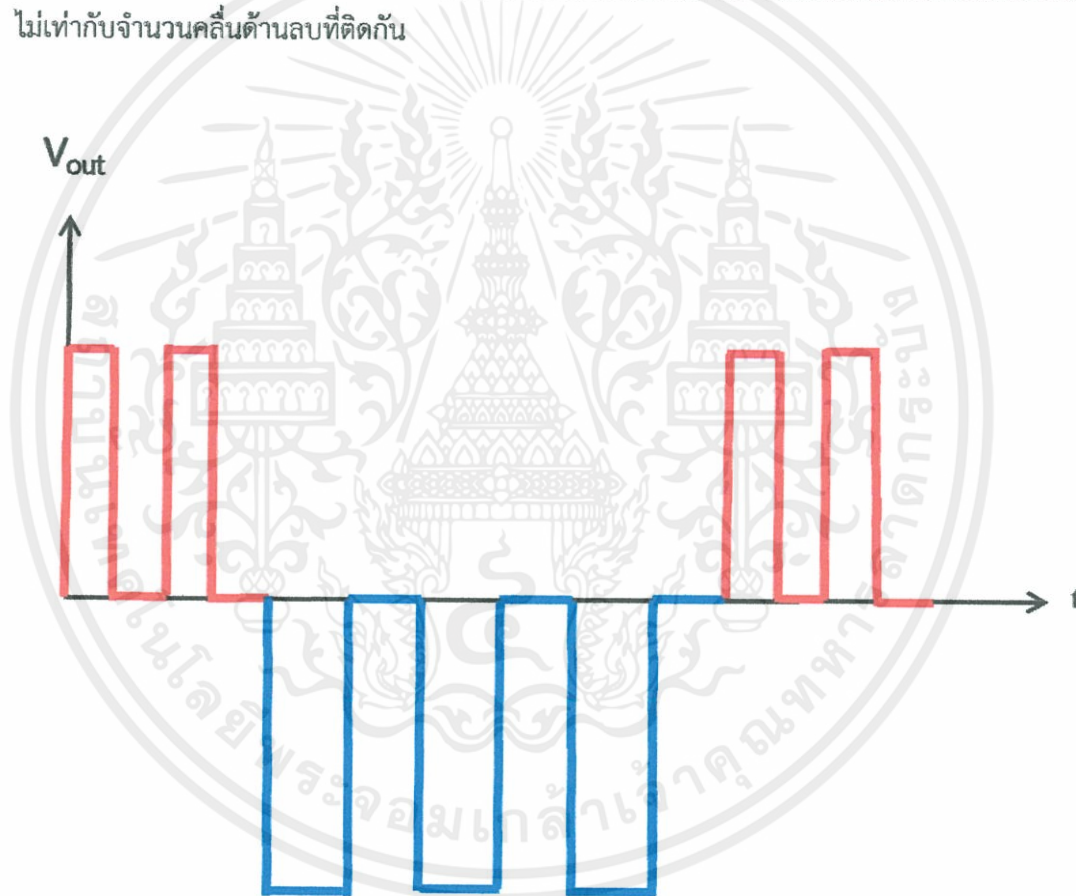


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 รูปที่ 2.11 รูปคลื่นแรงดันขาออกแบบอะซิมเมตริกไบโพลาร์

ในการใช้เทคนิคขบวนการชดเชยเพื่อเคลือบฟิล์มบางนั้น รูปคลื่นจะต้องมีเอาท์พุท ขบวนการคลื่นที่สามารถปรับค่าแอมพลิจูดด้านบวกและด้านลบได้ ปรับเลือกโหมดดิวตีโพล่าหรือไบโพล่า ได้ เลือกสมมาตรหรือไม่สมมาตรได้ ดังนั้น ขบวนการคลื่นจะมีค่าพารามิเตอร์ที่ปรับค่าได้ 6 ตัว คือ V_{DC1} , V_{DC2} , $T1$, $T2$, $T3$ และ $T4$ ซึ่งอธิบายได้ตามนี้

- V_{DC1} คือ ระดับแรงดันด้านบวกของชดเชย
- V_{DC2} คือ ระดับแรงดันด้านลบของชดเชย
- $T1$ คือ ช่วงเวลา ON ของขบวนการชดเชยด้านบวก
- $T2$ คือ ช่วงเวลา OFF ของขบวนการชดเชยด้านบวก
- $T3$ คือ ช่วงเวลา ON ของขบวนการชดเชยด้านลบ
- $T4$ คือ ช่วงเวลา OFF ของขบวนการชดเชยด้านลบ

นอกจากนี้ยังมีกรณีที่ใช้ขบวนการคลื่นแบบไม่สมมาตร คือ จำนวนคลื่นด้านบวกที่ติดกันจะไม่เท่ากับจำนวนคลื่นด้านลบที่ติดกัน



รูปที่ 2.12 รูปคลื่นขาออกแบบอะซิมเมตริกไบโพล่าที่มีหลายพัลส์ต่อซ้ำ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.2.5 การควบคุมโหมดการทำงาน

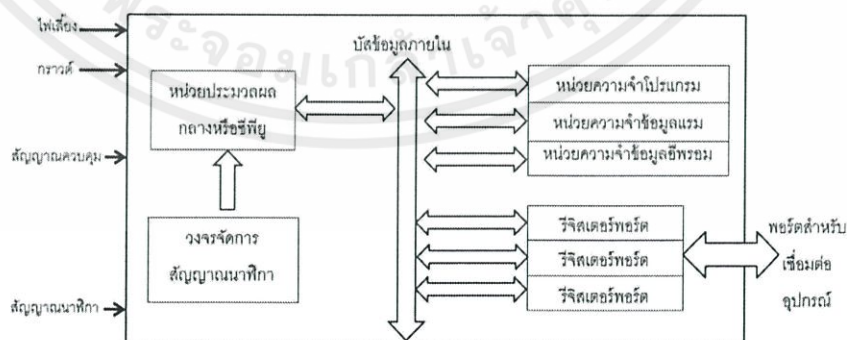
การควบคุมให้วงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้าดีซีฟิลส์ทำงานได้ตามโหมดที่ต้องการจะใช้นั้นสามารถทำได้โดยการโปรแกรมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ การควบคุมปฏิกิริยาการสปีดเตอริงในห้องสุญญากาศนั้นจะต้องปรับเปลี่ยนตัวแปรพารามิเตอร์ของขบวนการขึ้นทั้งหกตัวได้ตามที่ต้องการ ดังนั้นเพื่อให้ง่ายต่อการควบคุมตัวแปร ไมโครคอนโทรลเลอร์จะต้องมีพอร์ตอนุกรม (Serial Port) เพื่อส่งข้อมูลโหมดการทำงานให้กับคอมพิวเตอร์และใช้โปรแกรม LabVIEW เพื่อให้สามารถปรับแต่งพารามิเตอร์ทั้งหกตัวได้ง่ายขึ้น

2.3 ไมโครคอนโทรลเลอร์ (dsPIC30F4011)

เนื่องด้วยการควบคุมในโครงงานนี้จะใช้การควบคุมจากระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ จึงจะขอกล่าวเกี่ยวกับระบบและทฤษฎีของไมโครคอนโทรลเลอร์ ดังนี้

2.3.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์

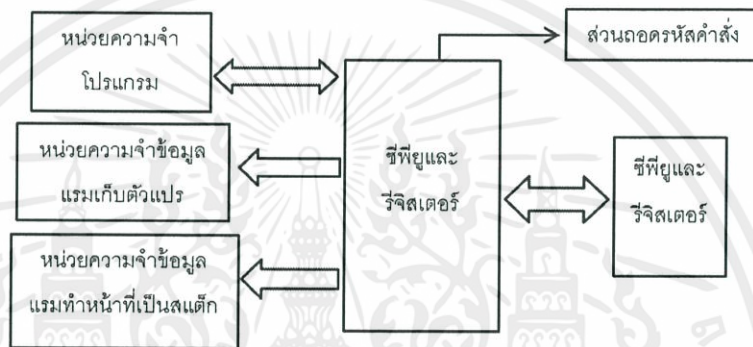
ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller) มาจากคำ 2 คำ คำหนึ่งคือไมโคร (Micro) หมายถึงขนาดเล็ก และคำว่า คอนโทรลเลอร์ (Controller) หมายถึง ตัวควบคุมหรืออุปกรณ์ควบคุม ดังนั้น ไมโครคอนโทรลเลอร์จึงหมายถึง อุปกรณ์ควบคุมขนาดเล็ก ในตัวอุปกรณ์ควบคุมขนาดเล็กนี้ได้บรรจุความสามารถที่คล้ายคลึงกับระบบคอมพิวเตอร์ กล่าวคือ ภายในไมโครคอนโทรลเลอร์ได้รวมเอาซีพียู หน่วยความจำ และพอร์ต ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักสำคัญของระบบคอมพิวเตอร์เข้าไว้ด้วยกัน โดยบรรจุรวมอยู่ในตัวถังเดียวกัน ในภาพที่ 2.13 แสดงส่วนประกอบหลักที่สำคัญและกลไกการทำงานเบื้องต้นของไมโครคอนโทรลเลอร์ ซีพียูจะติดต่อกับหน่วยความจำโปรแกรมเพื่ออ่านคำสั่งที่ระบุไว้ โดยต้องทำการอ้างตำแหน่งของหน่วยความจำผ่านสายสัญญาณที่เรียกว่า บัสตำแหน่ง (Address bus) แล้วทำการอ่านข้อมูลคำสั่งออกมาจากหน่วยความจำโปรแกรมในแอดเดรสนั้นๆ จากนั้นทำการประมวลผลโดยมีหน่วยความจำข้อมูลแรมเป็นที่พักของข้อมูลที่อยู่ในระหว่างการประมวลผลข้อมูล การประมวลผลจะส่งผ่านสายสัญญาณที่เรียกว่า บัสข้อมูล (Data bus) แล้วส่งต่อไปยังอุปกรณ์ภายนอกผ่านทางพอร์ตเอาต์พุต



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่ **รูปที่ 2.13** โครงสร้างและส่วนประกอบหลักเบื้องต้นของไมโครคอนโทรลเลอร์ โยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

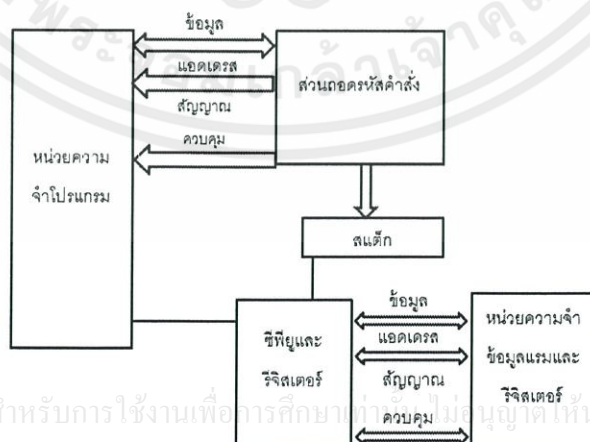
2.3.2 สถาปัตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร์

เป็นที่ยอมรับกันว่าสถาปัตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร์มีด้วยกัน 2 แบบคือ พรินซ์ตัน (Princeton) หรือ ฟอน นิวแมน (Von Neumann) และฮาร์วาร์ด (Harvard) ในภาพที่ 2.14 เป็นการจัดสรรในสถาปัตยกรรมแบบพรินซ์ตัน ซึ่งมีโครงสร้างที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อน ข้อดีของสถาปัตยกรรมแบบนี้คือ ออกแบบง่าย เพราะหน่วยความจำทั้งหมดอยู่รวมกัน สามารถเข้าถึงได้ง่าย หน่วยความจำมีขนาดใหญ่เพียงพอที่จะเก็บได้ทั้งโปรแกรมควบคุมการทำงานและข้อมูลของตัวแปรในการประมวลผล ข้อดีของสถาปัตยกรรมนี้คือ ความเร็วในการประมวลผล เนื่องจากหน่วยความจำอยู่รวมกัน จึงต้องติดต่อหน่วยความจำโปรแกรมสลับกับหน่วยความจำข้อมูล ส่งผลให้ซีพียูต้องใช้ไซเคิลในการทำงานมาก



รูปที่ 2.14 โครงสร้างสถาปัตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร์แบบพรินซ์ตัน หรือ ฟอน นิวแมน

ในขณะที่สถาปัตยกรรมแบบฮาร์วาร์ด ซึ่งแสดงในภาพที่ 2.15 จะแยกส่วนของหน่วยความจำ ข้อมูล และรีจิสเตอร์ออกจากหน่วยความจำ โปรแกรมทำให้ไซเคิลการทำงานลดลง เนื่องจากสามารถติดต่อหน่วยความจำโปรแกรม และหน่วยความจำข้อมูลได้เร็วกว่า นอกจากนั้นในขณะที่ซีพียูกำลังเอ็กซิกิวต์คำสั่งปัจจุบันอยู่สามารถที่จะเฟลตซ์คำสั่งถัดไปได้ยิ่งทำให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ทำงานได้เร็วขึ้น

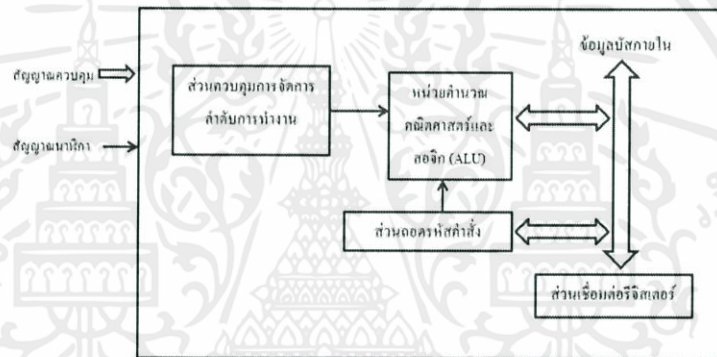


รูปที่ 2.15 โครงสร้างสถาปัตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร์แบบฮาร์วาร์ด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งยังมีให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.3.3 หน่วยประมวลผลกลาง หรือซีพียู

ซีพียูเป็นเหมือนมันสมองของไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึ่งทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลที่เข้ามาในระบบ แล้วทำการส่งต่อไปยังส่วนต่างๆ เพื่อควบคุมการทำงานต่อไป ในภาพที่ 2.16 แสดงส่วนประกอบพื้นฐานของซีพียูในไมโครคอนโทรลเลอร์ต่างๆ ไป จะเห็นว่าหัวใจหลักของซีพียูคือหน่วยคำนวณทางคณิตศาสตร์และลอจิก (ALU: Arithmetic and Logic Unit) ซึ่งได้รับการกำหนดจังหวะการทำงานจากส่วนควบคุมลำดับการทำงาน โดยจังหวะการทำงานนั้นจะสัมพันธ์กับสัญญาณนาฬิกา เมื่อซีพียูทำการติดต่อหน่วยความจำ สิ่งที่ปรากฏขึ้นบนบัสข้อมูลภายในซีพียูคือ รหัสคำสั่ง (Instruction Code) ซึ่งต้องผ่านการทำงานของส่วนถอดรหัสคำสั่ง (Instruction Decoder) เสียก่อนจะได้เป็นข้อมูลคำสั่งที่ซีพียูเข้าใจ และสามารถดำเนินการต่อได้หลังจากที่หน่วยคำนวณทางคณิตศาสตร์และลอจิกประมวลผลแล้วจึงส่งข้อมูลบางส่วนเชื่อมต่อร์จิสเตอร์ภายในซีพียู เพื่อที่จะติดต่อกับส่วนอื่นๆต่อไป



รูปที่ 2.16 ส่วนประกอบหลักของซีพียูในไมโครคอนโทรลเลอร์

2.3.4 หน่วยความจำ

ไมโครคอนโทรลเลอร์จะประกอบด้วยหน่วยความจำ 3 แบบคือ หน่วยความจำโปรแกรม (Program Memory), หน่วยความจำข้อมูลแรม (RAM Data Memory) และ หน่วยความจำข้อมูลอีพรอม (EEPROM Data Memory)

2.3.4.1 หน่วยความจำโปรแกรม

เป็นที่เก็บข้อมูลคำสั่งของโปรแกรมควบคุมหรือเรียกว่า โปรแกรมมอนิเตอร์ (Monitor Program) ซีพียูจะเข้ามาติดต่อเพื่ออ่านข้อมูลรหัสคำสั่งจากหน่วยความจำในส่วนนี้ แล้วนำไปประมวลผลเพื่อควบคุมการทำงานของระบบทั้งหมดต่อไป หน่วยความจำโปรแกรมนี้อิ่งมีขนาดใหญ่มากเท่าใดก็จะสามารถบรรจุโปรแกรมที่มีความซับซ้อน หรือสามารถเก็บตารางข้อมูลที่ใช้ในการประมวลผลได้มากตามไปด้วย โดยทั่วไปมีความจุไม่น้อยกว่า 512 ไบต์ ชนิดของหน่วยความจำ

เอกสารนี้เป็นโปรแกรมที่ใช้ในไมโครคอนโทรลเลอร์ มีอยู่ 3 แบบที่นิยมกันคือ แบบอีพรอม (EPROM: Erasable Read-Only Memory), แบบอีพรอม (EEPROM: Electrically Erasable Programmable Read-

Only Memory) และแบบแฟลช (Flash Memory) ความแตกต่างของทั้ง 3 แบบอยู่ที่จำนวนครั้งในการลบและเขียนข้อมูลทับลงไปใหม่

2.3.4.2 หน่วยความจำข้อมูลแรม

เป็นหน่วยความจำที่ต้องมีไมโครคอนโทรลเลอร์ทุกตัว เพราะใช้เป็นที่สำหรับเก็บข้อมูลทั้งระหว่างและหลังการประมวลผล ยังมีมากยิ่งช่วยในการทำงานสะดวกขึ้น เพราะหน่วยความจำแรมมีอัตราเร็วในการอ่านเขียนสูงมาก และไม่จำกัดจำนวนรอบในการอ่านเขียน ในพื้นที่ของหน่วยความจำข้อมูลแรมจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนของข้อมูลทั่วไปสำหรับเก็บค่าตัวแปร และส่วนของรีจิสเตอร์ โดยปกติแล้วหน่วยความจำข้อมูลแรมจะมีความจุไม่มากเมื่อเทียบกับหน่วยความจำโปรแกรมในบางตัวอยู่ในหลักสิบบิต แต่ถ้าไมโครคอนโทรลเลอร์มีความสามารถสูงชัน ความจุของหน่วยความจำข้อมูลแรมก็เพิ่มมากขึ้นตาม ทั้งนี้ต้องเพิ่มในส่วนของรีจิสเตอร์ตามความสามารถที่สูงชันของไมโครคอนโทรลเลอร์ ขนาดของหน่วยความจำข้อมูลแรมโดยส่วนใหญ่จะมีขนาด 8 บิต แต่สามารถต่อรวมกันเป็น 16 บิตได้ ส่วนการจัดสรรแอดเดรสของหน่วยความจำข้อมูลแรมจะขึ้นอยู่กับสถาปัตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร์ หากเป็นแบบฮาร์วาร์ด (Harvard) จะได้รับการจัดสรรให้อยู่แยกจากหน่วยความจำโปรแกรม จึงทำให้มีค่าแอดเดรสเหมือนกัน ทั้งในหน่วยความจำโปรแกรมและหน่วยความจำข้อมูล แต่จริงๆ แล้วอยู่ต่างที่กัน ซึ่งจะพบในไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51, PIC, AVR เป็นต้น แต่ถ้าเป็นแบบพริન્ซ์ตัน (Princeton) จะจัดสรรให้อยู่ในบริเวณเดียวกัน ดังนั้นค่าแอดเดรสจะไม่มีทางตรงกัน จะพบในไมโครคอนโทรลเลอร์ 68HCxxx ของ Motorola

2.3.4.3 หน่วยความจำข้อมูลอีพรอม

เป็นหน่วยความจำข้อมูลพิเศษที่ไมโครคอนโทรลเลอร์บางเบอร์ บางรุ่น บางตระกูลใช้สำหรับเก็บข้อมูลที่ต้องการรักษาไว้เมื่อไม่มีการจ่ายไฟเลี้ยงให้แก่ไมโครคอนโทรลเลอร์ การติดต่อเพื่ออ่านขึ้นอยู่กับไมโครคอนโทรลเลอร์แต่ละเบอร์ ขนาดของหน่วยความจำแบบนี้มักเท่ากับ 8 บิต ส่วนความจุจะแตกต่างกันไปตั้งแต่ไม่กี่สิบบิตจนถึงกิโลบิต การอ่านเขียนหน่วยความจำแบบนี้จะใช้สัญญาณไฟฟ้าทั้งหมด และสามารถรักษาข้อมูลล่าสุดไว้แม้ว่าจะไม่มีการจ่ายไฟเลี้ยงให้แก่ไมโครคอนโทรลเลอร์แล้วก็ตาม สำหรับจำนวนรอบในการเขียนโดยปกติจะอยู่ในหลักล้านขึ้นไป

2.3.5 หน่วยความจำพิเศษ

เป็นหน่วยความจำที่ใช้เก็บข้อมูลพิเศษ ไม่ได้ใช้สำหรับเก็บชุดคำสั่งของโปรแกรมหรือข้อมูลอื่นๆ มีหลายชนิดแตกต่างกันขึ้นอยู่กับตระกูลของไมโครคอนโทรลเลอร์

2.3.5.1 รีจิสเตอร์

เป็นหน่วยความจำพิเศษที่มีบทบาทสูงมาก สามารถอ่านและเขียนข้อมูลได้ตลอดเวลาจนกว่าจะหยุดจ่ายไฟเลี้ยงให้แก่ไมโครคอนโทรลเลอร์ หน้าที่หลักก็คือใช้เก็บข้อมูลในการทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยข้อมูลที่เก็บนี้มีทั้งข้อมูลแสดงสถานะการทำงาน, ข้อมูลสำหรับควบคุมการทำงานไมโครคอนโทรลเลอร์, ข้อมูลที่รับเข้ามาจากพอร์ตอินพุต, หรือข้อมูลที่ส่งออกไปยังอุปกรณ์ภายนอกผ่านพอร์ตเอาต์พุต โดยข้อมูลแต่ละประเภทก็จะจัดเก็บลงในรีจิสเตอร์ที่แตกต่างกันตามหน้าที่การทำงาน

2.3.5.2 โปรแกรมเคาน์เตอร์

การที่ซีพียูสามารถติดต่อกับหน่วยความจำโปรแกรมเพื่ออ่านข้อมูลคำสั่งได้อย่างถูกต้อง เป็นผลมาจากรีจิสเตอร์หน้าที่พิเศษตัวหนึ่งคือ รีจิสเตอร์ตัวนับโปรแกรม หรือโปรแกรมเคาน์เตอร์ (Program Counter, PC) โดยโปรแกรมเคาน์เตอร์จะเป็นตัวชี้ตำแหน่งแอดเดรสของหน่วยความจำโปรแกรมที่ซีพียูจะต้องไปกระทำในลำดับถัดไป

2.3.5.3 สแต็ก

สแต็ก (Stack) เป็นหน่วยความจำพิเศษที่ไม่โครคอนโทรลเลอร์ทุกตัวต้องมี โดยมีหน้าที่คือ เก็บข้อมูลที่ต้องการอยู่ของรีจิสเตอร์ และเมื่อข้อมูลนั้นถูกนำมาเก็บไว้ในสแต็กแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนข้อมูลในรีจิสเตอร์ตัวนั้นๆได้ทันที หลังจากทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงกลับมาอ่านข้อมูลเดิมกลับคืนจากสแต็ก ซึ่งกระบวนการเก็บข้อมูลของสแต็กจะมีลักษณะเป็นระดับหรือเป็นชั้นข้อมูลที่เก็บเข้ามาก่อนจะต้องอ่านออกทีหลังหรือแบบ FILO (First In Last Out) ในไมโครคอนโทรลเลอร์ส่วนใหญ่จะมีความจุของสแต็กไม่น้อยกว่า 8 ระดับ การที่ยังมีขนาดของสแต็กมากหรือมีจำนวนระดับมากก็จะยิ่งช่วยให้การทำงานสะดวกขึ้น เพราะในการประมวลผลมีโอกาสมากที่จะต้องพักข้อมูลในรีจิสเตอร์หลักเพื่อไปทำงานอื่นก่อน หลังจากนั้นจึงกลับมาทำงานต่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับงานที่มีการอินเทอร์รัพต์ หรือขัดจังหวะซีพียูอยู่บ่อยๆ ขนาดของสแต็กโดยปกติจะต้องเท่ากับขนาดของรีจิสเตอร์ตัวนับโปรแกรมหรือ PC เพราะมีโอกาสที่จะต้องเก็บค่าของ PC ไว้ในสแต็กด้วย

2.3.6 การทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์

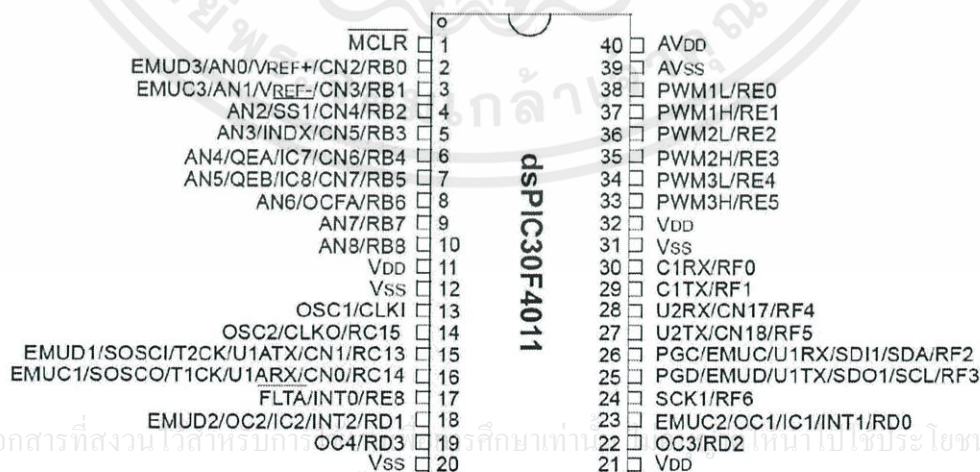
ไมโครคอนโทรลเลอร์จะสามารถทำงานได้เมื่อจ่ายไฟเลี้ยง และต่อวงจรกำเนิดสัญญาณนาฬิกาให้แก่มัน จากนั้นซีพียูภายในไมโครคอนโทรลเลอร์จะติดต่อกับหน่วยความจำโปรแกรมเพื่ออ่านข้อมูลคำสั่งและทำงานตามคำสั่งที่บรรจุอยู่ในหน่วยความจำโปรแกรม นั้นหมายความว่าต้องมีการเขียนข้อมูลลงในหน่วยความจำโปรแกรมก่อน โดยไมโครคอนโทรลเลอร์แต่ละเบอร์จะมีรูปแบบของข้อมูลคำสั่งที่แตกต่างกัน ภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรมสามารถแบ่งได้ 2 ระดับ คือ ภาษาาระดับสูง (High Level Language) และภาษาแอสเซมบลี (Assembly Language) โดยปกติไมโครคอนโทรลเลอร์ต้องโปรแกรมด้วยภาษาแอสเซมบลี เนื่องจากสามารถทำงานได้รวดเร็วผ่านกระบวนการแปลงข้อมูลคำสั่งเป็นเลขฐานสิบหกเพื่อทำงานตามคำสั่งเพียงหนึ่งขั้นตอน คือแปลงจากภาษาแอสเซมบลีเป็นข้อมูลฐานสิบหกที่เรียกว่า ออปโค้ด (Opcode) แต่ข้อเสียของการเขียนภาษาแอสเซมบลีคือผู้เขียนต้องทำความเข้าใจในชุดคำสั่งของไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์นั้นๆอย่างถ่องแท้ และเมื่อเปลี่ยนเบอร์ไมโครคอนโทรลเลอร์ก็จะต้องทำการเรียนรู้ และทำความเข้าใจชุดคำสั่งใหม่ซึ่งอาจทำให้เสียเวลามาก รวมทั้งผู้เขียนโปรแกรมต้องมีทักษะในการเขียนโปรแกรมสูงพอสมควร และเข้าใจถึงสถาปัตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นอย่างดี ในขณะที่การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาาระดับสูง อาทิเช่น ภาษาซี ภาษาเบสิก ต้องผ่านกระบวนการที่เรียกว่า คอมไพล์ (Compile) เพื่อแปลงภาษาาระดับสูงเหล่านั้นเป็นภาษาเครื่องหรือออปโค้ดของไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์นั้นๆเสียก่อน เมื่อใช้เครื่องมือทางซอฟต์แวร์ตัวนี้ทำให้ผู้เขียนโปรแกรมอาจไม่จำเป็นต้องศึกษาสถาปัตยกรรมและชุดคำสั่งของไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์นั้นๆอย่างลึกซึ้งเท่ากับการเขียน

ภาษาแอสเซมบลี ทั้งนี้เพราะคอมพิวเตอร์จะทำในส่วนนี้แทน แต่ข้อเสียของการใช้คอมพิวเตอร์คือราคาแพงมาก

2.4 โครงสร้างและสถาปัตยกรรมของ dsPIC30F4011

ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล PIC ของทางบริษัท Microchip เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ที่มีฟังก์ชันการทำงานต่างๆมากมาย เช่น Module Analog to Digital, Timer/Counter, USART, SPI และอื่นๆ ซึ่งส่วนต่างๆเหล่านี้จะถูกสร้างรวมอยู่ในชิพเพียงตัวเดียว ทำให้สามารถทำงานได้หลายๆอย่าง และสามารถลดในส่วนของฮาร์ดแวร์บางอย่างลง ส่วนในเรื่องของความเร็วชิพตระกูลนี้จะใช้เวลาในการทำคำสั่งต่างๆเพียง 1 หรือ 2 ไชเคลตต่อคำสั่งเท่านั้น โดยการทำงานนี้เป็นลักษณะไปป์ไลน์ (Pipe Line) ทำให้มีความเร็วในการทำงานมากกว่าชิพทั่วไป (ที่ความถี่เดียวกัน) และมีคุณสมบัติต่างๆของไมโครคอนโทรลเลอร์ dsPIC30F4011 สรุปได้อย่างคร่าวๆดังนี้

- การทำงานจะเป็นลักษณะไปป์ไลน์ ทำให้มีการทำงานที่เร็วขึ้น
- มีหน่วยความจำโปรแกรมแบบแฟลชขนาด 48 Kbytes (16 K Instruction word)
- มีหน่วยความจำข้อมูลแบบแรม 2 Kbytes
- มีหน่วยความจำแบบอีพรอม 1 Kbytes
- สามารถตอบสนองการอินเทอร์รัพต์ได้ 30 แหล่ง
- Power-on Reset (POR), Power-up Timer (PWRT) และ Oscillator Start-up Time (OST)
- Watchdog Timer (WDT)
- สามารถเลือกการป้องกันข้อมูลได้ (Code Protection)
- มีโหมดประหยัดพลังงาน (Sleep Mode)
- เลือกโหมดของสัญญาณนาฬิกาได้หลายโหมด
- ฟังก์ชันการโปรแกรมแบบ ICSP™ (In-Circuit Serial Programming™)
- ทำงานที่ไฟเลี้ยง 2.5 ถึง 5.5 โวลต์
- Analog to Digital Converter ความละเอียด 10 บิต 9 แชนเนลภายในตัว



รูปที่ 2.17 ตัวถังของ dsPIC30F4011 และตำแหน่งขาสัญญาณต่างๆ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการศึกษาเท่านั้น ไม่ควรนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.5 พอร์ตอนุกรม

พอร์ตอนุกรมในการสื่อสารข้อมูลนั้นพอร์ตอนุกรมจะมีความเร็วในการสื่อสารที่ช้ากว่าแบบขนาน เพราะการเคลื่อนย้ายข้อมูลแบบอนุกรมนั้นเป็นการส่งข้อมูลครั้งละ 1 บิต แต่พอร์ตขนานนั้นสามารถส่งข้อมูลที่ละหลายๆ บิตพร้อมๆ กันได้ แต่ข้อดีของการสื่อสารข้อมูลแบบอนุกรมคือสามารถส่งข้อมูลได้ในระยะทางที่ไกลกว่าแบบขนานและใช้สายสัญญาณที่น้อยกว่าการสื่อสารข้อมูลแบบขนาน ประเภทของการสื่อสารแบบอนุกรมแบ่งตามลักษณะสัญญาณในการส่งแบ่งได้ 2 แบบ คือ

1. การสื่อสารแบบซิงโครนัส (Synchronous) เป็นการสื่อสารข้อมูลโดยใช้สัญญาณนาฬิกาในการควบคุมจังหวะของการรับส่งสัญญาณ

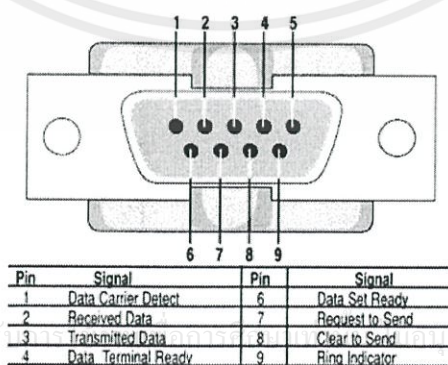
2. การสื่อสารแบบอะซิงโครนัส (Asynchronous) เป็นการสื่อสารที่ใช้สายข้อมูลเพียงตัวเดียว จะใช้รูปแบบของการส่งข้อมูล (Bit Pattern) เป็นตัวกำหนดว่าส่วนไหนเป็นส่วนเริ่มต้นข้อมูล ส่วนไหนเป็นตัวข้อมูล ส่วนไหนจะเป็นตัวตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และส่วนไหนเป็นส่วนปิดท้ายของข้อมูล โดยต้องกำหนดให้สัญญาณนาฬิกาเท่ากันทั้งภาคส่งและภาครับ

สำหรับการติดต่อสื่อสารลักษณะนี้จะใช้การรับส่งข้อมูลแบบ Asynchronous คือจะใช้สายข้อมูลเพียงสายเดียว

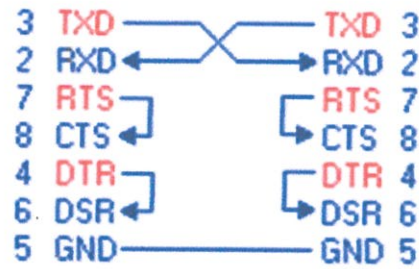
2.5.1 มาตรฐาน RS-232-C

มาตรฐาน RS-232-C เป็นมาตรฐาน RS-232 ที่มีการปรับปรุงแก้ไขจากมาตรฐานเดิม ซึ่งเราอาจคุ้นเคยกับชื่อนี้มากกว่า RS-232-A หรือ RS-232-B อันที่จริงแล้วยังมีมาตรฐาน RS-232-D ที่ใหม่กว่า RS-232-C โดยที่มีการเพิ่มข้อกำหนดของคอนเน็กเตอร์แบบ DB เข้าไปด้วย เช่น DB-25 ซึ่งในขณะนั้นสิทธิบัตรของตัวคอนเน็กเตอร์แบบนี้ได้หมดอายุลงพอดี จึงสามารถรวมข้อกำหนดเข้าไว้ได้

ลักษณะโดยทั่วไปของการเชื่อมต่อข้อมูลแบบอนุกรมตามมาตรฐาน RS-232 คือเป็นการสื่อสารข้อมูลแบบจุดต่อจุด ซึ่งเดิมทีเป็นการสื่อสารข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์กับโมเด็ม ซึ่งจริงๆ แล้วทั้งสองฝั่งจะเป็นอะไรก็ได้ การสื่อสารเป็นแบบสองทางพร้อมกัน (Full-duplex) โดยอาจใช้สายสัญญาณอื่นร่วมเพื่อทำแฮนด์เชค (Hand-shake) หรือไม่ก็ได้ มาตรฐาน RS-232 จำกัดความยาวสายไว้ที่ 50 ฟุต (หรือประมาณ 15 เมตร) สำหรับการส่งสัญญาณที่ความเร็ว 19,200 บิตต่อวินาที โดยที่ความยาวสายจะต้องสั้นลงถ้าต้องการสื่อสารที่ความเร็วสูงขึ้น และถ้ามีสัญญาณรบกวนมากๆ เช่นในโรงงาน หรือบริเวณใกล้เครื่องจักรที่เป็นแบบมีการสวิตซ์สัญญาณไฟฟ้าที่กระแสดูๆ ก็จะทำให้ต้องมีการลดความเร็วในการส่งสัญญาณลงหรือใช้สายที่สั้นลง



รูปที่ 2.18 การเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกเข้ากับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย DB9



รูปที่ 2.19 การต่ออุปกรณ์ภายนอกผ่าน DB9 แบบ 3 เส้น

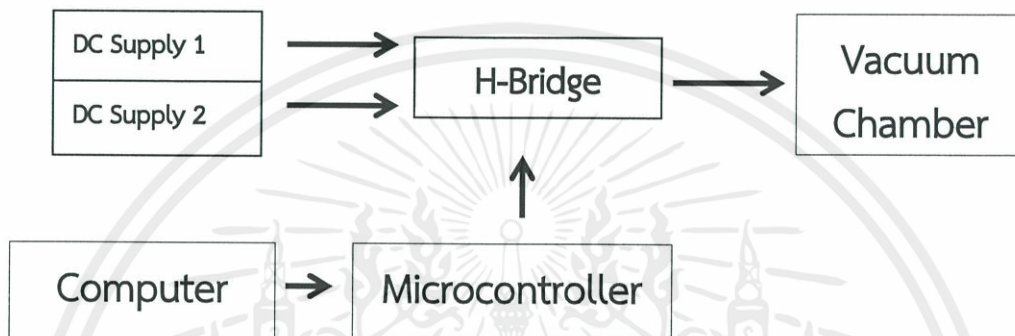


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 3

การออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบ

การออกแบบและสร้างแหล่งจ่ายไฟฟ้าดิจิทัลให้เหมาะสมกับการเคลือบฟิล์มบางให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุดนั้นจะต้องออกแบบให้มีความคงทนต่อแรงดันไฟฟ้าที่มีค่าสูง ขนาดกะทัดรัด โดยใช้การสวิตซ์แบบอะซิมเมตริกไบโพลาร์ซึ่งมีข้อดีเหนือกว่าการสวิตซ์แบบอื่นหลายประการ บล็อกไดอะแกรมรวมของระบบแสดงไว้ดังรูป

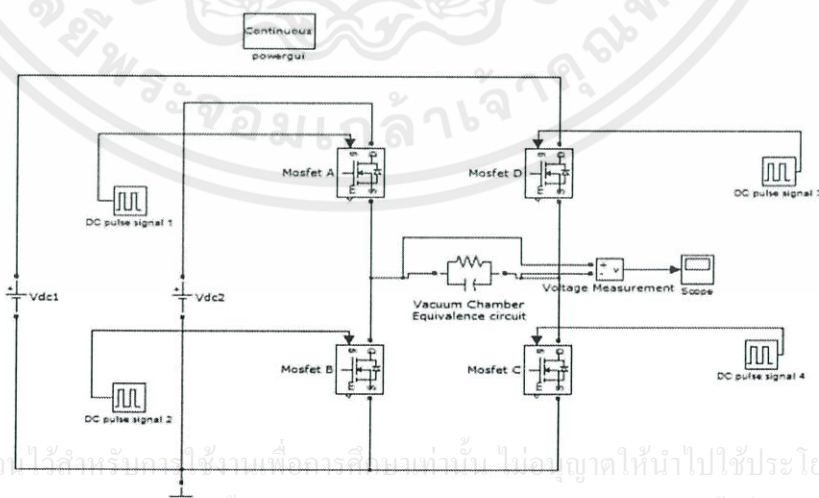


รูปที่ 3.1 Block Diagram ของระบบ

จากรูปที่ 3.1 ส่วนประกอบหลักของระบบที่ต้องสร้างขึ้นมาคือส่วนของวงจร H-Bridge วงจรควบคุม การโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ และการสร้างการควบคุมผ่านพอร์ตอนุกรมด้วยคอมพิวเตอร์ ดังนั้น ก่อนการสร้างเครื่องต้นแบบของจริงนั้นจะต้องจำลองในโปรแกรมเสียก่อน

3.1 การจำลองวงจร (Simulation)

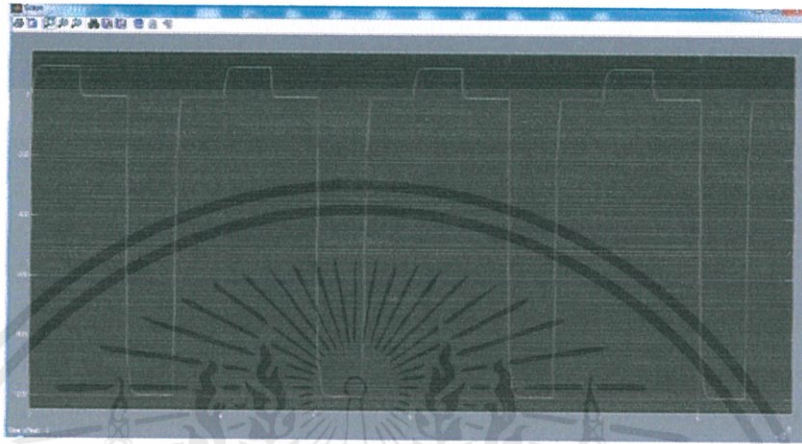
การจำลองวงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้าดิจิทัลด้วยโปรแกรม MATLAB Simulink



รูปที่ 3.2 การจำลองแหล่งจ่ายไฟฟ้าดิจิทัลด้วยโปรแกรม MATLAB Simulink

จากรูปด้านบนนี้ จะใช้สัญญาณควบคุมสวิตซ์ทั้งสี่ตัว มีแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูงปรับค่าได้สองชุดต่อเข้ากับวงจร H-Bridge และจำลองโหลดที่เป็นห้องสุญญากาศด้วยวงจร R-C ขนานซึ่งเป็นวงจรสมมูลอย่างง่ายของระบบแมกนีตรอนสปีดเตอร์ริง

จากนั้น กำหนดค่าการจำลองต่างๆ กำหนดให้ความถี่ของขบวนการคลื่นสี่เหลี่ยมเป็น 50 kHz จะได้รูปคลื่นแรงดันขาออกจาก H-Bridge ดังรูป



รูปที่ 3.3 แรงดันขาออกจากวงจรที่ได้จากการจำลองด้วยโปรแกรม MATLAB Simulink

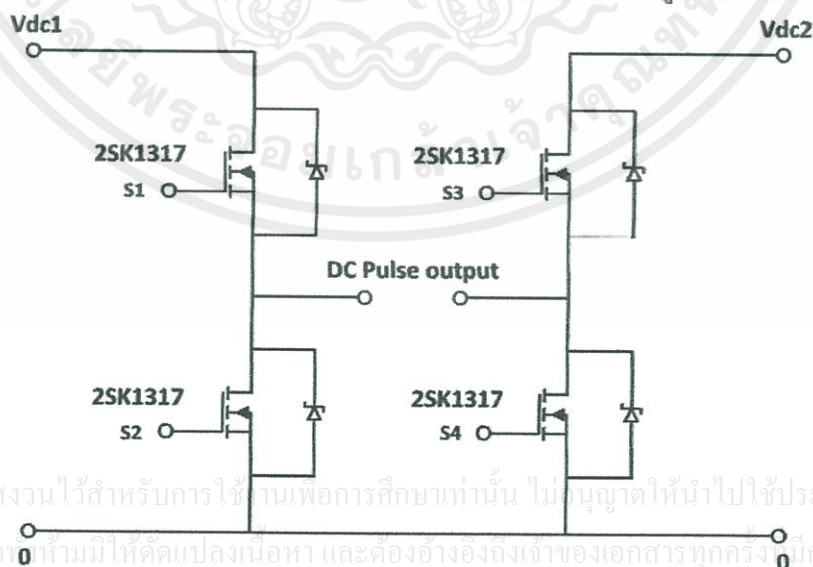
จากรูปที่ 3.3 ให้แหล่งจ่าย $V_{DC,1}$ จ่ายแรงดัน 100 V และ แหล่งจ่าย $V_{DC,2}$ จ่ายแรงดัน 1000 V

3.2 การสร้างวงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้าสี่เหลี่ยม

3.2.1 การสร้างวงจรกำลัง

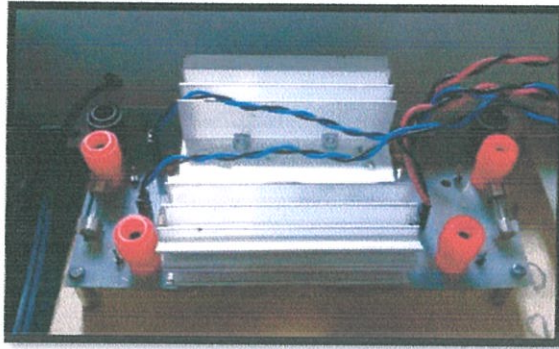
3.2.1.1 ออกแบบวงจรกำลัง

วงจรกำลังของแหล่งจ่ายไฟฟ้าสี่เหลี่ยมจะต้องมีแรงดันขาออกเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่ปรับค่าตัวแปรได้ตามหัวข้อ 2.2.4 ดังนั้น วงจรกำลังที่ออกแบบจะมีรูปร่างดังนี้



รูปที่ 3.4 รูปแบบวงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้าสี่เหลี่ยม

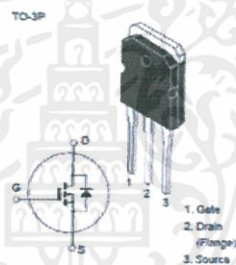
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกกรณีมีการนำไปใช้



รูปที่ 3.5 วงจรกำลังที่สร้างขึ้นจริง

3.2.1.2 ชนิดของมอสเฟตกำลัง

เนื่องจากวงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้าดีซีฟิลส์นั้นจะต้องสามารถจ่ายกำลังไฟฟ้าได้ถึง 1000 V ดังนั้นมอสเฟตที่ใช้จะต้องทนแรงดันได้ถึง 1000 V ขึ้นไป จึงเลือกใช้มอสเฟตกำลังเบอร์ 2SK1317 ที่สามารถทนแรงดันได้ถึง 1,500 V และสามารถทนกระแสได้ 2.5 A



Application

High speed power switching

Features

- High breakdown voltage $V_{DSS} = 1500\text{ V}$
- High speed switching
- Low drive current
- No secondary breakdown
- Suitable for switching regulator, DC-DC converter and motor driver

รูปที่ 3.6 มอสเฟตกำลัง 2SK1317

3.2.1.3 แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าแรงสูงสองเอ้าท์พุท

แหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูงปรับค่าได้จะใช้อุปกรณ์รุ่น Pinnacle 2/2 kW DC 11/12 Operation สามารถจ่ายแรงดันสูงสุด 1kV ได้สองเอ้าท์พุท



รูปที่ 3.7 แหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูงปรับค่าได้ที่ใช้ในการทำการทดลอง

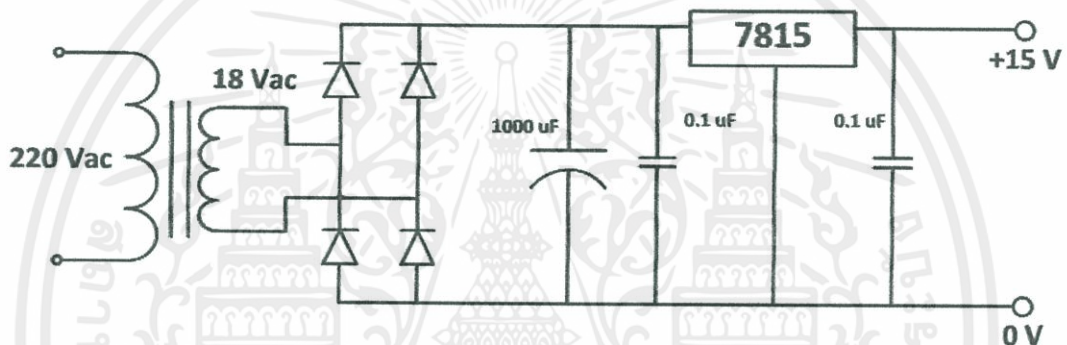
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้พดัดแปลงเนื้อหาหรือโครงสร้างของเอกสารชุดนี้ซึ่งจะมีการนำไปใช้

3.2.2 การสร้างวงจรควบคุม

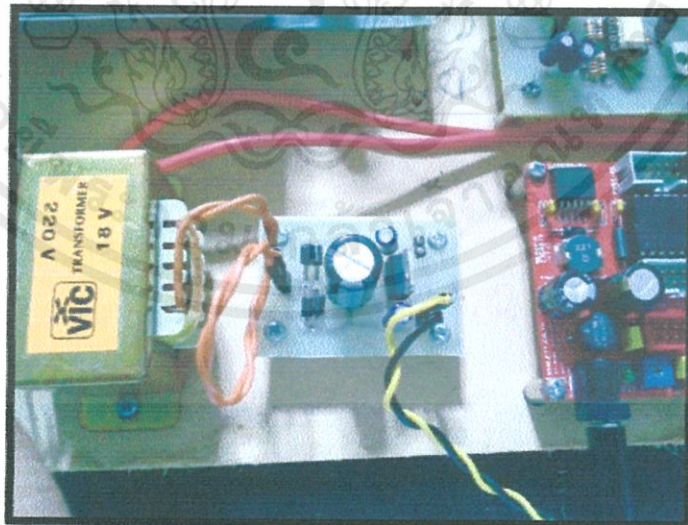
3.2.2.1 วงจรไฟเลี้ยง (Power Supply)

วงจรไฟเลี้ยงที่ออกแบบจะใช้หม้อแปลงไฟฟ้า 220 / 18 V ต่อเข้ากับวงจรเรียงกระแสแบบเต็มคลื่น กรองกระแสไฟฟ้าให้เรียบด้วยตัวเก็บประจุขนาด 1000 μF จากนั้นใช้โวลเตจเรกูเลเตอร์เบอร์ 7815 เพื่อจำกัดแรงดันให้เหลือ 15 V

วงจรไฟเลี้ยงนี้นั้นทำขึ้นมาห้าววงจร สี่วงจรแรกจ่ายแรงดันไฟตรง 15 V เพื่อเป็นไฟเลี้ยงของวงจรขับเคลื่อน (Gate driver circuit) ส่วนวงจรที่สองนั้นจะจ่ายแรงดันไฟตรง 15 V เพื่อเป็นไฟเลี้ยงของบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ สาเหตุที่ต้องแยกวงจรไฟเลี้ยงออกเป็นสองวงจรก็เพราะต้องการจะให้วงจรขับเคลื่อนซึ่งเชื่อมกันทางไฟฟ้าอยู่กับวงจรกำลังนั้นแยกอิสระกับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ถ้าหากเกิดความผิดปกติขึ้นในวงจรกำลัง ความผิดปกตินั้นจะได้ไม่ส่งผลกระทบต่อบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์



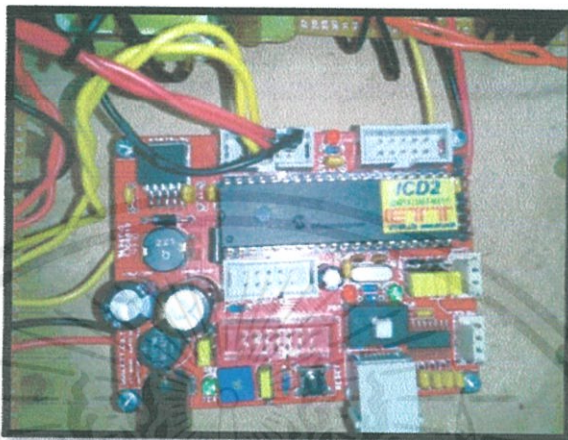
รูปที่ 3.8 วงจรไฟเลี้ยงกระแสตรง 15 V เพื่อเป็นไฟเลี้ยงบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการ **รูปที่ 3.9** วงจรไฟเลี้ยงที่สร้างขึ้นจริง ภาควิชาไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.2.2.2 วงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller Circuit)

วงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ใช้จะใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์รุ่น dsPIC30F4011 ซึ่งเป็นบอร์ดสำเร็จรูป ใช้กำเนิดสัญญาณขับเคลื่อนซีพียูที่ 5 V ด้วยการเขียนโปรแกรมภาษาซีผ่านโปรแกรม MPLAB IDE 8.84

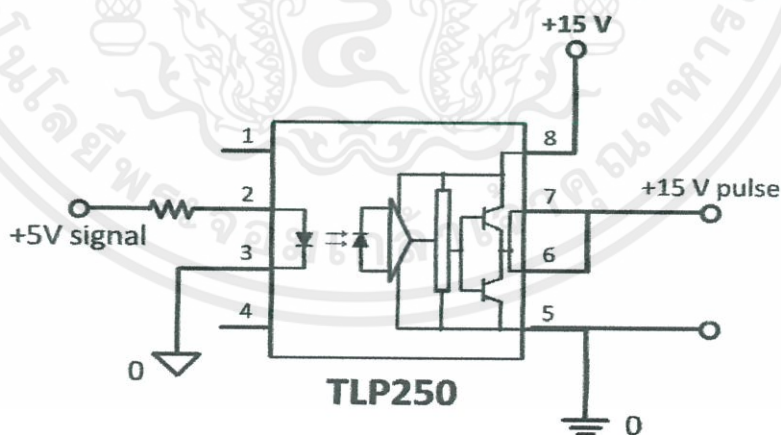


รูปที่ 3.10 บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ รุ่น dsPIC30F4011

3.2.2.3 การแยกกราวด์ด้วยแสง (Opto-isolator)

การแยกกราวด์ด้วยแสงคือการทำให้อุปกรณ์แยกกันอย่างอิสระทางไฟฟ้า โดยใช้อุปกรณ์ทางแสงที่เรียกว่าออปโตคัปเปิล (Optocoupler)

หลักการของออปโตคัปเปิลคือการนำสัญญาณมาผ่านไดโอดเปล่งแสง (LED) แสงที่ปรากฏจะไปกระตุ้นให้ทรานซิสเตอร์ทางแสง (Phototransistor) สามารถนำกระแสได้ ทำให้ได้รูปสัญญาณที่เหมือนกันแหล่งกำเนิดออกมาจากอีกด้านหนึ่งของออปโตคัปเปิล



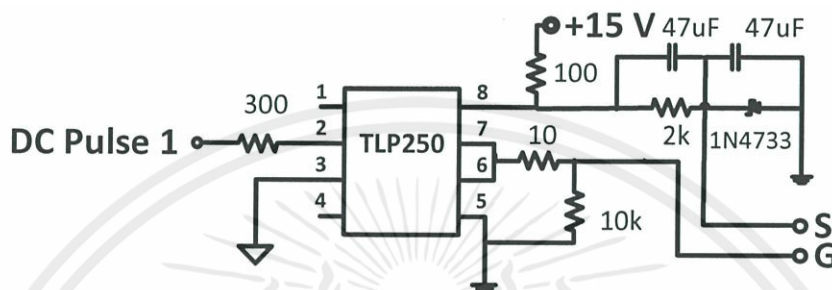
รูปที่ 3.11 หลักการทำงานของออปโตคัปเปิล

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์ 3.2.2.4 วงจรขับเคลื่อนและแยกกราวด์ (Gate Driver and isolate Circuit) ให้นำไปใช้โดยไม่แจ้งชื่อผู้จัดทำ

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ข้อมูลประสงค์ของวงจรขับเคลื่อนและแยกกราวด์คือเพื่อใช้ในการขับนำอุปกรณ์ สวิตซ์ิ่งและแยกวงจรควบคุมกับวงจรกำลังกันโดยเชื่อมต่อกันด้วยแสงเพื่อป้องกันความเสียหายจาก

วงจรกำลังส่งผลสู่วงจรควบคุม โดยวงจรขับเคลื่อนจะสร้างแรงดันที่เพียงพอที่จะนำไปขับขาเกตเพื่อที่จะทำให้มอสเฟตกำลังสามารถทำงาน (on) หรือหยุดทำงานได้ (off)

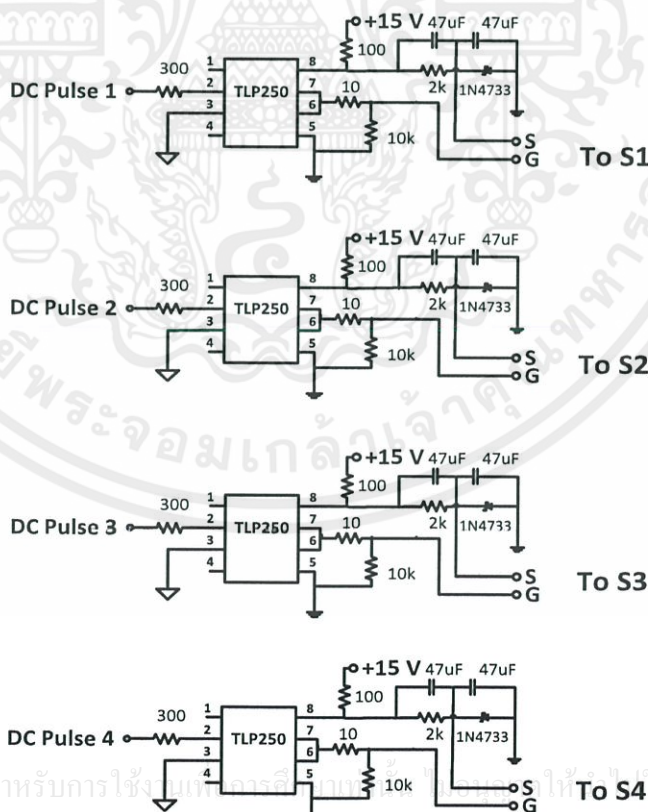
โดยภายในวงจรจะมี Opto-Isolator ซึ่งทำหน้าที่แยกวงจรระหว่างส่วนวงจรควบคุมออกจากวงจรกำลัง และด้านของแรงดันวงจรขับเคลื่อนและแยกกราวด์จะให้ทั้งแรงดันบวกและแรงดันลบโดยที่แรงดันทางด้านบวกจะมีค่าไม่น้อยกว่า 8 โวลต์ และแรงดันทางด้านลบจะมีค่าประมาณ -5 โวลต์ เพื่อให้มอสเฟตมีการคายประจุให้เรียบร้อยก่อนแล้วจึงทำงานใหม่



รูปที่ 3.12 วงจรขับเคลื่อนและแยกกราวด์

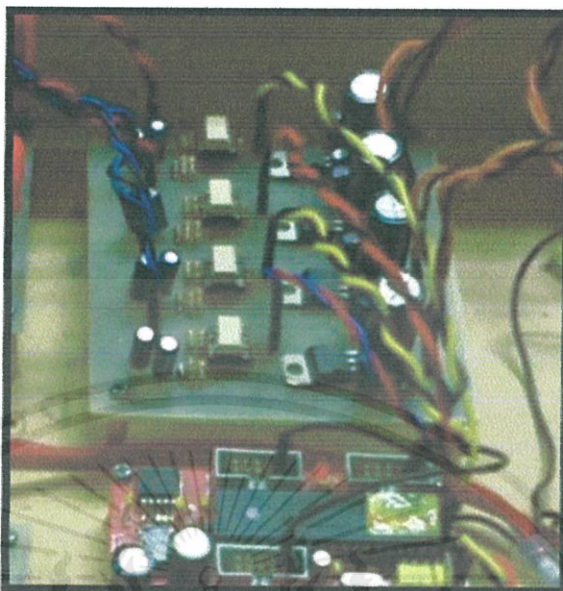
3.2.2.5 ภาพรวมของวงจรควบคุม

ภาพรวมของวงจรควบคุมจะมีลักษณะดังรูป



รูปที่ 3.13 ภาพรวมของวงจรควบคุม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเท่านั้น ไม่ควรเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี



รูปที่ 3.14 รูปวงจรขับเคลื่อนและวงจรออปโตไอโซเลเตอร์ที่สร้างขึ้นจริง



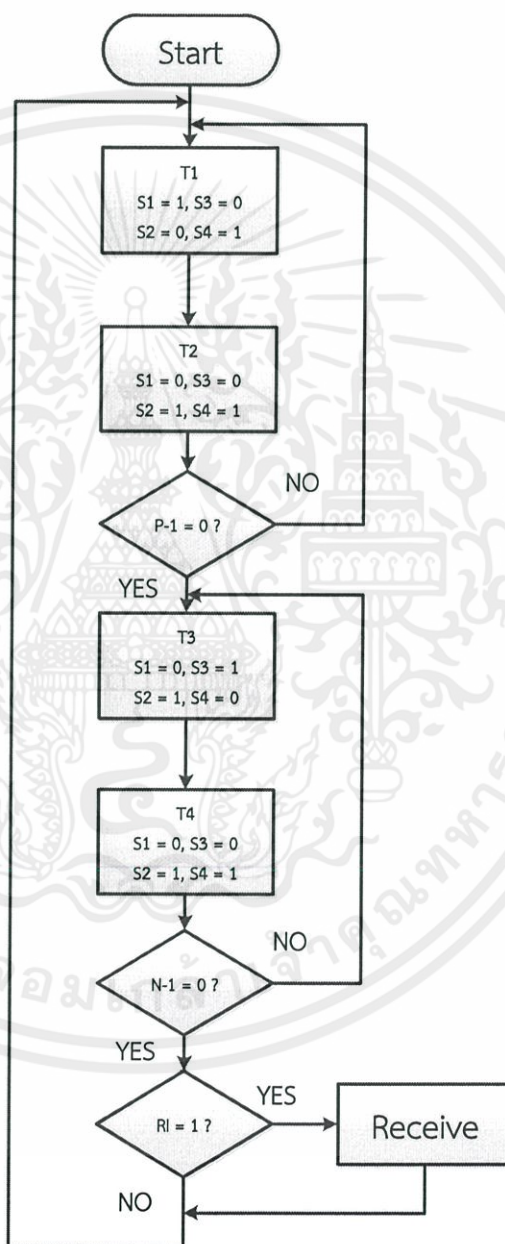
รูปที่ 3.15 วงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้าดิจิทัลสแตนด์บายที่สร้างขึ้นจริง

3.2.3 การสร้างสัญญาณขับเคลื่อนด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์

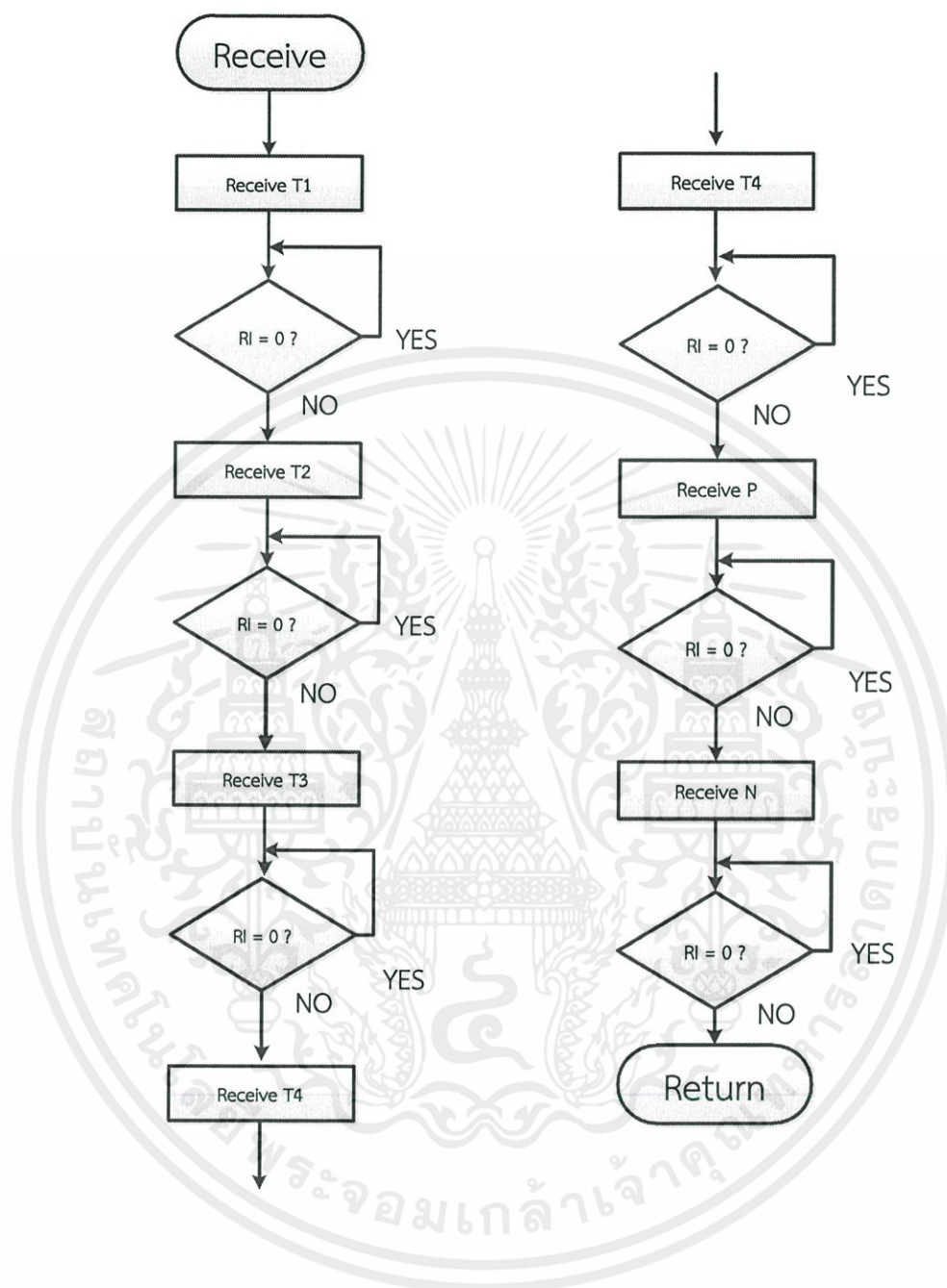
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวน **3.2.3.1 โฟลวชาร์ต (Flowchart)** มาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดลอก โฟลวชาร์ตของการโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์จะทำการวนลูปค่า T1 ถึง T4 ไปเรื่อยๆ และเมื่อมีการรับค่าจากพอร์ตอนุกรมเกิดขึ้น โปรแกรมจะขัดจังหวะ (Interrupt)

การทำงานของโปรแกรมหลัก (Main Routine) เพื่อรับค่า T1 ถึง T4, P และ N ที่ส่งเข้ามาจากพอร์ตอนุกรม ดังนั้น โฟลวชาร์ตของโปรแกรมควบคุมการทำงานของแหล่งจ่ายไฟฟ้าดีซีฟิลส์จะแบ่งเป็น โฟลวชาร์ตของโปรแกรมหลัก (Main Routine) และ โปรแกรมย่อย (Sub Routine) ดังนี้



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับ **รูปที่ 3.16** โฟลวชาร์ตของโปรแกรมหลักให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

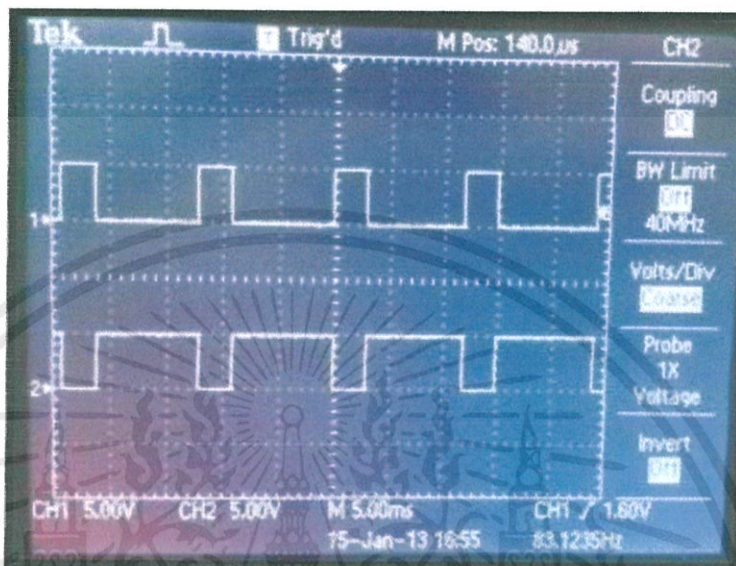


รูปที่ 3.17 โฟลวชาร์ตของวงจรร้อย

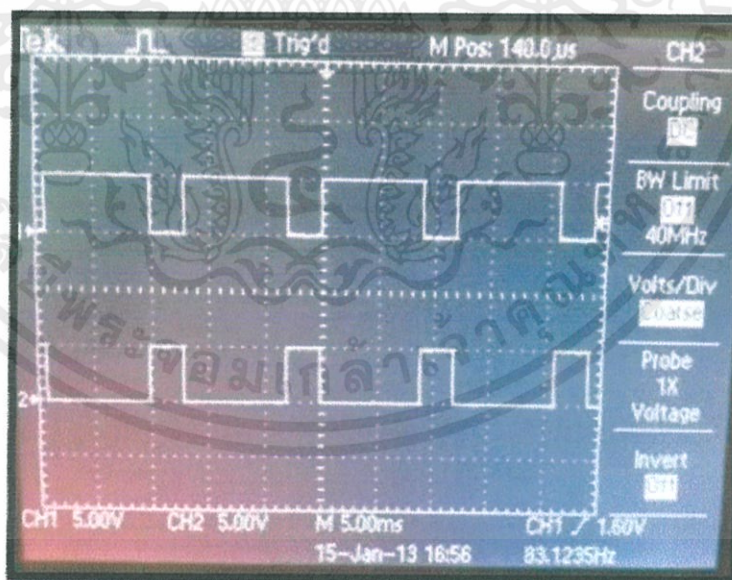
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.2.3.2 รูปคลื่นดิจิทัลที่ได้จากการโปรแกรม

จากการโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อสร้างรูปคลื่นดิจิทัลตามที่ต้องการนั้นจะได้รูปคลื่นที่จะไปขับขาเกตของมอสเฟตทั้งสองตัวดังนี้

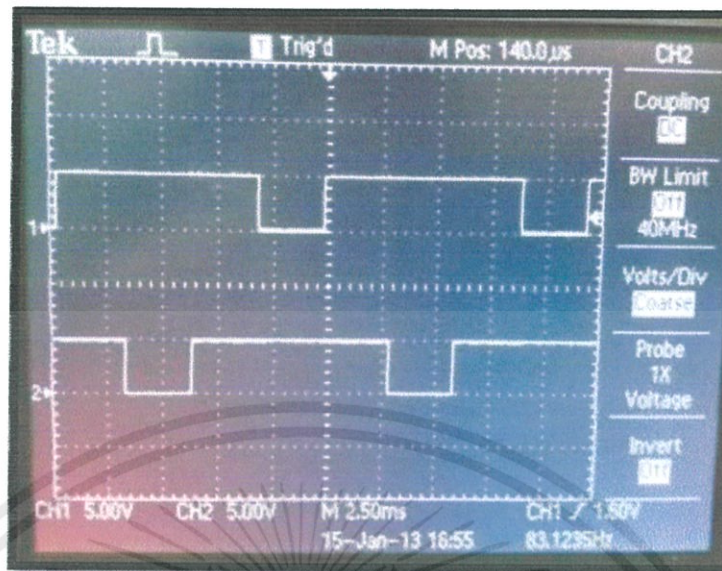


รูปที่ 3.18 สัญญาณขับขาเกตของมอสเฟต S1 (บน) และมอสเฟต S2 (ล่าง)

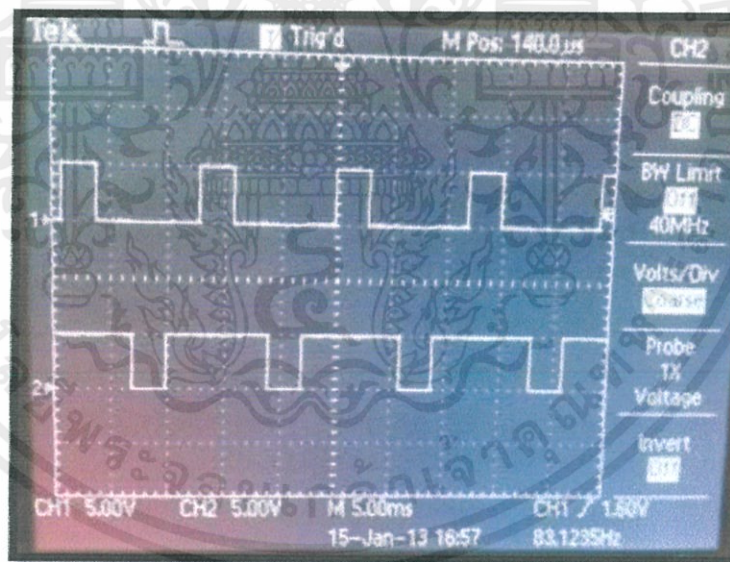


รูปที่ 3.19 สัญญาณขับขาเกตของมอสเฟต S3 (บน) และมอสเฟต S4 (ล่าง)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

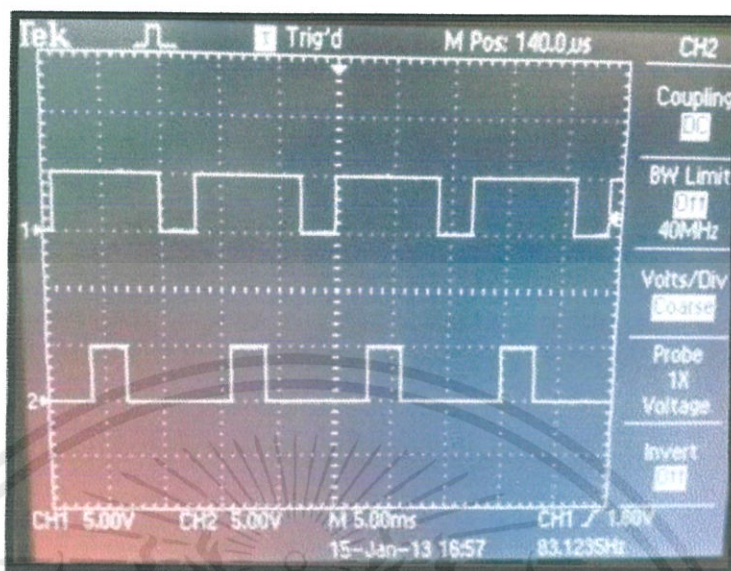


รูปที่ 3.20 สัญญาณขั้วขาเกิดของมอสเฟต S2 (บน) และมอสเฟต S3 (ล่าง)



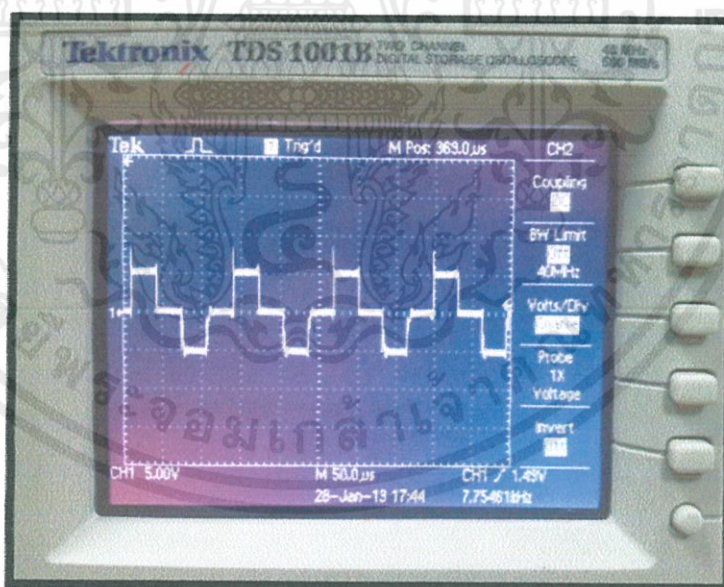
รูปที่ 3.21 สัญญาณขั้วขาเกิดของมอสเฟต S1 (บน) และมอสเฟต S3 (ล่าง)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 3.22 สัญญาณขั้วขาเกิดของมอสเฟต S2 (บน) และมอสเฟต S4 (ล่าง)

เมื่อได้สัญญาณขั้วนำสวิตซ์ทั้งสี่ตัวแล้ว จะได้แรงดันขาออกของวงจรกำลังดังรูปต่อไปนี่ ซึ่งเป็นรูปคลื่นมาตรฐานของแหล่งจ่ายไฟฟ้าดีซีพัลส์แบบซิมเมตริกไบโพล่า



รูปที่ 3.23 สัญญาณแรงดันขาออกของวงจรกำลังแบบซิมเมตริกไบโพล่า

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.3 การสร้างการควบคุมผ่านคอมพิวเตอร์ (Computer Control Panel)

3.3.1 การรับส่งข้อมูลออกจากพอร์ตอนุกรมสู่ไมโครคอนโทรลเลอร์

การส่งข้อมูลผ่านพอร์ตอนุกรมเข้าสู่ไมโครคอนโทรลเลอร์นั้นจะต้องส่งข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์ขาที่ 3 (TX) ซึ่งการที่ไมโครคอนโทรลเลอร์จะสามารถรับข้อมูลมาได้อย่างถูกต้องนั้นจะต้องตั้งค่าอัตราการรับข้อมูล (Baud Rate) ของไมโครคอนโทรลเลอร์ให้ตรงกับอัตราการส่งข้อมูลของคอมพิวเตอร์ โดยการส่งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์นั้นสามารถทำได้หลายวิธี วิธีที่ใช้โดยทั่วไปคือการส่งข้อมูลด้วยโปรแกรมไฮเปอร์เทอร์มินอล (Hyperterminal) ซึ่งอินเตอร์เฟซของโปรแกรมไฮเปอร์เทอร์มินอลนั้นจะแสดงไว้ดังรูปที่ 3.25 ส่วนวิธีที่สามารถทำการส่งข้อมูลได้หลายรูปแบบขึ้นสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การใช้โปรแกรม Visual Basic 6.0 ซึ่งสามารถตั้งค่าการส่งข้อมูลและสร้างอินเตอร์เฟซขึ้นมาได้

ส่วนทางด้าน การตั้งค่าไมโครคอนโทรลเลอร์นั้นต้องตั้งค่าให้อัตราการรับส่งข้อมูลและจำนวนบิตที่จะรับต่อข้อมูลหนึ่งชิ้นให้ตรงกับข้อมูลที่ได้รับจากคอมพิวเตอร์ โดยขณะที่มีข้อมูลเข้ามาทางพอร์ตอนุกรม ไมโครคอนโทรลเลอร์จะทำการขัดจังหวะ (Interrupt) โปรแกรมหลักเพื่อเข้าสู่การวนลูปปรับค่าพารามิเตอร์ต่างๆ เมื่อรับข้อมูลจนครบทุกค่าตามที่ต้องการแล้ว โปรแกรมจะกลับเข้าสู่โปรแกรมหลักและแสดงผลด้วยค่าพารามิเตอร์ที่ใส่เข้าไปใหม่ต่อไป



รูปที่ 3.24 พอร์ตอนุกรมของบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์



รูปที่ 3.25 การเชื่อมต่อพอร์ตอนุกรมระหว่างคอมพิวเตอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานภายในเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมีเหตุดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งหากนำไปใช้

3.3.2 การควบคุมพารามิเตอร์สัญญาณโดยโปรแกรม Visual Basic 6.0

3.3.2.1 Visual Basic

จากการทำการทดลองวงจรแหล่งจ่ายดีซีพัลส์แมกนีตรอนสปีดเตอร์จึงจำเป็นต้องมีการปรับค่าคาบของคลื่นพัลส์และจำนวนคลื่นพัลส์ให้ได้ลักษณะคลื่นพัลส์ที่เหมาะสมกับการใช้งานในรูปแบบต่างๆ จึงมีการนำโปรแกรม Visual Basic มาเป็นตัวกลางในการรับคำสั่งจากผู้ใช้งานและส่งข้อมูลไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์ให้ปรับค่าตามคำสั่งนั้น ดังนั้นโปรแกรม Visual Basic จึงเป็นตัวช่วยให้การปรับค่าคาบของคลื่นพัลส์และจำนวนคลื่นพัลส์ในไมโครคอนโทรลเลอร์ได้ง่ายยิ่งขึ้น ในที่นี้กลุ่มผู้จัดทำได้ใช้โปรแกรม Visual Basic 6.0

3.3.2.2 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Visual Basic

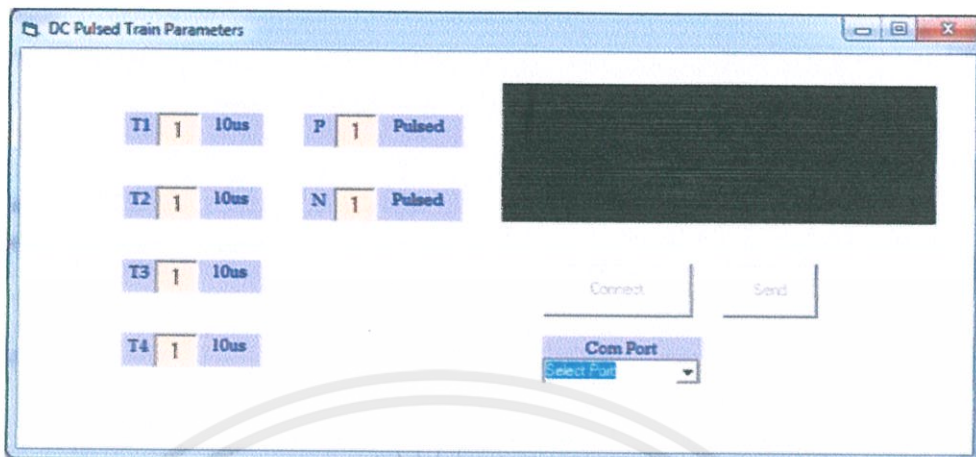
Visual Basic เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ ที่มีประสิทธิภาพสูง และออกแบบมาเพื่อทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows คำว่า Visual หมายถึงวิธีการที่ใช้สร้างติดต่อกับผู้ใช้แบบกราฟิก (GUI : Graphic User Interface) ส่วน BASIC เป็นคำที่ย่อมาจาก (Beginner All-Purpose Symbolic Instruction Code) แต่ก่อนนั้นการสร้างแอปพลิเคชัน (Application) จะถูกเรียกว่าการเขียนโปรแกรม โดยในอดีตการเขียนโปรแกรมเป็นเรื่องยุ่งยากสำหรับคนทั่วไป อีกทั้งโปรแกรมที่ถูกเขียนขึ้นมาก็ใช้งานยาก ดังนั้นจึงได้มีการนำเสนอการเขียนโปรแกรมแบบ Visual Programming ขึ้นมา ซึ่งรูปแบบก็คือ การเขียนโปรแกรมไปพร้อม ๆ กับการเห็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น มีเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการเขียนโปรแกรมมากขึ้น

แนวทางการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Visual Basic จะเป็นไปในลักษณะการนำคอนโทรลชนิดต่างๆ เช่น TextBox, Label, ComboBox เป็นต้น นำมาวาง เพื่อออกแบบหน้าต่างแอปพลิเคชันที่เรียกว่า กราฟิกยูสเซอร์ อินเตอร์เฟซ (Graphic User Interface-GUI) สามารถที่จะออกแบบอินเตอร์เฟซได้อย่างอิสระให้ตรงกับจุดประสงค์ และเป็นการนำไปใช้งานก่อนแล้วจึงเริ่มเขียนโค้ด ซึ่งถือเป็นหลักการเขียนโปรแกรมที่เรียกว่า การเขียนโปรแกรมเพื่อตอบสนองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น (Event-Driven Programming)

3.3.2.3 การสร้างอินเตอร์เฟซด้วยโปรแกรม Visual Basic 6.0

การส่งข้อมูลให้สะดวก รวดเร็ว และไม่ยุ่งยากสามารถทำได้ด้วยการสร้างอินเตอร์เฟซ อินเตอร์เฟซที่สร้างนั้นสามารถกรอกค่าพารามิเตอร์ทุกตัวได้อย่างอิสระ และสามารถส่งข้อมูลได้เป็นชุดทั้งหมดในครั้งเดียว อินเตอร์เฟซที่สร้างมาจะแสดงไว้ดังรูปที่ 3.26

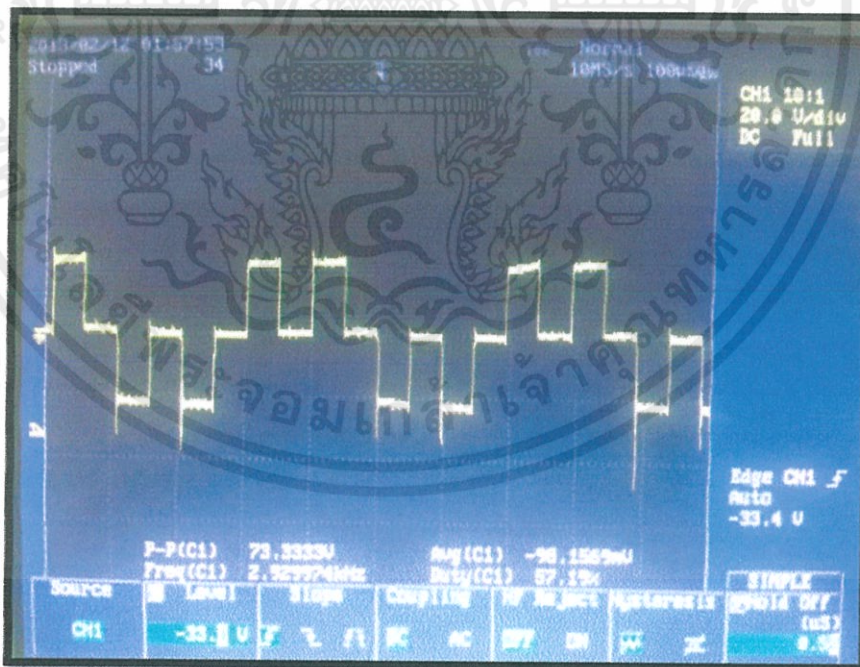
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 3.26 อินเตอร์เฟสเพื่อควบคุมแหล่งจ่ายไฟฟ้าดิจิทัล

3.3.3 รูปคลื่นดิจิทัลที่ได้จากการควบคุมผ่านคอมพิวเตอร์

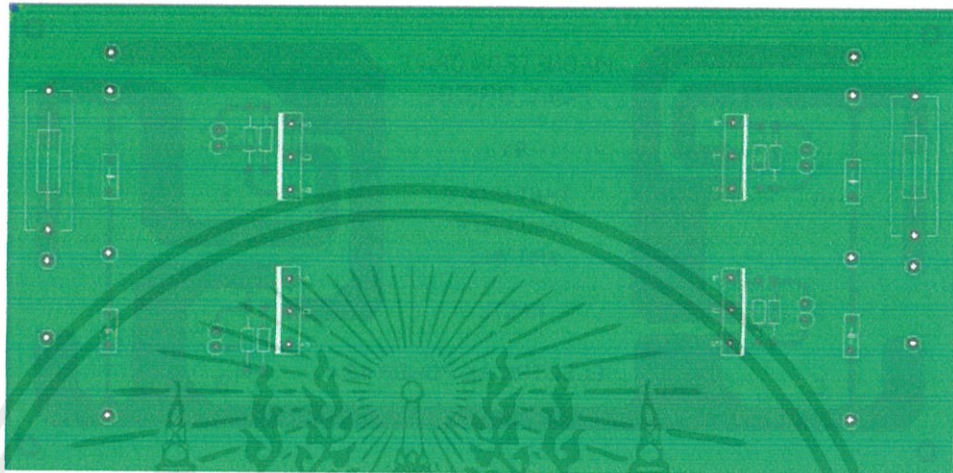
จากการทดลองควบคุมพารามิเตอร์ของแหล่งจ่ายไฟฟ้าดิจิทัลผ่านการส่งข้อมูลด้วยอินเตอร์เฟสของโปรแกรม Visual Basic 6.0 โดยตั้งค่าพารามิเตอร์ให้เป็นแบบซิมเมตริกไบโพลาร์จะเป็นดังรูปที่ 3.27



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์ โดยผู้จัดทำเอกสารนี้ไว้เพื่อประโยชน์ด้านการค้า
รูปที่ 3.27 รูปคลื่นพัลส์ที่ถูกควบคุมผ่านโปรแกรม Visual Basic 6.0
 ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.4 ลายปรีนของวงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้าดิจิทัล

3.4.1 ลายปรีนของวงจร H-Bridge



ก)

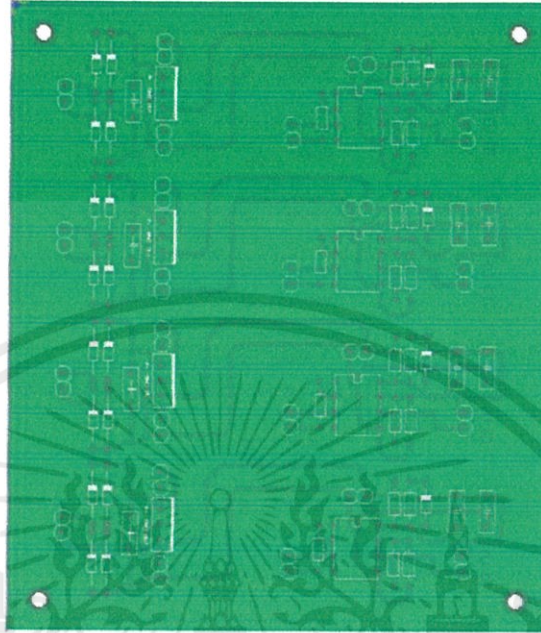


ข)

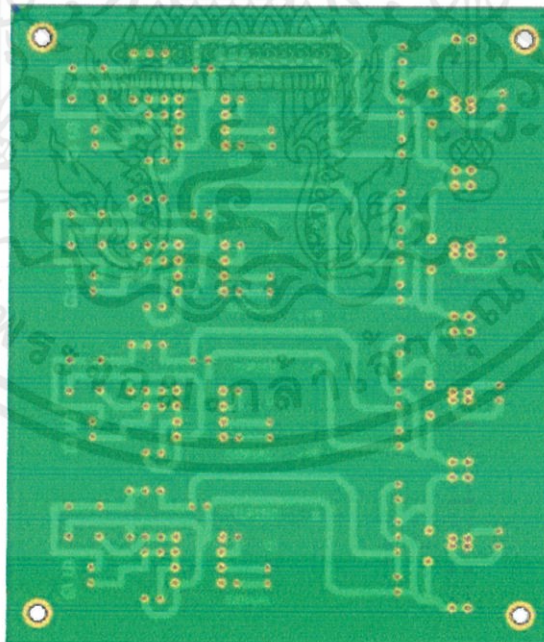
รูปที่ 3.28 ก) ลายวงจร H-Bridge ด้านบน ข) ลายวงจร H-Bridge ด้านล่าง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.4.2 ลายปรีนของวงจรขับเคลื่อนและแยกกราวด์



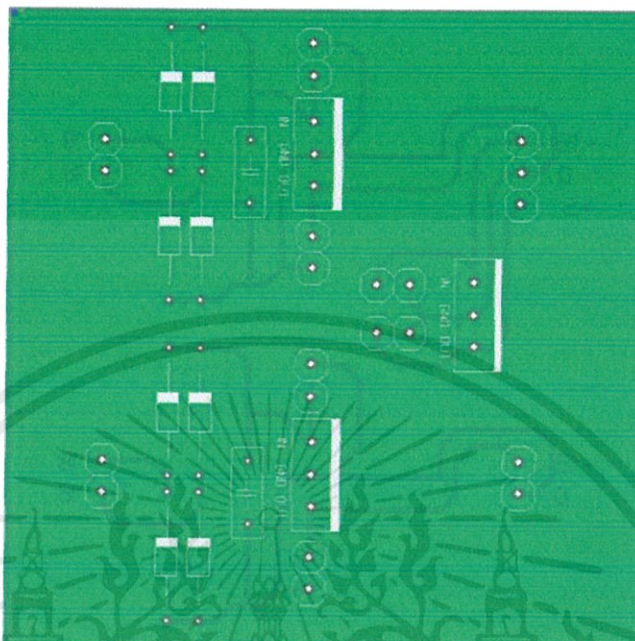
ก)



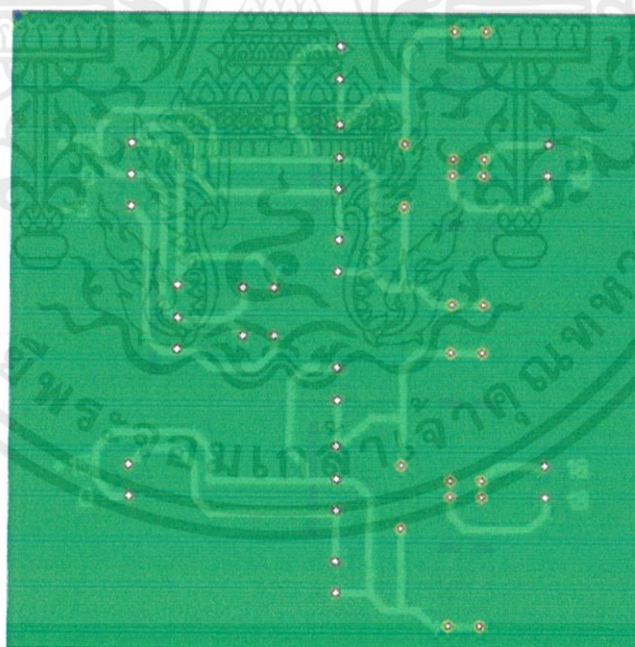
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

รูปที่ 3.29 ก) ลายวงจรขับเคลื่อนด้านบน ข) ลายวงจรขับเคลื่อนด้านล่าง

3.4.3 ลายปรีนของวงจรไฟเลี้ยง



ก)



ข)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวน **รูปที่ 3.30** ก) ลายวงจรไฟเลี้ยงด้านบน ข) ลายวงจรไฟเลี้ยงด้านล่าง ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.4 สรุป

จากข้อมูลทั้งหมดในบทนี้จะแสดงถึงรายละเอียดของวงจรในแต่ละส่วนของโครงการ คือ ผลการจำลองวงจรในสภาวะต่างๆ วงจรขับเคลื่อนและแยกกราวด์ วงจรกำลัง (H-Bridge) วงจรไฟเลี้ยงวงจรขับเคลื่อนและไมโครคอนโทรลเลอร์พอร์ตอนุกรม การอินเตอร์เฟสด้วยโปรแกรม Visual Basic 6.0 โพลชาร์ตของโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ รูปคลื่นสัญญาณจากไมโครคอนโทรลเลอร์ และแสดงรูปคลื่นที่ได้จากการควบคุมผ่านพอร์ตอนุกรม ซึ่งจะเห็นว่าวงจรรวมของแหล่งจ่ายไฟฟ้าดีซีพัลส์นั้นสามารถสร้างขบวนคลื่นดีซีพัลส์ได้ตรงกับผลการจำลองด้วยโปรแกรม MATLAB และสามารถปรับค่าพารามิเตอร์ต่างๆได้ด้วยการควบคุมผ่านพอร์ตอนุกรม



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 4

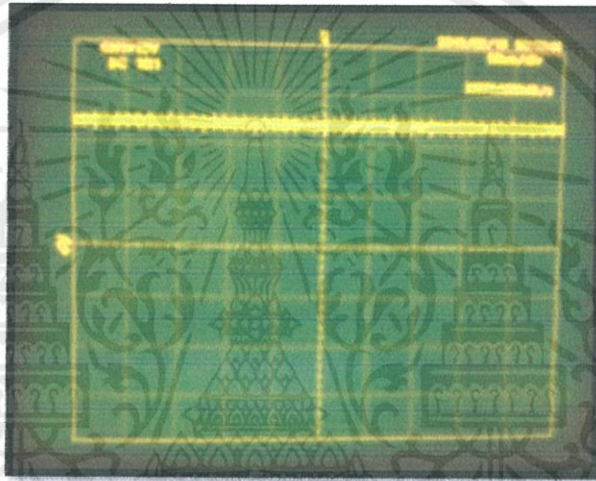
ผลการทดลอง

4.1 ผลการทดสอบแหล่งจ่ายไฟฟ้าดีซีฟิลส์

แรงดันขาออกของแหล่งจ่ายไฟฟ้าดีซีฟิลส์สามารถปรับการทำงานได้หกแบบดังกล่าวไปแล้วข้างต้น ผลการทดสอบแรงดันไฟฟ้าขาออกของวงจรจะแสดงดังต่อไปนี้

4.1.1 แรงดันขาออกในโหมด Positive DC

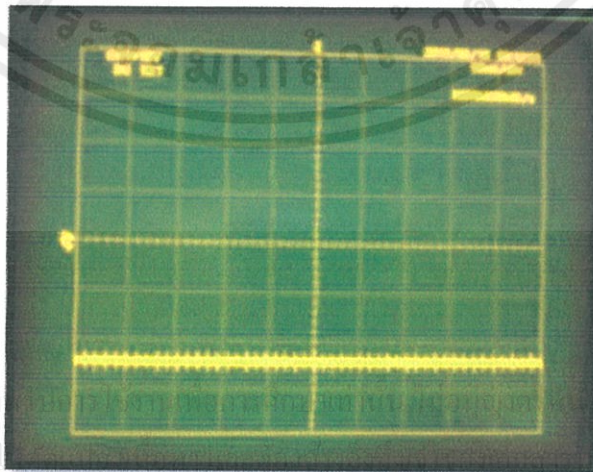
โหมด Positive DC จะมีแรงดันขาออกด้านเดียวเท่ากับ V_{dc1} และมี V_{dc2} เท่ากับ ศูนย์ การสวิตช์จะใช้ S1 และ S4 ให้ on ตลอดเวลา ผลการทดลองแสดงไว้ดังรูป



รูปที่ 4.1 แรงดันขาออกในโหมด Positive DC

4.1.2 แรงดันขาออกในโหมด Negative DC

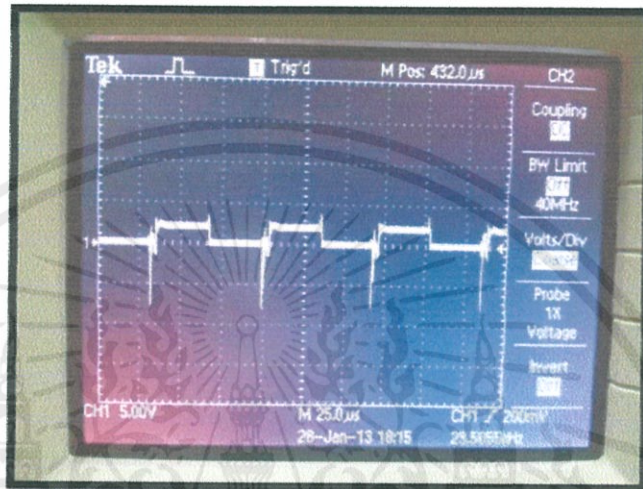
โหมด Negative DC จะมีแรงดันขาออกด้านเดียวเท่ากับ V_{dc2} และมี V_{dc1} เท่ากับ ศูนย์ การสวิตช์จะใช้ S2 และ S3 ให้ on ตลอดเวลา ผลการทดลองแสดงไว้ดังรูป



รูปที่ 4.2 แรงดันขาออกในโหมด Negative DC

4.1.3 แรงดันขาออกในโหมด Positive Unipolar

โหมด Positive Unipolar จะมีแรงดันขาออกในลักษณะรูปขบวนคลื่นพัลส์ด้านบวกด้านเดียว มีแรงดันเท่ากับ V_{dc1} การสวิตช์จะใช้คู่ S1 และ S4 กับคู่ S2 และ S4 ทำงานสลับกัน โดยช่วงที่ S1 และ S4 on จะเป็นเวลา T1 ส่วนช่วงที่ S2 และ S4 on จะเป็นเวลา T2 ซึ่ง T1 และ T2 นั้นสามารถปรับค่าได้



รูปที่ 4.3 แรงดันขาออกในโหมด Positive Unipolar

4.1.4 แรงดันขาออกในโหมด Negative Unipolar

โหมด Negative Unipolar จะมีแรงดันขาออกในลักษณะรูปขบวนคลื่นพัลส์ด้านลบด้านเดียว มีแรงดันเท่ากับ V_{dc2} การสวิตช์จะใช้คู่ S2 และ S3 กับคู่ S2 และ S4 ทำงานสลับกัน โดยช่วงที่ S2 และ S3 on จะเป็นเวลา T3 ส่วนช่วงที่ S2 และ S4 on จะเป็นเวลา T4 ซึ่ง T3 และ T4 นั้นสามารถปรับค่าได้

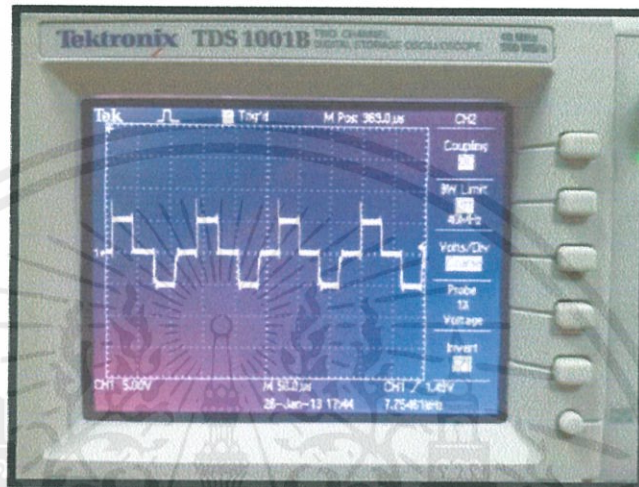


รูปที่ 4.4 แรงดันขาออกในโหมด Negative Unipolar

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับใช้เฉพาะงานเพื่อการศึกษารวบรวม ไม่นับรวมค่าเงิน ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.1.5 แรงดันขาออกในโหมด Symmetric Bipolar

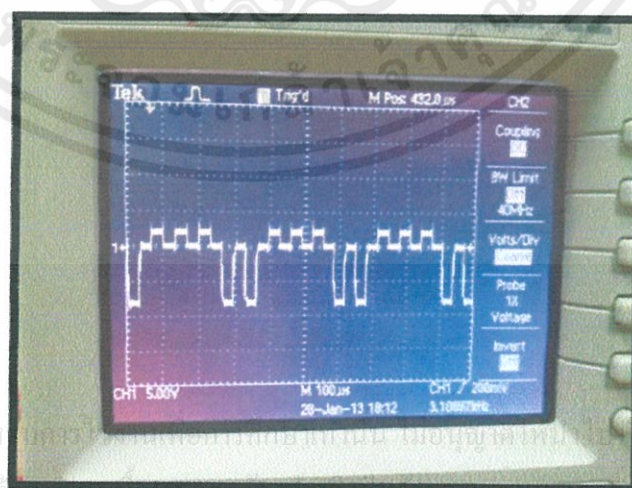
โหมด Symmetric Bipolar นั้น จะเกิดจากการทำงานต่อเนื่องกันระหว่างชุดขับสวิตช์แต่ละชุด ซึ่งจะเรียงลำดับเริ่มแรกจาก S1 & S4 switch on เป็นระยะเวลา T1 จากนั้น S2 & S4 switch on เป็นระยะเวลา T2 จากนั้น S2 & S3 switch on เป็นระยะเวลา T3 และจากนั้น S2 & S4 switch on เป็นระยะเวลา T4 และเริ่มต้น T1 ใหม่ โดยที่ขณะทำงานจะต้องมีแรงดัน V_{dc1} และ V_{dc2} เท่ากัน และจำนวนพัลส์ต่อซั๊กก็ต้องเท่ากันด้วย ดังนั้นจะทำให้ได้รูปคลื่นดีซีพัลส์ดังนี้



รูปที่ 4.5 แรงดันขาออกในโหมด Symmetric Bipolar

4.1.6 แรงดันขาออกในโหมด Asymmetric Bipolar

โหมด Aymmetric Bipolar นั้น จะเกิดจากการทำงานต่อเนื่องกันระหว่างชุดขับสวิตช์แต่ละชุด ซึ่งจะเรียงลำดับเริ่มแรกจาก S1 & S4 switch on เป็นระยะเวลา T1 จากนั้น S2 & S4 switch on เป็นระยะเวลา T2 จากนั้น S2 & S3 switch on เป็นระยะเวลา T3 และจากนั้น S2 & S4 switch on เป็นระยะเวลา T4 และเริ่มต้น T1 ใหม่ โดยที่ขณะทำงานจะต้องมีแรงดัน V_{dc1} และ V_{dc2} ไม่เท่ากัน และจำนวนพัลส์ต่อซั๊กก็ต้องไม่เท่ากันด้วย ดังนั้นจะทำให้ได้รูปคลื่นดีซีพัลส์ดังนี้



รูปที่ 4.6 แรงดันขาออกในโหมด Asymmetric Bipolar

4.2 ผลการทดสอบแหล่งจ่ายไฟฟ้าดีซีพัลส์เมื่อทดลองเคลือบฟิล์มบาง

การทดสอบแหล่งจ่ายไฟฟ้าดีซีพัลส์ด้วยการเคลือบฟิล์มบางอะลูมิเนียมจะทำการทดสอบโดยการนำชิ้นงานซึ่งเป็นกระจกใสซึ่งเป็นชิ้นงานมาวางบนแท่นในห้องสุญญากาศ (Vacuum Chamber) และทำการเคลือบโดยใช้อะลูมิเนียมเป็นสารเคลือบ แล้วนำแหล่งจ่ายไฟฟ้าดีซีพัลส์มาต่อเข้ากับเครื่องแมกนีตรอนสปัตเตอร์ริง และด้านขาเข้าของแหล่งจ่ายไฟฟ้าดีซีพัลส์ต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้า Pinnacle 2/2 kW จากนั้นควบคุมรูปคลื่นของแหล่งจ่ายไฟฟ้าดีซีพัลส์ให้เป็นดังรูปที่ 4.5 จากนั้นตั้งค่าความดันของก๊าซเฉื่อยและเปิดวาล์วสุญญากาศทั้งหมดเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเคลือบฟิล์มบาง เปิดสวิทช์จ่ายไฟฟ้าจาก Pinnacle 2/2 kW เข้าสู่แหล่งจ่ายไฟฟ้าดีซีพัลส์ ดีซีพัลส์จะทำหน้าที่แปลงแรงดันกระแสตรงจาก Pinnacle 2/2 kW ไปเป็นแรงดันตามรูปที่ 4.10 ถ้าหากแรงดันด้านพัลส์ลบมีค่ามากพอ ภายในห้องสุญญากาศจะมีแสงไฟสีม่วงปรากฏบนแท่นที่วางชิ้นงาน ซึ่งแสงไฟสีม่วงจะแสดงถึงปฏิกิริยาพลาสมาทำให้อะตอมแตกตัวไปชนอะลูมิเนียมจนอะตอมบนผิวของอะลูมิเนียมแตกตัวออกไปเคลือบชิ้นงาน ซึ่งชิ้นงานที่ออกมาได้จะเป็นแผ่นกระจกเงาเคลือบอะลูมิเนียมนั่นเอง

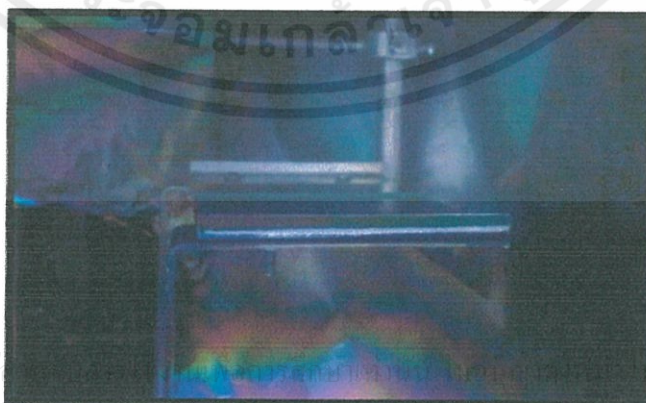
4.2.1 ผลการทดสอบเคลือบฟิล์มบางอะลูมิเนียม

การทดสอบเคลือบฟิล์มบางอะลูมิเนียมใช้รูปคลื่นพัลส์ตามรูปที่ 4.10 พัลส์ด้านบวกจะใช้แรงดัน 150 โวลต์ ส่วนพัลส์ด้านลบจะใช้แรงดัน 400 โวลต์ ใช้ความถี่ 50 kHz ในการเคลือบฟิล์มบาง คาบ T1 เท่ากับ $6.25 \mu\text{s}$ T2 เท่ากับ $1 \mu\text{s}$ T3 เท่ากับ $18.75 \mu\text{s}$ และ T4 เท่ากับ $1 \mu\text{s}$ ก๊าซเร่งปฏิกิริยาใช้ก๊าซอาร์กอน ทดสอบเคลือบชิ้นงานกระจกใสใช้เวลาทำปฏิกิริยาประมาณ 5 นาที จะได้ผลการทดสอบดังนี้

4.2.1.1 ขั้นตอนการเคลือบฟิล์มบาง

ขั้นตอนการเตรียมการเคลือบฟิล์มบางด้วยแหล่งจ่ายไฟฟ้าดีซีพัลส์สามารถทำได้ดังนี้

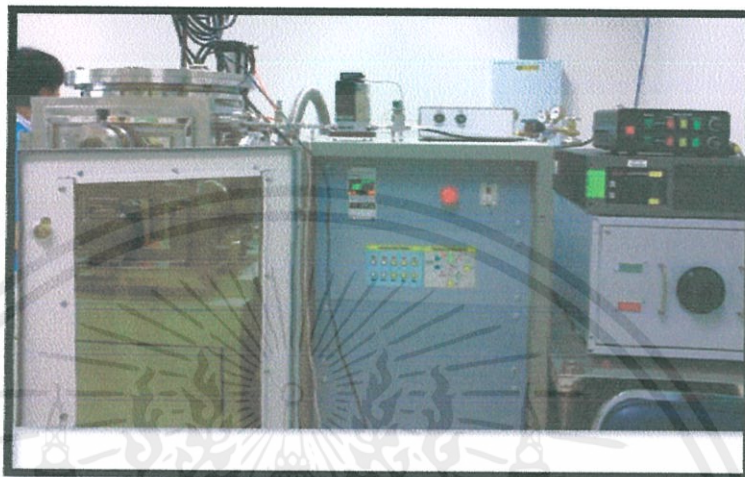
- 1) นำชิ้นงานกระจกใสเข้ามาวางที่ขั้วอาร์กอนเพื่อเตรียมการเคลือบฟิล์มบางตามรูปที่ 4.7



รูปที่ 4.7 ชิ้นงานที่ต้องการจะเคลือบภายในห้องสุญญากาศก่อนทำการเคลือบ

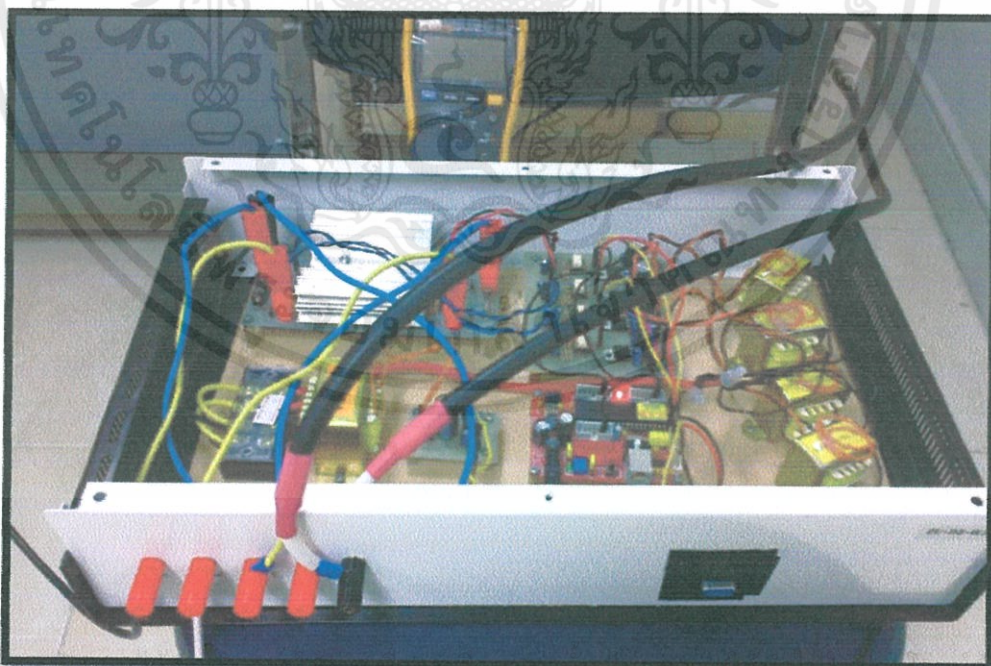
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้ใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งยังมีให้คิดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2) ตั้งค่าความดันอากาศและความดันก๊าซเฉื่อยให้เหมาะสมกับการเคลือบฟิล์มบางผ่านตู้ควบคุมห้องสุญญากาศ



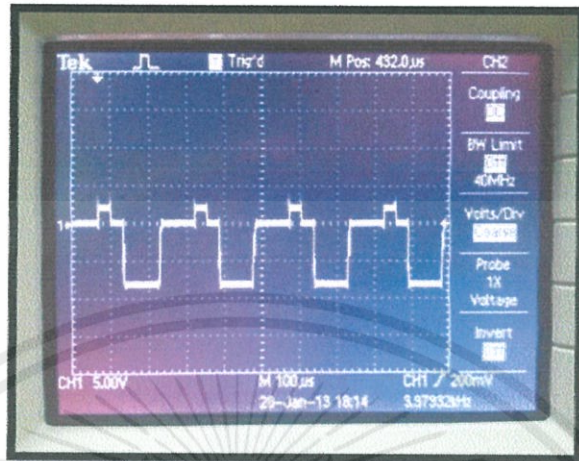
รูปที่ 4.8 ตู้ควบคุมห้องสุญญากาศ

3) ต่อแหล่งจ่ายไฟฟ้า Pinnacle 2/2 kW เข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้าดีซีพัลส์ เพื่อเตรียมการเคลือบฟิล์มบาง



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์ของภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี การนำ
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกที่รูปที่ 4.9 ต่อแหล่งจ่าย Pinnacle 2/2 kW เข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้าดีซีพัลส์ การนำไปใช้

4) ตั้งค่าการทำงานของแหล่งจ่ายไฟฟ้าดิสทริบิวต์ให้เป็นโหมดอะซิมเมตริกไบโพลาร์โดยที่ $P = N = 1$ ลูกคลื่น จะได้รูปคลื่นการเคลือบดังรูปที่ 4.10



รูปที่ 4.10 รูปคลื่นอะซิมเมตริกไบโพลาร์ที่ใช้ในการเคลือบฟิล์มบาง

5) ที่แหล่งจ่าย Pinnacle 2/2 kW ตั้งค่าแรงดัน Output A เป็น 400 โวลต์ และตั้งค่าแรงดัน Output B เป็น 150 โวลต์

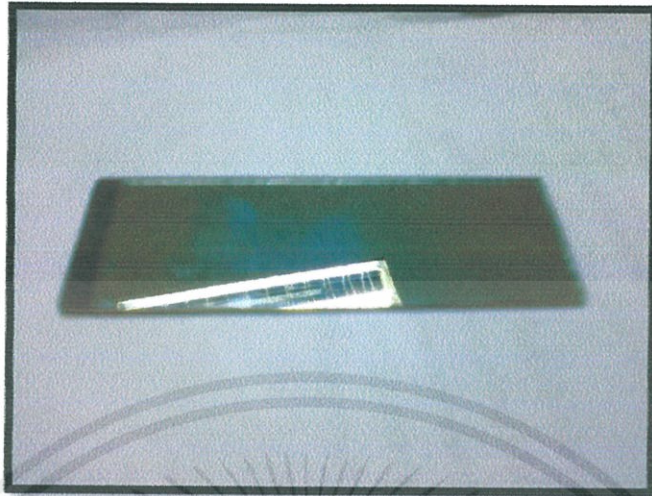
6) เมื่อเปิดแหล่งจ่าย Pinnacle 2/2 kW ภายในห้องสุญญากาศจะเกิดปฏิกิริยาสปัตเตอร์และเริ่มทำการเคลือบฟิล์มบางดังรูปที่ 4.11 ปฏิกิริยาสปัตเตอร์จะใช้เวลาในการเคลือบฟิล์มบางประมาณ 5 นาที ห้องสุญญากาศจะกินกระแสประมาณ 0.63 แอมป์



รูปที่ 4.11 ภายในห้องสุญญากาศขณะเกิดปฏิกิริยาสปัตเตอร์

4.2.2 ผลการเคลือบฟิล์มบางอะลูมิเนียม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวน เมื่อเคลือบชิ้นงานกระจกใสด้วยอะลูมิเนียมแล้ว รอยบนกระจกทั้งอุณหภูมิห้องสุญญากาศ การค้า
ไม่ว่ากรณีใด กลับมาสู่สภาวะปกติ แล้วจึงนำชิ้นงานที่ถูกเคลือบออกมา จะพบว่ากระจกใสที่ใส่เข้าไปในตอนต้นนั้น
มีสารเคลือบเกาะอยู่ที่ผิวชิ้นงานกลายเป็นกระจกเงาดังรูปที่ 4.12



รูปที่ 4.12 ชิ้นงานที่ถูกเคลือบฟิล์มอะลูมิเนียมเรียบร้อยแล้ว

4.3 สรุปผลการทดลอง

จากการทดลองรูปคลื่นแรงดันขาออกทั้ง 6 แบบ และการทดลองเคลือบฟิล์มบางอะลูมิเนียมบนชิ้นงาน พบว่า รูปแบบรูปคลื่นแรงดันขาออกของแหล่งจ่ายไฟฟ้าดีซีพัลส์สามารถแสดงผลออกมาได้ทั้ง 6 แบบ และผลการทดลองเคลือบฟิล์มบางปรากฏว่าฟิล์มบางถูกเคลือบลงบนผิวชิ้นงานอย่างเรียบร้อยดี

แต่ในการทดลองเคลือบฟิล์มบางนั้นพบว่า มีบางจนบนชิ้นงานนั้นมีบริเวณที่มีสีขุ่นไม่ใส เนื่องจากเงื่อนไขด้านความดันก๊าซนั้นไม่ดี มีการปรับความดันขณะเกิดการสปัตเตอร์িং ทำให้ชิ้นงานถูกเคลือบอย่างมีตำหนิ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 5

บทสรุปผลการทดลอง ข้อเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนา

5.1 บทสรุป

วงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้าดีซีพัลส์ต้นแบบที่ได้ออกแบบและสร้างมาเพื่อการควบคุมการเคลือบฟิล์มบางด้วยเทคนิคพัลส์ดีซีแมกนีตรอนสปีดเตอร์ริงได้ถูกทดสอบในห้องทดลอง ฟังก์ชันการทำงานในโหมดต่างๆของวงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้าดีซีพัลส์นั้นได้ครอบคลุมความต้องการในการทำปฏิกิริยาแบบต่างๆในกระบวนการเคลือบฟิล์มบางได้ทั้งหมด ในการเคลือบที่ต้องการให้ชั้นงานถูกเคลือบด้วยวิธีที่ต่างกันในแต่ละระดับชั้นการเคลือบ (layers) แหล่งจ่ายไฟฟ้าดีซีพัลส์สามารถปรับโหมดการเคลือบได้อย่างสะดวกด้วยการปรับค่าผ่านพอร์ตอนุกรม เมื่อต้องการให้เกิดปฏิกิริยาด้วยกระบวนการที่เฉพาะ รูปขบวนคลื่นที่เฉพาะสำหรับปฏิกิริยานั้นก็จะถูกขับออกมา และรูปขบวนคลื่นก็จะไปขับให้เกิดปฏิกิริยาการเคลือบฟิล์มในห้องสุญญากาศ (Vacuum chamber) วงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้าดีซีพัลส์ที่สร้างขึ้นมานั้นสามารถกำเนิดรูปขบวนคลื่นพัลส์ได้ทั้ง 6 โหมดการทำงาน คือ Positive DC , Negative DC , Positive Unipolar , Negative Unipolar , Symmetric Bipolar และ Asymmetric Bipolar นอกจากนี้ วงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้าดีซีพัลส์ยังสามารถควบคุมการกำเนิดรูปขบวนคลื่นพัลส์ในรูปแบบต่างๆได้อย่างง่ายและเข้าใจง่ายสำหรับผู้ใช้

5.2 ข้อเสนอแนะและข้อควรระวัง

จากการดำเนินการทดลองตลอดการทดลองนี้พบว่ามีข้อควรระวังและข้อเสนอแนะดังนี้

1. ไม่ควรเก็บวงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้าดีซีพัลส์ไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิสูง เนื่องจากจะทำให้หน่วยความจำไมโครคอนโทรลเลอร์นั้นได้รับความเสียหาย ทำให้ต้องโปรแกรมหน่วยความจำใหม่
2. ในการใช้งานควรระวังอย่าให้ขั้วของแหล่งจ่ายทั้งสองขั้วสัมผัสกัน เพราะจะทำให้เกิดการลัดวงจรและจะทำให้วงจรได้รับความเสียหายได้
3. เนื่องจากภายในแหล่งจ่ายไฟฟ้าดีซีพัลส์เป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์กำลังซึ่งใช้แรงดันสูง อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อตัวบุคคลได้ ดังนั้นผู้ใช้งานจึงควรมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานเป็นอย่างดี เพื่อความปลอดภัยของตัวบุคคลและอุปกรณ์
4. ในการใช้งานไม่ควรจ่ายไฟฟ้าและแรงดันสูงเกินกว่าที่กำหนด เพราะจะทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังภายในวงจรเกิดความเสียหายได้

5.3 ปัญหาที่พบในการทำโครงการ

1. เมื่อนำวงจรแหล่งจ่ายดีซีพัลส์ไปทดลองกับเครื่องแมกนีตรอนสปีดเตอร์ริง พบว่าการปรับแรงดันไฟฟ้าพัลส์บวกและพัลส์ลบไม่สามารถปรับแยกกันได้ตามต้องการ เนื่องจากเครื่องจ่ายไฟของเครื่องแมกนีตรอนสปีดเตอร์ริงมีการต่อคอมมอนด้านแรงดันไฟฟ้าที่สูง (ด้านบวก) แต่วงจรดีซีพัลส์ของเราต่อคอมมอนที่แรงดันไฟฟ้าต่ำ (ด้านลบ) ส่งผลให้การปรับแรงดันไฟฟ้าด้านบวกและด้านลบไม่สามารถปรับแยกกันได้ตามต้องการ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการทำงานเป็นกรณีเฉพาะ ไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใด

2. ผลกระทบของการต่อคอมมอนในเครื่องจ่ายไฟฟ้าไม่ตรงจุดกันส่งผลให้มอสเฟตเกิดความเสียหายทำให้ต้องเปลี่ยนมอสเฟตใหม่ทั้งหมด ต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3. หลังจากเปลี่ยนมอสเฟตแล้ว ผลจากสัญญาณรบกวนของวงจรส่งผลให้ไม่สามารถปรับฟิล์มด้านบวกได้ เนื่องจากเครื่องจ่ายไฟฟ้าเกิดการอาร์คภายใน แต่สามารถเคลือบฟิล์มได้เพราะการเคลือบใช้ฟิล์มด้านลบ
4. การเคลือบฟิล์มสามารถทำได้แต่ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากไม่สามารถใช้ฟิล์มด้านบวกเพื่อให้มีการคายประจุที่สะสมในการเคลือบได้ ส่งผลให้ชิ้นงานออกมาไม่สมบูรณ์

5.4 แนวทางการพัฒนาโครงการ

1. พัฒนาวงจรแหล่งจ่ายดีซีฟิล์ม โดยสามารถจ่ายแรงดันได้ตั้งแต่ 1,000 โวลต์ขึ้นไป และมีการควบคุมค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ได้มากขึ้นจากหน้าจอกอมพิวเตอร์
2. พัฒนาให้สามารถใช้งานกับเครื่องแมกนีตรอนสเปคเตอร์ริงในสถานะที่มีเงื่อนไขพารามิเตอร์ต่างๆ เพิ่มขึ้นได้ เช่น การใช้ก๊าซเฉื่อยมากกว่าหนึ่งชนิดในการทดสอบการเคลือบฟิล์มบาง เป็นต้น
3. ทำการพัฒนาวงจรแหล่งจ่ายดีซีฟิล์มให้มีการสวิตซ์ซึ่งในวงจรกำลังดีขึ้น เพื่อลดสัญญาณรบกวนในวงจร



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เอกสารอ้างอิง

- [1] Tolga Tavsanoğlu , “Deposition And Characterization of Single And Multilayer Boron Carbide And Boron Carbonitride Thin Film by Different Sputtering Configurations” , **Doctoral Degree of Material Sciences** , Istanbul Technique University , 2009
- [2] A. Belkind and Fellowships , **Pulsed-DC Reactive Sputtering of Dielectrics : Pulsing Parameter Effects** , Stevens Institute of Technology , Hoboken , NJ and Advanced Energy Industries, Inc. , Fort Collins , CO
- [3] Weerasak Somkhunthot and Fellowships , **Design and Construction of Bipolar Pulsed-DC Power Supply for Magnetron Sputtering System** , 2006
- [4] Yueh-Ru Yang and Fellowships , **A DC-Pulse Power Supply Designed for Plasma Applications** , Ming Chi University of Technology , Taishan Township , Taipei Country , 24301 , Taiwan , 2009
- [5] กมล เอี่ยมพนากิจ และคณะ , **ผลกระทบของ ดีซี พัลส์ แมกนีตรอน สเปคเตอร์ริง ต่อสมบัติของฟิล์มบางอินเดียมทินออกไซด์สำหรับการเตรียมฟิล์มบนวัสดุรองรับที่อุณหภูมิต่ำ** , ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปทุมธานี 12121 และ สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปทุมธานี 12110
- [6] Narong Aphiratsakun and Fellowships , **Implementation of a Single Phase Unipolar Inverter Using DSP TMS320F241** , Faculty of Engineering , Assumption University , Bangkok , Thailand
- [7] Microship Technology Inc. , **dsPIC30F4011/4012 Datasheet High Performance Digital Signal Controllers** , 2009
- [8] Microship Technology Inc. , **dsPIC30F Family Reference Manual** , High Performance Digital Signal Controllers , 2004
- [9] Microship Technology Inc. , **dsPIC30F Programmer’s Reference Manual** , High Performance Digital Signal Controllers , 2003

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- [10] A. Subrahmanyam and Fellowships , **Patent on “A Design for an efficient cylindrical Magnetron Cathode with Rotating Magnets and Optical Emission incorporated”** , Indian Institute of Technology Madras and National Advanced Research Centre
- [11] Dr. Kevin Cooke , **“PVD High Performance Coating for Aerospace Applications”** , IMFair 2011 , Teer Coating Limited , Miba Coating Group , 2011
- [12] Jung Won Cho , **“Pulsed DC Reactive Magnetron Sputtering of Aluminum Nitride Thin Film”** , Degree of Doctor of Philosophy , Department of Material Science and Engineering , North Carolina State University , 2002
- [13] S. Calatroni and W. Vollenberg , **“High Power Pulsed Magnetron Sputtering (HPPMS)”** , SRF-TF Workshop , CERN
- [14] Microship Technology Inc. , **“AN937 : Implementing PID Controller Using PIC18 MCU”** , 2004
- [15] รชต เตชะเวชเจริญ และคณะ , **“เตาอบควบคุมอุณหภูมิ”** , **ปริญญาานิพนธ์วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต** , สาขาอิเล็กทรอนิกส์ , คณะวิศวกรรมศาสตร์ , สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง , 2553
- [16] อธิปต์ จันทร์ดี และคณะ , **“การพัฒนาตัวควบคุมแบบป้อนกลับในวงจรรินเวอร์เตอร์พีดับเบิลยูเอ็มสำหรับแหล่งจ่ายไฟฟ้าแบบต่อเนื่องเฟสเดียว”** , **ปริญญาานิพนธ์วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต** , ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า , คณะวิศวกรรมศาสตร์ , สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง , 2553
- [17] A. Zeng and Fellowships , **“Impedance Study on Electromagnetics of Sputtered DLC Films”** , A School of Mechanical and Production Engineering , Nanyang Technological University , 50 Nanyang Avenue , Singapore 639798 , Singapore , 2002
- [18] C. P. Castillo Morquecho and Fellowships , **“Electrochemical Impedance Spectroscopy Behavior of Nanometric Al-Cr and Cr-Al Coatings by Magnetron Sputtering”** , CIMAV-Chihuahua. Miguel de Cervantes 120 , Complejo Industrial Chihuahua. C.P. 31109 , 2012

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

[19] David TURCIO-ORTEGA and Fellowships , “**Electrochemical Behavior of Titanium Thin Films Obtained by Magnetron Sputtering**” , Instituto de Investigaciones en Materiales , Universidad Nacional Autónoma de México , Ciudad Universitaria , 04510 México D. F. , México , 2008



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2SK1317

Silicon N-Channel MOS FET

HITACHI

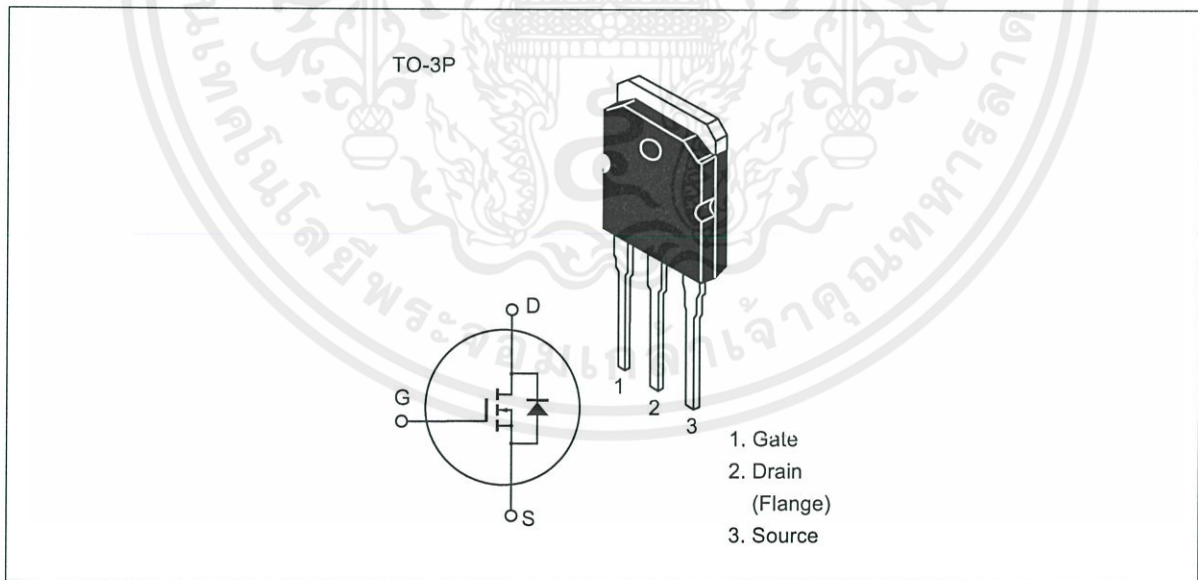
Application

High speed power switching

Features

- High breakdown voltage $V_{DSS} = 1500\text{ V}$
- High speed switching
- Low drive current
- No secondary breakdown
- Suitable for switching regulator, DC-DC converter and motor driver

Outline



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2SK1317

Absolute Maximum Ratings (Ta = 25°C)

Item	Symbol	Ratings	Unit
Drain to source voltage	V _{DSS}	1500	V
Gate to source voltage	V _{GSS}	±20	V
Drain current	I _D	2.5	A
Drain peak current	I _{D(pulse)} *1	7	A
Body to drain diode reverse drain current	I _{DR}	2.5	A
Channel dissipation	Pch*2	100	W
Channel temperature	Tch	150	°C
Storage temperature	Tstg	-55 to +150	°C

Notes: 1. PW ≤ 10 μs, duty cycle ≤ 1%

2. Value at T_c = 25°C

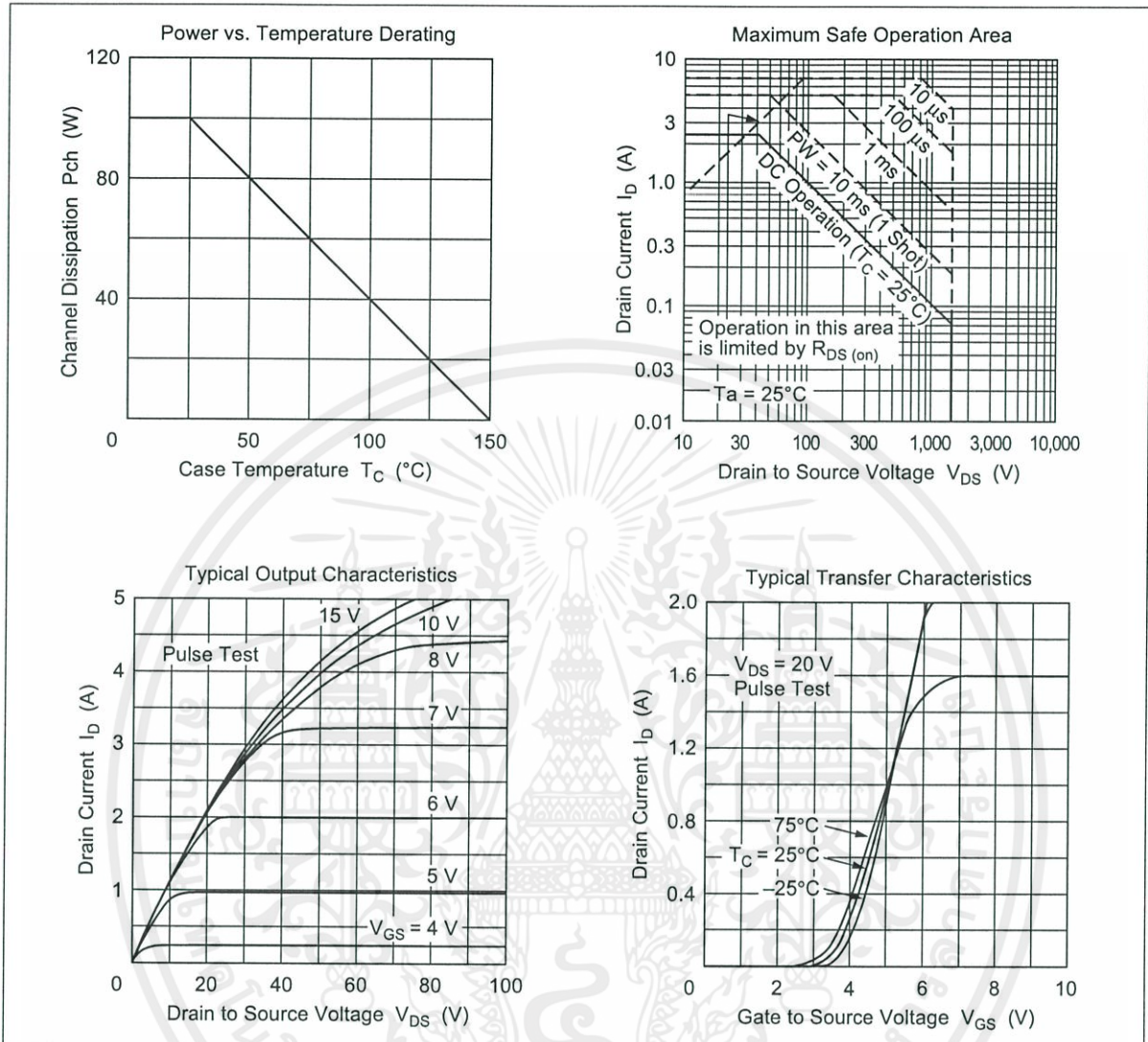
Electrical Characteristics (Ta = 25°C)

Item	Symbol	Min	Typ	Max	Unit	Test conditions
Drain to source breakdown voltage	V _{(BR)DSS}	1500	—	—	V	I _D = 10 mA, V _{GS} = 0
Gate to source leak current	I _{GSS}	—	—	±1	μA	V _{GS} = ±20 V, V _{DS} = 0
Zero gate voltage drain current	I _{DSS}	—	—	500	μA	V _{DS} = 1200 V, V _{GS} = 0
Gate to source cutoff voltage	V _{GS(off)}	2.0	—	4.0	V	I _D = 1 mA, V _{DS} = 10 V
Static drain to source on state resistance	R _{DS(on)}	—	9	12	Ω	I _D = 2 A, V _{GS} = 15 V*1
Forward transfer admittance	y _{fs}	0.45	0.75	—	S	I _D = 1 A, V _{DS} = 20 V*1
Input capacitance	C _{iss}	—	990	—	pF	V _{DS} = 10 V, V _{GS} = 0,
Output capacitance	C _{oss}	—	125	—	pF	f = 1 MHz
Reverse transfer capacitance	C _{rss}	—	60	—	pF	
Turn-on delay time	t _{d(on)}	—	17	—	ns	I _D = 2 A, V _{GS} = 10 V,
Rise time	t _r	—	70	—	ns	R _L = 15 Ω
Turn-off delay time	t _{d(off)}	—	110	—	ns	
Fall time	t _f	—	60	—	ns	
Body to drain diode forward voltage	V _{DF}	—	0.9	—	V	I _F = 2 A, V _{GS} = 0
Body to drain diode reverse recovery time	t _{rr}	—	1750	—	ns	I _F = 2 A, V _{GS} = 0, di _p /dt = 100 A/μs

Note: 1. Pulse test

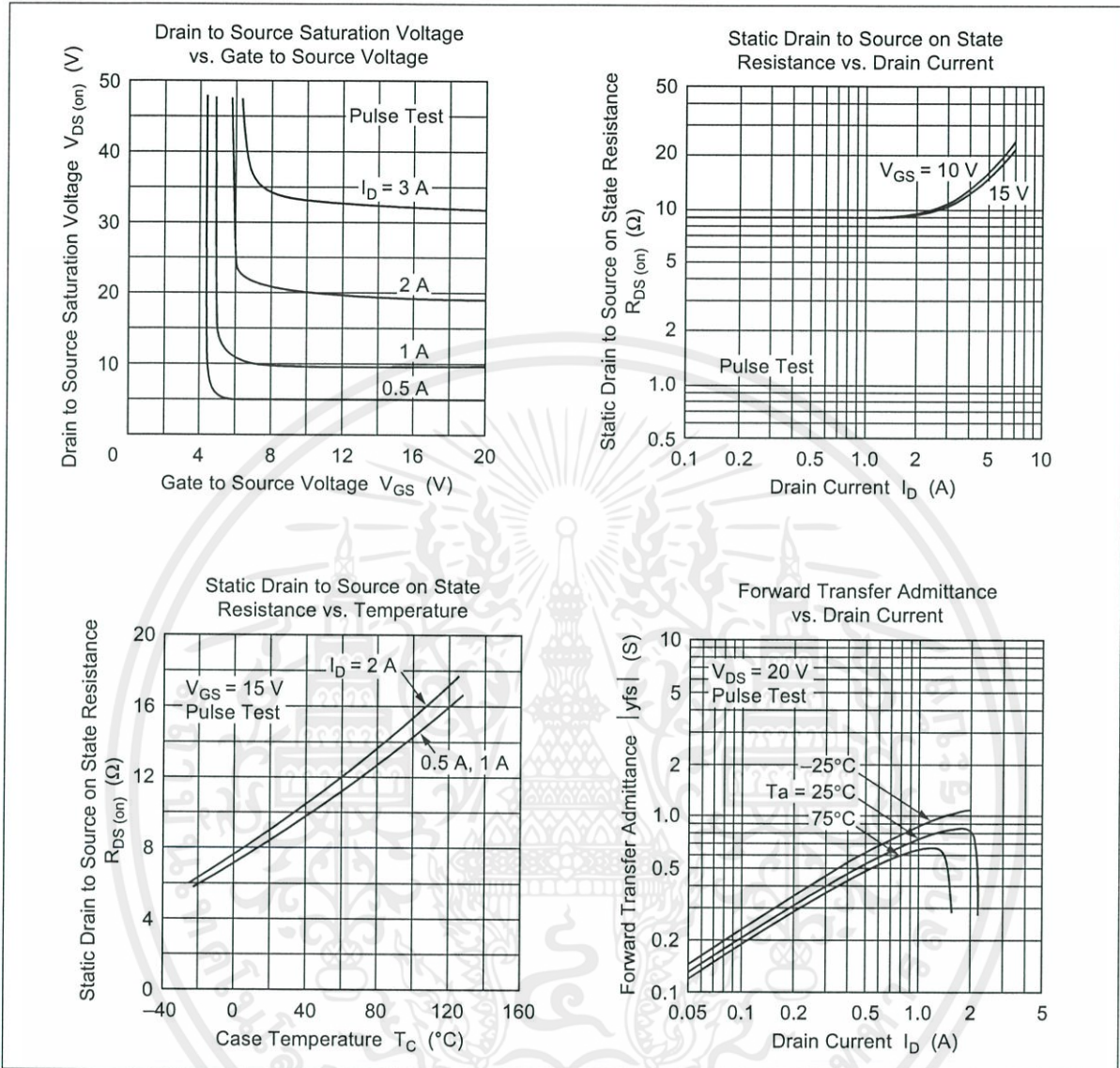
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

HITACHI

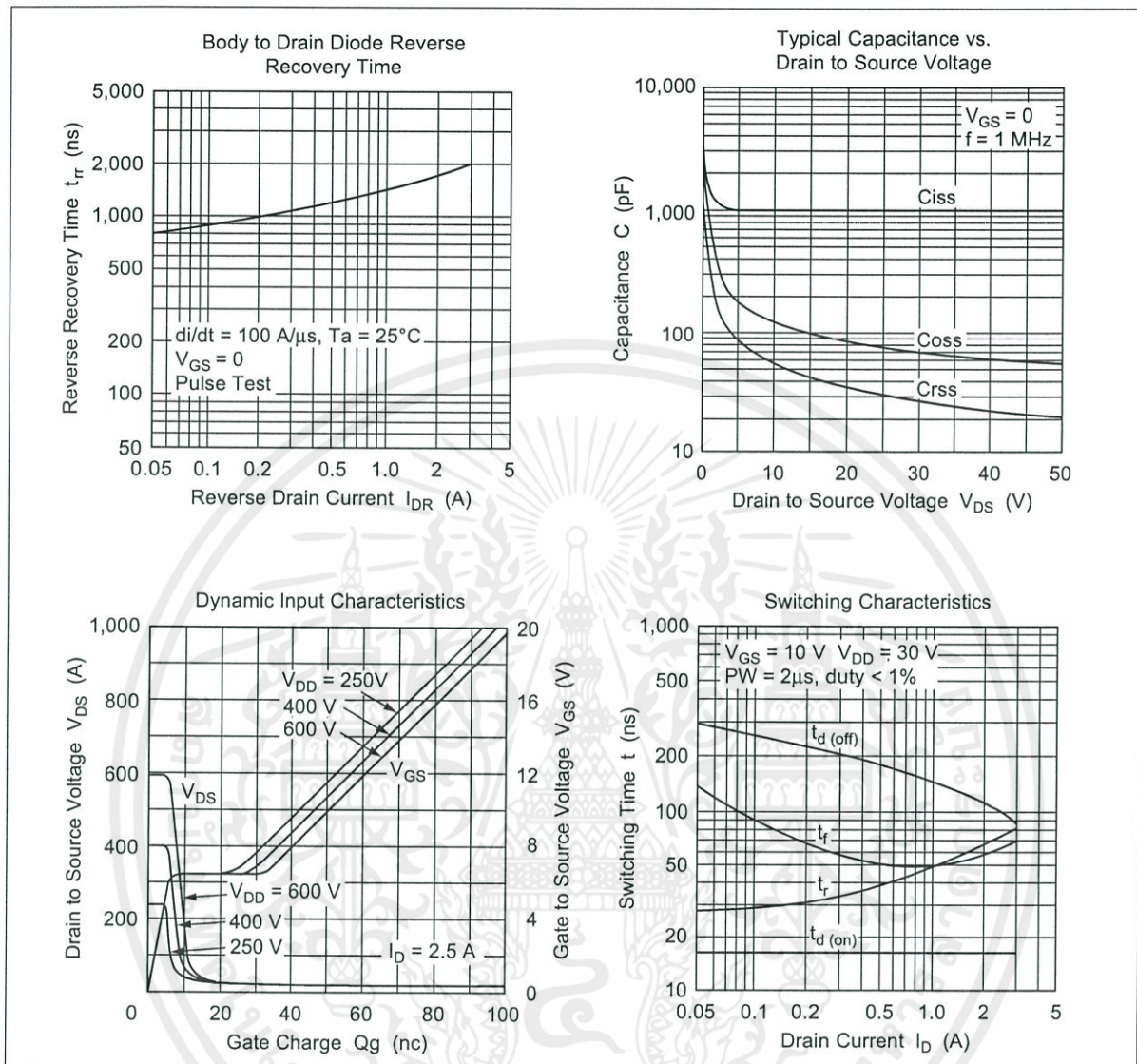


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

HITACHI

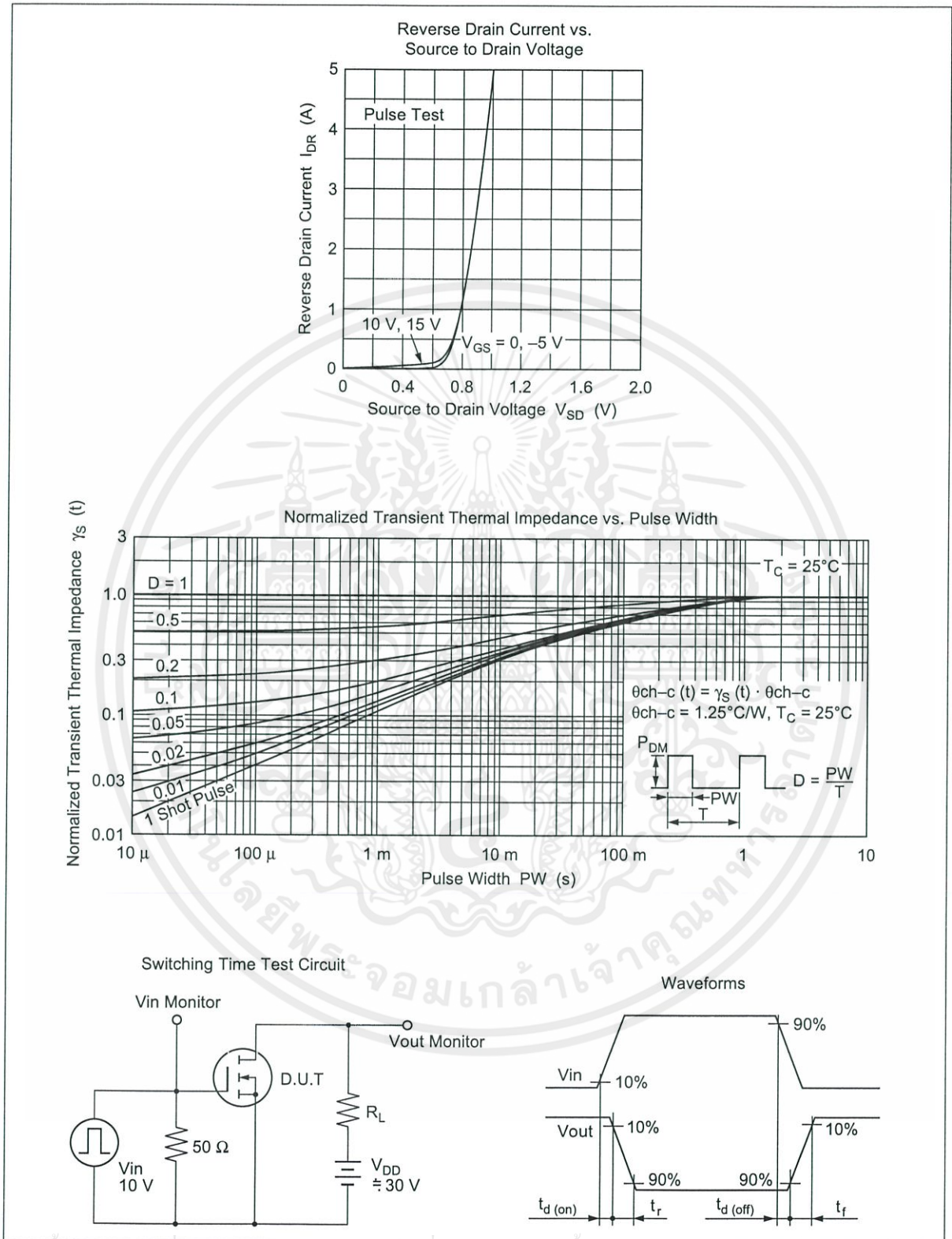


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



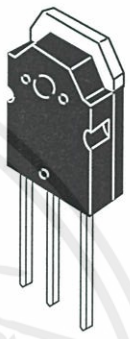
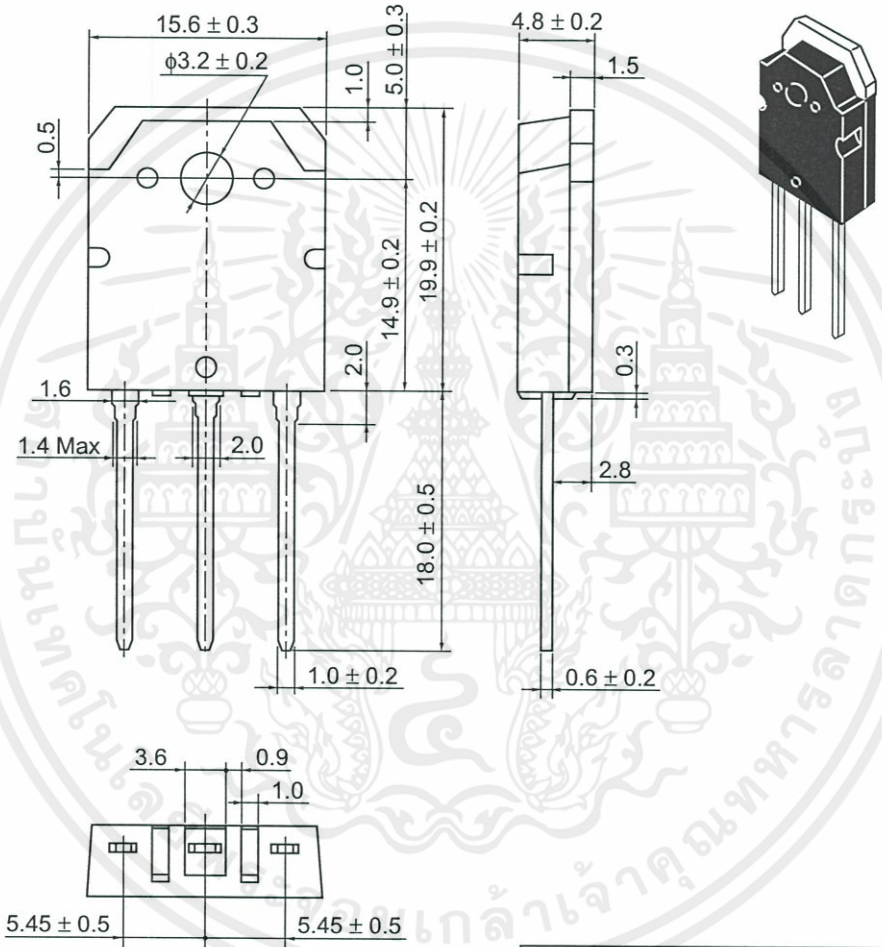
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

HITACHI



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Unit: mm



Hitachi Code	TO-3P
JEDEC	—
EIAJ	Conforms
Weight (reference value)	5.0 g

Cautions

1. Hitachi neither warrants nor grants licenses of any rights of Hitachi's or any third party's patent, copyright, trademark, or other intellectual property rights for information contained in this document. Hitachi bears no responsibility for problems that may arise with third party's rights, including intellectual property rights, in connection with use of the information contained in this document.
2. Products and product specifications may be subject to change without notice. Confirm that you have received the latest product standards or specifications before final design, purchase or use.
3. Hitachi makes every attempt to ensure that its products are of high quality and reliability. However, contact Hitachi's sales office before using the product in an application that demands especially high quality and reliability or where its failure or malfunction may directly threaten human life or cause risk of bodily injury, such as aerospace, aeronautics, nuclear power, combustion control, transportation, traffic, safety equipment or medical equipment for life support.
4. Design your application so that the product is used within the ranges guaranteed by Hitachi particularly for maximum rating, operating supply voltage range, heat radiation characteristics, installation conditions and other characteristics. Hitachi bears no responsibility for failure or damage when used beyond the guaranteed ranges. Even within the guaranteed ranges, consider normally foreseeable failure rates or failure modes in semiconductor devices and employ systemic measures such as fail-safes, so that the equipment incorporating Hitachi product does not cause bodily injury, fire or other consequential damage due to operation of the Hitachi product.
5. This product is not designed to be radiation resistant.
6. No one is permitted to reproduce or duplicate, in any form, the whole or part of this document without written approval from Hitachi.
7. Contact Hitachi's sales office for any questions regarding this document or Hitachi semiconductor products.

HITACHI

Hitachi, Ltd.

Semiconductor & Integrated Circuits.

Nippon Bldg., 2-6-2, Ohte-machi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0004, Japan

Tel: Tokyo (03) 3270-2111 Fax: (03) 3270-5109

URL NorthAmerica : <http://semiconductor.hitachi.com/>
Europe : <http://www.hitachi-eu.com/hel/ecg>
Asia (Singapore) : <http://www.has.hitachi.com.sg/grp3/sicd/index.htm>
Asia (Taiwan) : http://www.hitachi.com.tw/E/Product/SICD_Frame.htm
Asia (HongKong) : <http://www.hitachi.com.hk/eng/bo/grp3/index.htm>
Japan : <http://www.hitachi.co.jp/Sicd/indx.htm>

For further information write to:

Hitachi Semiconductor
(America) Inc.
179 East Tasman Drive,
San Jose, CA 95134
Tel: <1> (408) 433-1990
Fax: <1>(408) 433-0223

Hitachi Europe GmbH
Electronic components Group
Dornacher StraÙe 3
D-85622 Feldkirchen, Munich
Germany
Tel: <49> (89) 9 9180-0
Fax: <49> (89) 9 29 30 00

Hitachi Europe Ltd.
Electronic Components Group.
Whitebrook Park
Lower Cookham Road
Maidenhead
Berkshire SL6 8YA, United Kingdom
Tel: <44> (1628) 585000
Fax: <44> (1628) 778322

Hitachi Asia Pte. Ltd.
16 Collyer Quay #20-00
Hitachi Tower
Singapore 049318
Tel: 535-2100
Fax: 535-1533

Hitachi Asia Ltd.
Taipei Branch Office
3F, Hung Kuo Building, No.167,
Tun-Hwa North Road, Taipei (105)
Tel: <886> (2) 2718-3666
Fax: <886> (2) 2718-8180

Hitachi Asia (Hong Kong) Ltd.
Group III (Electronic Components)
7/F., North Tower, World Finance Centre,
Harbour City, Canton Road, Tsim Sha Tsui,
Kowloon, Hong Kong
Tel: <852> (2) 735 9218
Fax: <852> (2) 730 0281
Telex: 40815 HITEC HX

Copyright © Hitachi, Ltd., 1999. All rights reserved. Printed in Japan.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการฝึกอบรมเท่านั้น และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

HITACHI

TLP250

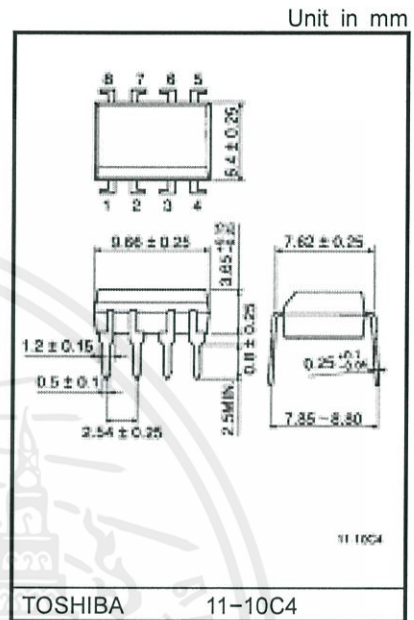
Transistor Inverter
 Inverter For Air Conditioner
 IGBT Gate Drive
 Power MOS FET Gate Drive

The TOSHIBA TLP250 consists of a GaAlAs light emitting diode and a integrated photodetector.
 This unit is 8-lead DIP package.
 TLP250 is suitable for gate driving circuit of IGBT or power MOS FET.

- Input threshold current: $I_F=5\text{mA}(\text{max.})$
- Supply current (I_{CC}): $11\text{mA}(\text{max.})$
- Supply voltage (V_{CC}): $10\text{--}35\text{V}$
- Output current (I_O): $\pm 1.5\text{A}(\text{max.})$
- Switching time (t_{pLH}/t_{pHL}): $1.5\mu\text{s}(\text{max.})$
- Isolation voltage: $2500V_{\text{rms}}(\text{min.})$
- UL recognized: UL1577, file No.E67349
- Option (D4) type
 VDE approved: DIN VDE0884/06.92,certificate No.76823
 Maximum operating insulation voltage: 630V_{PK}
 Highest permissible over voltage: 4000V_{PK}

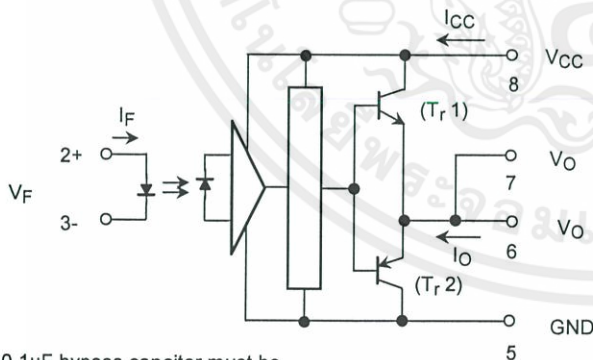
(Note) When a VDE0884 approved type is needed, please designate the "option (D4)"

- Creepage distance: $6.4\text{mm}(\text{min.})$
 Clearance: $6.4\text{mm}(\text{min.})$



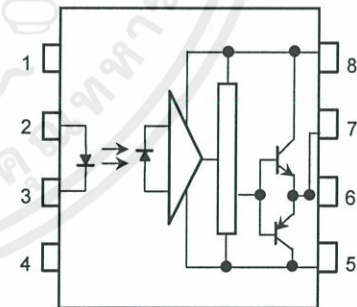
Weight: 0.54 g

Schematic



A $0.1\mu\text{F}$ bypass capacitor must be connected between pin 8 and 5 (See Note 5).

Pin Configuration (top view)



- 1 : N.C.
- 2 : Anode
- 3 : Cathode
- 4 : N.C.
- 5 : GND
- 6 : V_O (Output)
- 7 : V_O
- 8 : V_{CC}

Truth Table

Input LED	Tr1	Tr2
On	On	Off
Off	Off	On

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Absolute Maximum Ratings (Ta = 25°C)

Characteristic		Symbol	Rating	Unit	
LED	Forward current	I _F	20	mA	
	Forward current derating (Ta ≥ 70°C)	ΔI _F / ΔTa	-0.36	mA / °C	
	Peak transient forward current (Note 1)	I _{FPT}	1	A	
	Reverse voltage	V _R	5	V	
	Junction temperature	T _j	125	°C	
Detector	"H" peak output current (P _W ≤ 2.5μs, f ≤ 15kHz) (Note 2)	I _{OPH}	-1.5	A	
	"L" peak output current (P _W ≤ 2.5μs, f ≤ 15kHz) (Note 2)	I _{OPL}	+1.5	A	
	Output voltage	(Ta ≤ 70°C)	V _O	35	V
		(Ta = 85°C)		24	
	Supply voltage	(Ta ≤ 70°C)	V _{CC}	35	V
		(Ta = 85°C)		24	
	Output voltage derating (Ta ≥ 70°C)	ΔV _O / ΔTa	-0.73	V / °C	
	Supply voltage derating (Ta ≥ 70°C)	ΔV _{CC} / ΔTa	-0.73	V / °C	
	Junction temperature	T _j	125	°C	
Operating frequency (Note 3)	f	25	kHz		
Operating temperature range	T _{opr}	-20~85	°C		
Storage temperature range	T _{stg}	-55~125	°C		
Lead soldering temperature (10 s) (Note 4)	T _{sol}	260	°C		
Isolation voltage (AC, 1 min., R.H. ≤ 60%) (Note 5)	BV _S	2500	V _{rms}		

Note 1: Pulse width P_W ≤ 1μs, 300pps

Note 2: Exponential waveform

Note 3: Exponential waveform, I_{OPH} ≤ -1.0A (≤ 2.5μs), I_{OPL} ≤ +1.0A (≤ 2.5μs)

Note 4: It is 2 mm or more from a lead root.

Note 5: Device considered a two terminal device: Pins 1, 2, 3 and 4 shorted together, and pins 5, 6, 7 and 8 shorted together.

Note 6: A ceramic capacitor(0.1μF) should be connected from pin 8 to pin 5 to stabilize the operation of the high gain linear amplifier. Failure to provide the bypassing may impair the switching property. The total lead length between capacitor and coupler should not exceed 1cm.

Recommended Operating Conditions

Characteristic	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit
Input current, on (Note 7)	I _{F(ON)}	7	8	10	mA
Input voltage, off	V _{F(OFF)}	0	—	0.8	V
Supply voltage	V _{CC}	15	—	30 20	V
Peak output current	I _{OPH} /I _{OPL}	—	—	±0.5	A
Operating temperature	T _{opr}	-20	25	70 85	°C

Note 7: Input signal rise time (fall time) < 0.5 μs.

Electrical Characteristics (Ta = -20~70°C, unless otherwise specified)

Characteristic		Symbol	Test Circuit	Test Condition	Min.	Typ.*	Max.	Unit
Input forward voltage		V _F	—	I _F = 10 mA, Ta = 25°C		1.6	1.8	V
Temperature coefficient of forward voltage		ΔV _F / ΔTa	—	I _F = 10 mA	—	-2.0	—	mV / °C
Input reverse current		I _R	—	V _R = 5V, Ta = 25°C		—	10	μA
Input capacitance		C _T	—	V = 0, f = 1MHz, Ta = 25°C	—	45	250	pF
Output current	"H" level	I _{OPH}	3	V _{CC} = 30V (*1) I _F = 10 mA V _{B-6} = 4V	-0.5	-1.5	—	A
	"L" level	I _{OPL}	2		I _F = 0 V _{B-5} = 2.5V	0.5	2	
Output voltage	"H" level	V _{OH}	4	V _{CC1} = +15V, V _{EE1} = -15V R _L = 200Ω, I _F = 5mA	11	12.8	—	V
	"L" level	V _{OL}	5	V _{CC1} = +15V, V _{EE1} = -15V R _L = 200Ω, V _F = 0.8V	—	-14.2	-12.5	
Supply current	"H" level	I _{CCH}	—	V _{CC} = 30V, I _F = 10mA Ta = 25°C	—	7	—	mA
				V _{CC} = 30V, I _F = 10mA	—	—	11	
	"L" level	I _{CCL}	—	V _{CC} = 30V, I _F = 0mA Ta = 25°C	—	7.5	—	
				V _{CC} = 30V, I _F = 0mA	—	—	11	
Threshold input current	"Output L→H"	I _{FLH}	—	V _{CC1} = +15V, V _{EE1} = -15V R _L = 200Ω, V _O > 0V	—	1.2	5	mA
Threshold input voltage	"Output H→L"	I _{FHL}	—	V _{CC1} = +15V, V _{EE1} = -15V R _L = 200Ω, V _O < 0V	0.8	—	—	V
Supply voltage		V _{CC}	—		10	—	35	V
Capacitance (input-output)		C _S	—	V _S = 0, f = 1MHz Ta = 25°C	—	1.0	2.0	pF
Resistance(input-output)		R _S	—	V _S = 500V, Ta = 25°C R.H. ≤ 60%	1×10 ¹²	10 ¹⁴	—	Ω

* All typical values are at Ta = 25°C (*1): Duration of I_O time ≤ 50μs

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Switching Characteristics (Ta = -20~70°C , unless otherwise specified)

Characteristic	Symbol	Test Circuit	Test Condition	Min.	Typ.*	Max.	Unit
Propagation delay time	L→H	t _{pLH}	6 I _F = 8mA (Note 7) V _{CC1} = +15V, V _{EE1} = -15V R _L = 200Ω	—	0.15	0.5	μs
	H→L	t _{pHL}		—	0.15	0.5	
Output rise time	t _r	—		—	—	—	
Output fall time	t _f	—		—	—	—	
Common mode transient immunity at high level output	C _{MH}	7	V _{CM} = 600V, I _F = 8mA V _{CC} = 30V, Ta = 25°C	-5000	—	—	V / μs
Common mode transient immunity at low level output	C _{ML}	7	V _{CM} = 600V, I _F = 0mA V _{CC} = 30V, Ta = 25°C	5000	—	—	V / μs

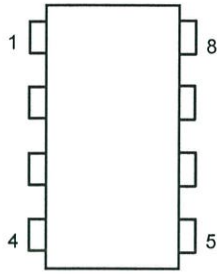
* All typical values are at Ta = 25°C

Note 7: Input signal rise time (fall time) < 0.5 μs.

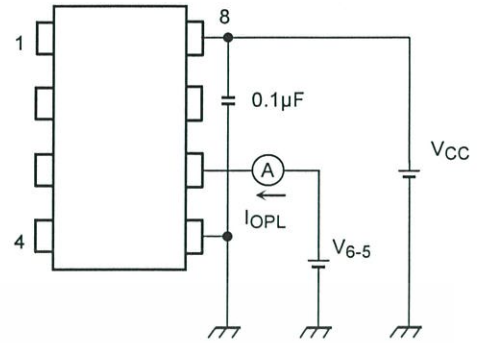


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

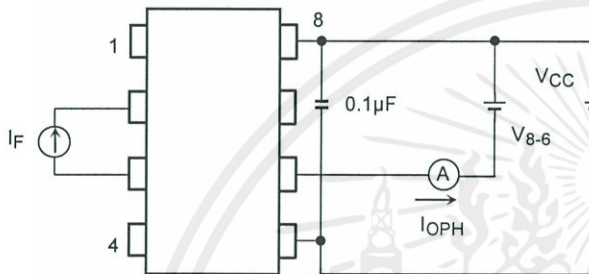
Test Circuit 1 :



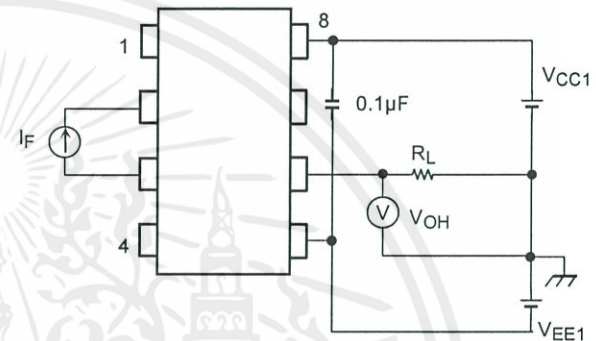
Test Circuit 2 : IOPL



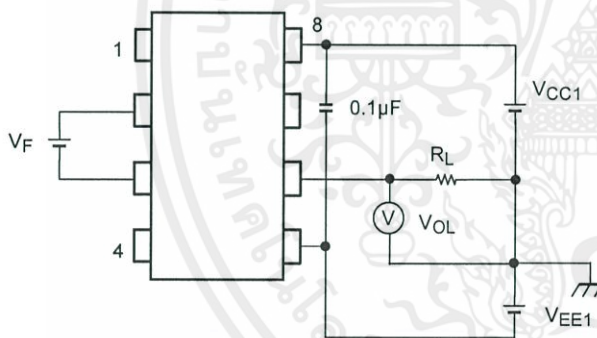
Test Circuit 3 : IOPH



Test Circuit 4 : VOH

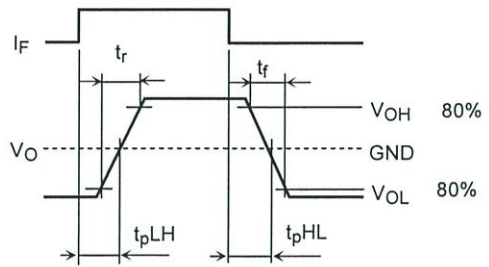
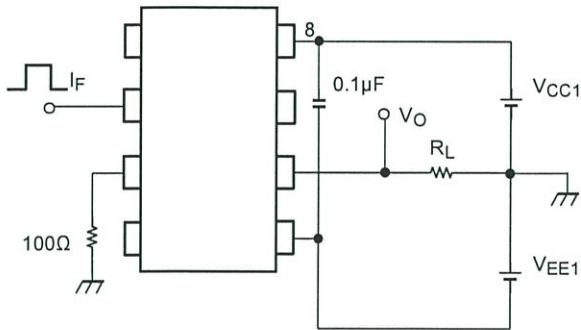


Test Circuit 5 : VOL

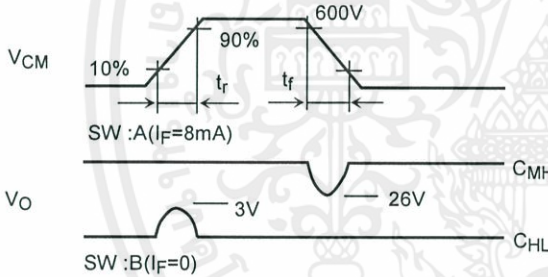
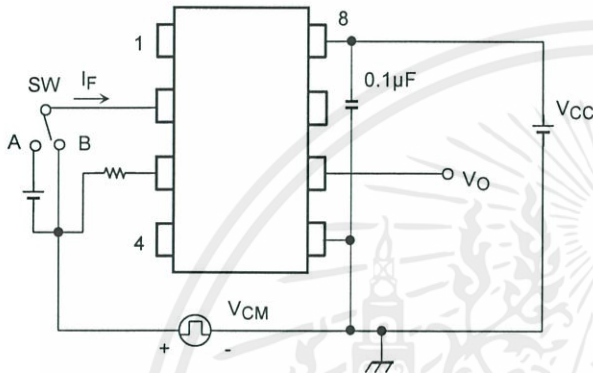


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Test Circuit 6: t_{pLH} , t_{pHL} , t_r , t_f



Test Circuit 7: C_{MH} , C_{ML}

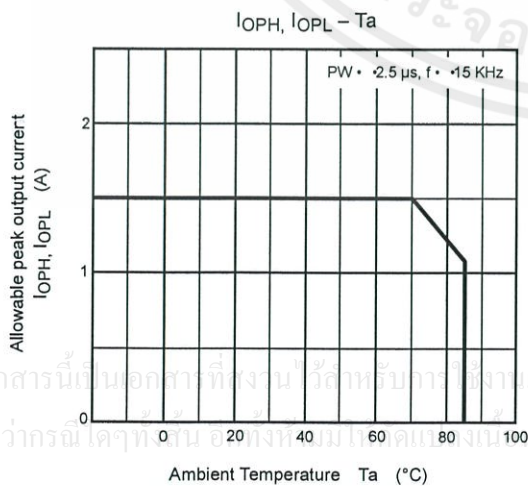
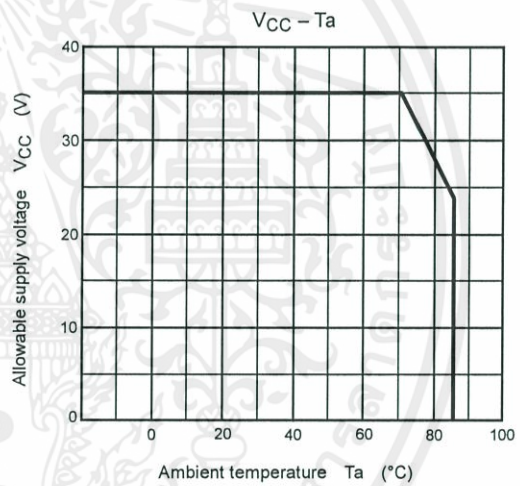
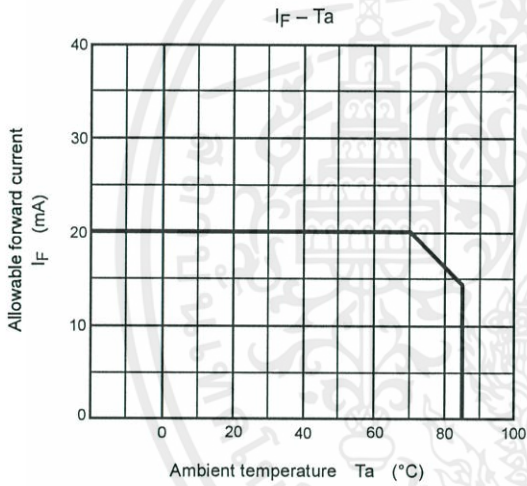
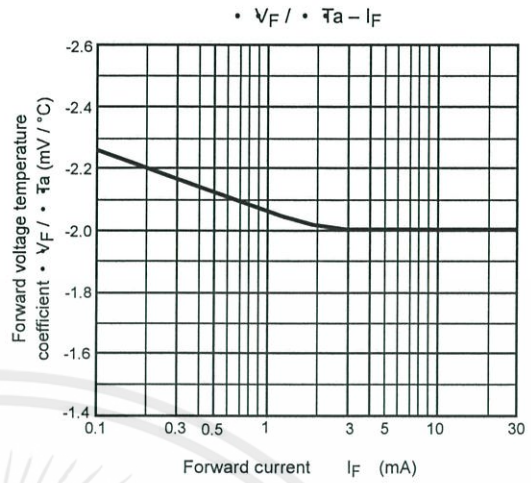
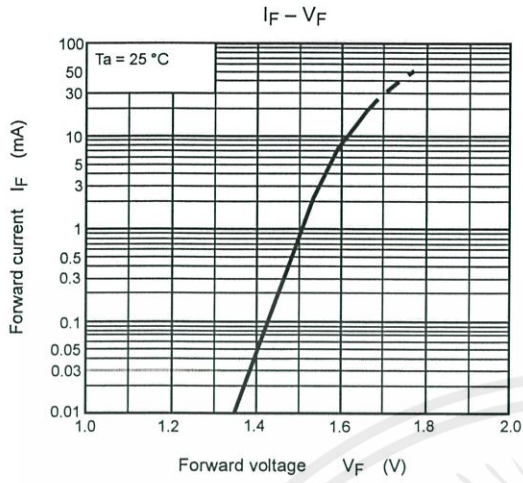


$$C_{ML} = \frac{480 (V)}{t_r (\mu s)}$$

$$C_{MH} = \frac{480 (V)}{t_f (\mu s)}$$

$C_{ML}(C_{MH})$ is the maximum rate of rise (fall) of the common mode voltage that can be sustained with the output voltage in the low (high) state.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งนี้ อนึ่งหากมีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้น และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

RESTRICTIONS ON PRODUCT USE

- The information contained herein is subject to change without notice.
- The information contained herein is presented only as a guide for the applications of our products. No responsibility is assumed by TOSHIBA for any infringements of patents or other rights of the third parties which may result from its use. No license is granted by implication or otherwise under any patent or patent rights of TOSHIBA or others.
- TOSHIBA is continually working to improve the quality and reliability of its products. Nevertheless, semiconductor devices in general can malfunction or fail due to their inherent electrical sensitivity and vulnerability to physical stress. It is the responsibility of the buyer, when utilizing TOSHIBA products, to comply with the standards of safety in making a safe design for the entire system, and to avoid situations in which a malfunction or failure of such TOSHIBA products could cause loss of human life, bodily injury or damage to property.
In developing your designs, please ensure that TOSHIBA products are used within specified operating ranges as set forth in the most recent TOSHIBA products specifications. Also, please keep in mind the precautions and conditions set forth in the "Handling Guide for Semiconductor Devices," or "TOSHIBA Semiconductor Reliability Handbook" etc..
- The TOSHIBA products listed in this document are intended for usage in general electronics applications (computer, personal equipment, office equipment, measuring equipment, industrial robotics, domestic appliances, etc.). These TOSHIBA products are neither intended nor warranted for usage in equipment that requires extraordinarily high quality and/or reliability or a malfunction or failure of which may cause loss of human life or bodily injury ("Unintended Usage"). Unintended Usage include atomic energy control instruments, airplane or spaceship instruments, transportation instruments, traffic signal instruments, combustion control instruments, medical instruments, all types of safety devices, etc.. Unintended Usage of TOSHIBA products listed in this document shall be made at the customer's own risk.
- The products described in this document are subject to the foreign exchange and foreign trade laws.
- TOSHIBA products should not be embedded to the downstream products which are prohibited to be produced and sold, under any law and regulations.
- GaAs(Gallium Arsenide) is used in this product. The dust or vapor is harmful to the human body. Do not break, cut, crush or dissolve chemically.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

LM78XX Series Voltage Regulators

General Description

The LM78XX series of three terminal regulators is available with several fixed output voltages making them useful in a wide range of applications. One of these is local on card regulation, eliminating the distribution problems associated with single point regulation. The voltages available allow these regulators to be used in logic systems, instrumentation, HiFi, and other solid state electronic equipment. Although designed primarily as fixed voltage regulators these devices can be used with external components to obtain adjustable voltages and currents.

The LM78XX series is available in an aluminum TO-3 package which will allow over 1.0A load current if adequate heat sinking is provided. Current limiting is included to limit the peak output current to a safe value. Safe area protection for the output transistor is provided to limit internal power dissipation. If internal power dissipation becomes too high for the heat sinking provided, the thermal shutdown circuit takes over preventing the IC from overheating.

Considerable effort was expended to make the LM78XX series of regulators easy to use and minimize the number

of external components. It is not necessary to bypass the output, although this does improve transient response. Input bypassing is needed only if the regulator is located far from the filter capacitor of the power supply.

For output voltage other than 5V, 12V and 15V the LM117 series provides an output voltage range from 1.2V to 57V.

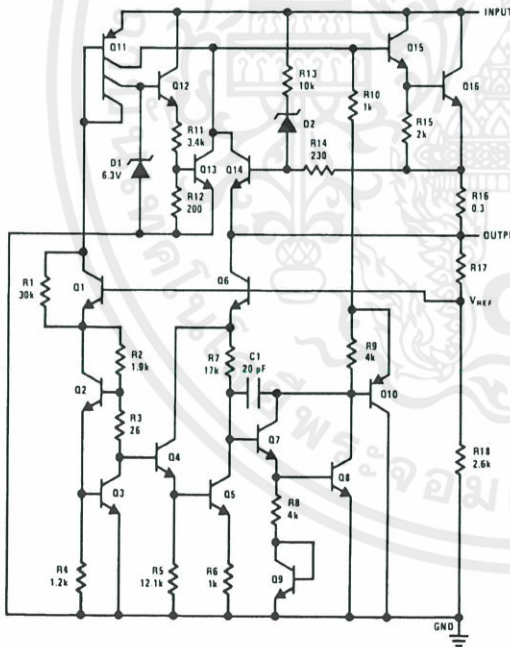
Features

- Output current in excess of 1A
- Internal thermal overload protection
- No external components required
- Output transistor safe area protection
- Internal short circuit current limit
- Available in the aluminum TO-3 package

Voltage Range

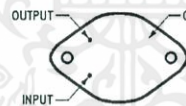
LM7805C	5V
LM7812C	12V
LM7815C	15V

Schematic and Connection Diagrams



TL/H/7746-1

Metal Can Package
TO-3 (K)
Aluminum

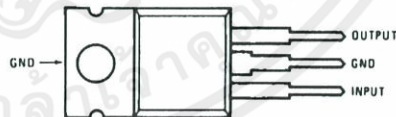


TL/H/7746-2

Bottom View

Order Number LM7805CK,
LM7812CK or LM7815CK
See NS Package Number KC02A

Plastic Package
TO-220 (T)



TL/H/7746-3

Top View

Order Number LM7805CT,
LM7812CT or LM7815CT
See NS Package Number T03B

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Absolute Maximum Ratings

If Military/Aerospace specified devices are required, please contact the National Semiconductor Sales Office/Distributors for availability and specifications.

Input Voltage ($V_O = 5V, 12V$ and $15V$) 35V
 Internal Power Dissipation (Note 1) Internally Limited
 Operating Temperature Range (T_A) 0°C to $+70^\circ\text{C}$

Maximum Junction Temperature
 (K Package) 150°C
 (T Package) 150°C
 Storage Temperature Range -65°C to $+150^\circ\text{C}$
 Lead Temperature (Soldering, 10 sec.)
 TO-3 Package K 300°C
 TO-220 Package T 230°C

Electrical Characteristics LM78XXC (Note 2) $0^\circ\text{C} \leq T_j \leq 125^\circ\text{C}$ unless otherwise noted.

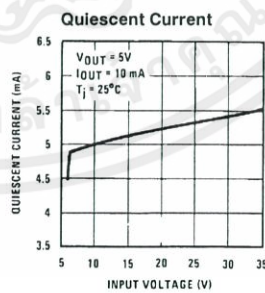
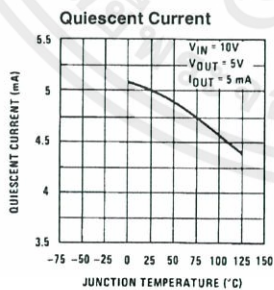
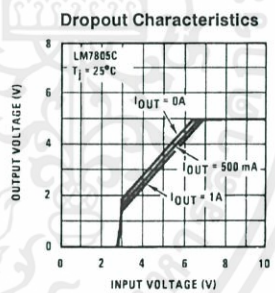
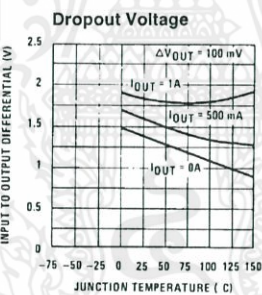
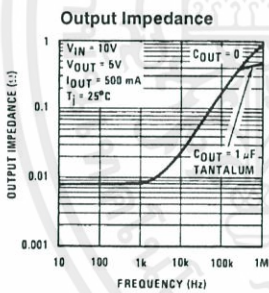
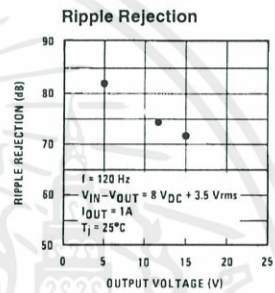
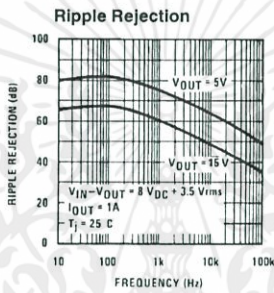
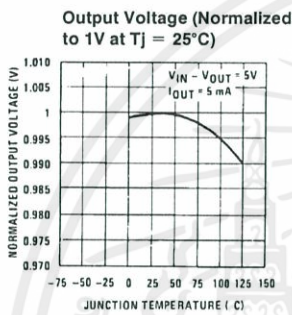
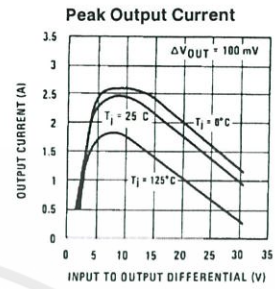
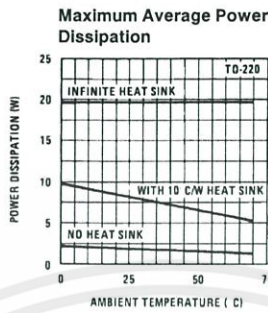
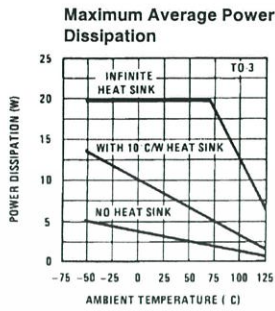
Output Voltage			5V			12V			15V			Units		
Input Voltage (unless otherwise noted)			10V			19V			23V					
Symbol	Parameter	Conditions	Min	Typ	Max	Min	Typ	Max	Min	Typ	Max			
V_O	Output Voltage	$T_j = 25^\circ\text{C}, 5\text{ mA} \leq I_O \leq 1\text{ A}$	4.8	5	5.2	11.5	12	12.5	14.4	15	15.6	V		
		$P_D \leq 15\text{ W}, 5\text{ mA} \leq I_O \leq 1\text{ A}$	4.75		5.25	11.4		12.6	14.25		15.75	V		
		$V_{\text{MIN}} \leq V_{\text{IN}} \leq V_{\text{MAX}}$	(7.5 $\leq V_{\text{IN}} \leq 20$)			(14.5 $\leq V_{\text{IN}} \leq 27$)			(17.5 $\leq V_{\text{IN}} \leq 30$)			V		
ΔV_O	Line Regulation	$I_O = 500\text{ mA}$	$T_j = 25^\circ\text{C}$	3	50	4	120	4	150			mV		
			ΔV_{IN}	(7 $\leq V_{\text{IN}} \leq 25$)			(14.5 $\leq V_{\text{IN}} \leq 30$)			(17.5 $\leq V_{\text{IN}} \leq 30$)		V		
		$0^\circ\text{C} \leq T_j \leq +125^\circ\text{C}$	ΔV_{IN}		50		120		150		150	mV		
			ΔV_{IN}	(8 $\leq V_{\text{IN}} \leq 20$)			(15 $\leq V_{\text{IN}} \leq 27$)			(18.5 $\leq V_{\text{IN}} \leq 30$)		V		
		$I_O \leq 1\text{ A}$	$T_j = 25^\circ\text{C}$		50		120		150		150	mV		
			ΔV_{IN}	(7.5 $\leq V_{\text{IN}} \leq 20$)			(14.6 $\leq V_{\text{IN}} \leq 27$)			(17.7 $\leq V_{\text{IN}} \leq 30$)		V		
ΔV_O	Load Regulation	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$5\text{ mA} \leq I_O \leq 1.5\text{ A}$	10	50	12	120	12	150			mV		
			$250\text{ mA} \leq I_O \leq 750\text{ mA}$		25		60		75			mV		
		$5\text{ mA} \leq I_O \leq 1\text{ A}, 0^\circ\text{C} \leq T_j \leq +125^\circ\text{C}$		50		120		150			mV			
I_Q	Quiescent Current	$I_O \leq 1\text{ A}$	$T_j = 25^\circ\text{C}$		8		8		8			mA		
			$0^\circ\text{C} \leq T_j \leq +125^\circ\text{C}$		8.5		8.5		8.5			mA		
ΔI_Q	Quiescent Current Change	$5\text{ mA} \leq I_O \leq 1\text{ A}$	$T_j = 25^\circ\text{C}, I_O \leq 1\text{ A}$		0.5		0.5		0.5			mA		
			$V_{\text{MIN}} \leq V_{\text{IN}} \leq V_{\text{MAX}}$	(7.5 $\leq V_{\text{IN}} \leq 20$)			(14.8 $\leq V_{\text{IN}} \leq 27$)			(17.9 $\leq V_{\text{IN}} \leq 30$)		V		
			$I_O \leq 500\text{ mA}, 0^\circ\text{C} \leq T_j \leq +125^\circ\text{C}$		1.0		1.0		1.0		1.0	mA		
V_N	Output Noise Voltage	$T_A = 25^\circ\text{C}, 10\text{ Hz} \leq f \leq 100\text{ kHz}$		40		75		90				μV		
			$\frac{\Delta V_{\text{IN}}}{\Delta V_{\text{OUT}}}$	Ripple Rejection	$f = 120\text{ Hz}$	$I_O \leq 1\text{ A}, T_j = 25^\circ\text{C}$ or	62	80	55	72	54	70		dB
						$I_O \leq 500\text{ mA}$	62		55		54			
		$0^\circ\text{C} \leq T_j \leq +125^\circ\text{C}$	(8 $\leq V_{\text{IN}} \leq 18$)			(15 $\leq V_{\text{IN}} \leq 25$)			(18.5 $\leq V_{\text{IN}} \leq 28.5$)		V			
R_O	Dropout Voltage	$T_j = 25^\circ\text{C}, I_{\text{OUT}} = 1\text{ A}$		2.0		2.0		2.0				V		
	Output Resistance	$f = 1\text{ kHz}$		8		18		19				$\text{m}\Omega$		
	Short-Circuit Current	$T_j = 25^\circ\text{C}$		2.1		1.5		1.2				A		
	Peak Output Current	$T_j = 25^\circ\text{C}$		2.4		2.4		2.4				A		
	Average TC of V_{OUT}	$0^\circ\text{C} \leq T_j \leq +125^\circ\text{C}, I_O = 5\text{ mA}$		0.6		1.5		1.8				$\text{mV}/^\circ\text{C}$		
V_{IN}	Input Voltage Required to Maintain Line Regulation	$T_j = 25^\circ\text{C}, I_O \leq 1\text{ A}$		7.5		14.6		17.7				V		

Note 1: Thermal resistance of the TO-3 package (K, KC) is typically $4^\circ\text{C}/\text{W}$ junction to case and $35^\circ\text{C}/\text{W}$ case to ambient. Thermal resistance of the TO-220 package (T) is typically $4^\circ\text{C}/\text{W}$ junction to case and $50^\circ\text{C}/\text{W}$ case to ambient.

Note 2: All characteristics are measured with capacitor across the input of $0.22\ \mu\text{F}$, and a capacitor across the output of $0.1\ \mu\text{F}$. All characteristics except noise voltage and ripple rejection ratio are measured using pulse techniques ($t_w \leq 10\text{ ms}$, duty cycle $\leq 5\%$). Output voltage changes due to changes in internal temperature must be taken into account separately.

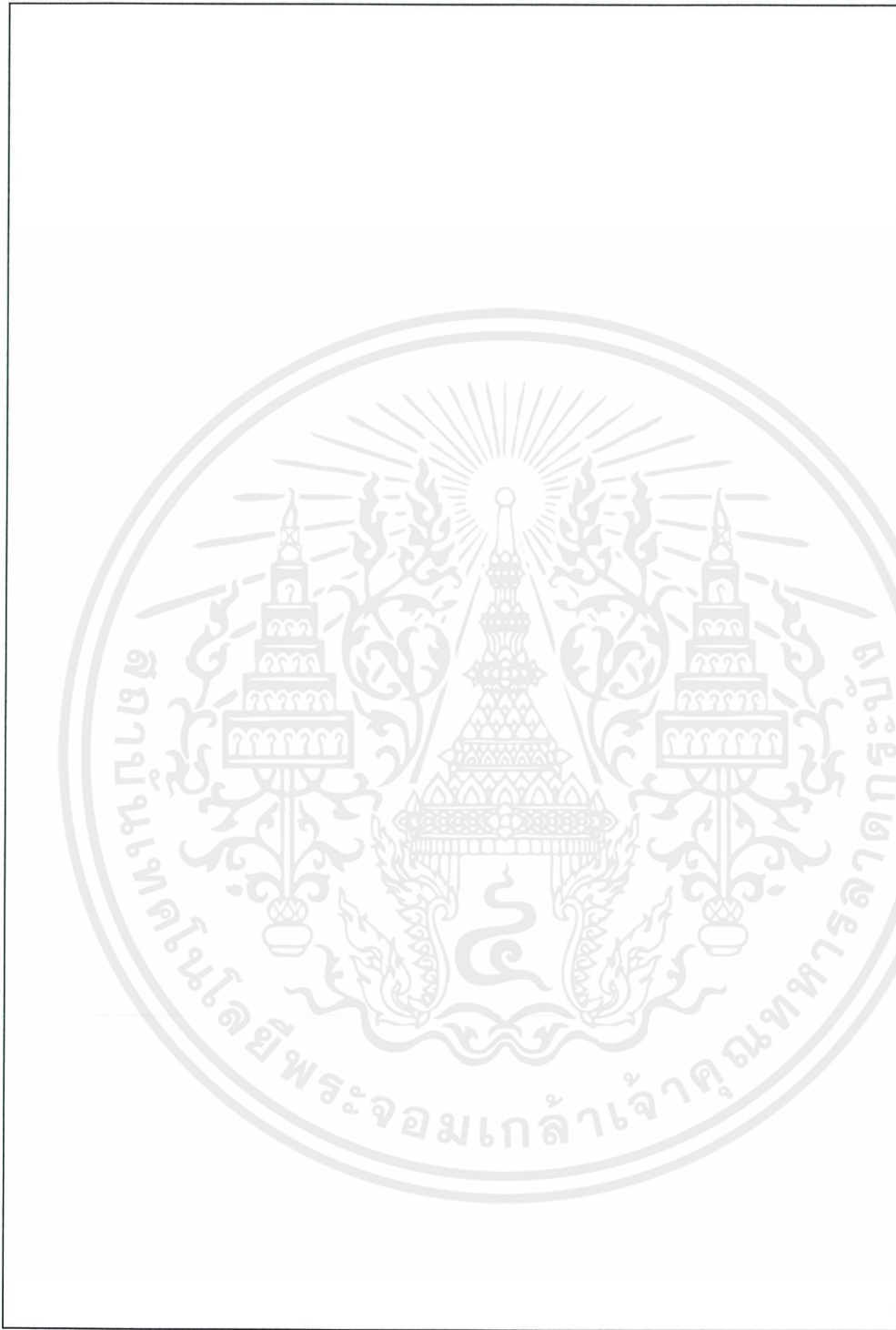
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Typical Performance Characteristics



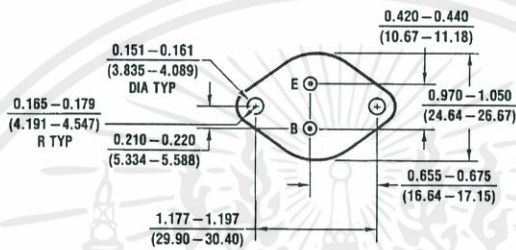
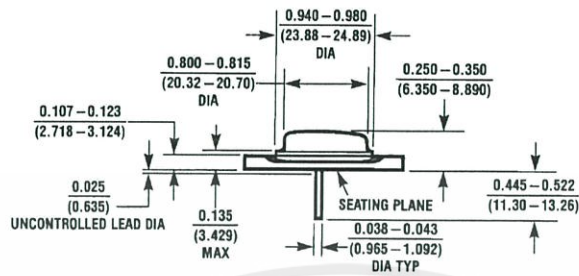
TL/H/7746-4

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

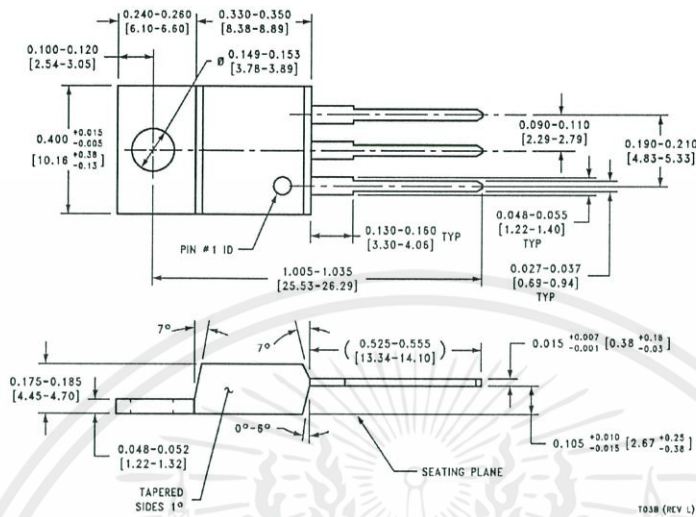
Physical Dimensions inches (millimeters)



Aluminum Metal Can Package (KC)
Order Number LM7805CK, LM7812CK or LM7815CK
NS Package Number KC02A

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Physical Dimensions inches (millimeters) (Continued)



TO-220 Package (T)
Order Number LM7805CT, LM7812CT or LM7815CT
NS Package Number T03B

LIFE SUPPORT POLICY

NATIONAL'S PRODUCTS ARE NOT AUTHORIZED FOR USE AS CRITICAL COMPONENTS IN LIFE SUPPORT DEVICES OR SYSTEMS WITHOUT THE EXPRESS WRITTEN APPROVAL OF THE PRESIDENT OF NATIONAL SEMICONDUCTOR CORPORATION. As used herein:

1. Life support devices or systems are devices or systems which, (a) are intended for surgical implant into the body, or (b) support or sustain life, and whose failure to perform, when properly used in accordance with instructions for use provided in the labeling, can be reasonably expected to result in a significant injury to the user.
2. A critical component is any component of a life support device or system whose failure to perform can be reasonably expected to cause the failure of the life support device or system, or to affect its safety or effectiveness.



National Semiconductor Corporation
 1111 West Bardin Road
 Arlington, TX 76017
 Tel: 1(800) 272-9959
 Fax: 1(800) 737-7018

National Semiconductor Europe
 Fax: (+49) 0-180-530 85 86
 Email: cnjwge@tevm2.nsc.com
 Deutsch Tel: (+49) 0-180-530 85 85
 English Tel: (+49) 0-180-532 78 32
 Français Tel: (+49) 0-180-532 93 58
 Italiano Tel: (+49) 0-180-534 16 80

National Semiconductor Hong Kong Ltd.
 13th Floor, Straight Block,
 Ocean Centre, 5 Canton Rd.
 Tsimshatsui, Kowloon
 Hong Kong
 Tel: (852) 2737-1600
 Fax: (852) 2736-9960

National Semiconductor Japan Ltd.
 13th Floor, Straight Block,
 Ocean Centre, 5 Canton Rd.
 Fax: 81-043-299-2309
 Fax: 81-043-299-2408

National does not assume any responsibility for use of any circuitry described, no circuit patent licenses are implied and National reserves the right at any time without notice to change said circuitry and specifications.

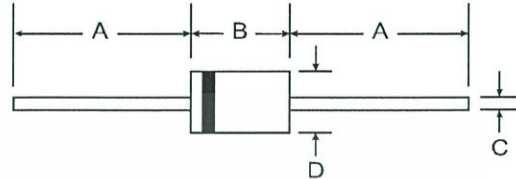
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Features

- Diffused Junction
- High Current Capability and Low Forward Voltage Drop
- Surge Overload Rating to 30A Peak
- Low Reverse Leakage Current
- **Lead Free Finish, RoHS Compliant (Note 3)**

Mechanical Data

- Case: DO-41
- Case Material: Molded Plastic. UL Flammability Classification Rating 94V-0
- Moisture Sensitivity: Level 1 per J-STD-020D
- Terminals: Finish - Bright Tin. Plated Leads Solderable per MIL-STD-202, Method 208
- Polarity: Cathode Band
- Mounting Position: Any
- Ordering Information: See Page 2
- Marking: Type Number
- Weight: 0.30 grams (approximate)



Dim	DO-41 Plastic	
	Min	Max
A	25.40	—
B	4.06	5.21
C	0.71	0.864
D	2.00	2.72
All Dimensions in mm		

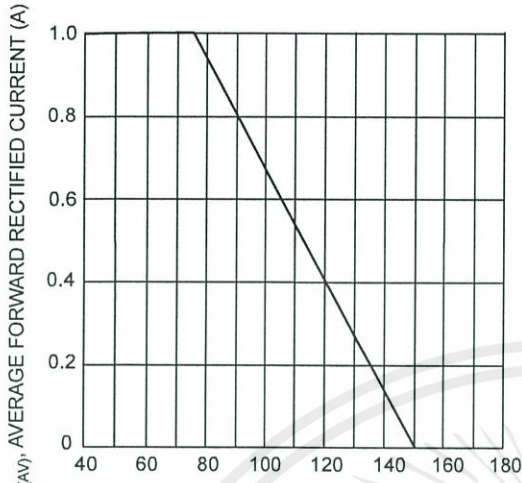
Maximum Ratings and Electrical Characteristics @ $T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise specified

Single phase, half wave, 60Hz, resistive or inductive load.
For capacitive load, derate current by 20%.

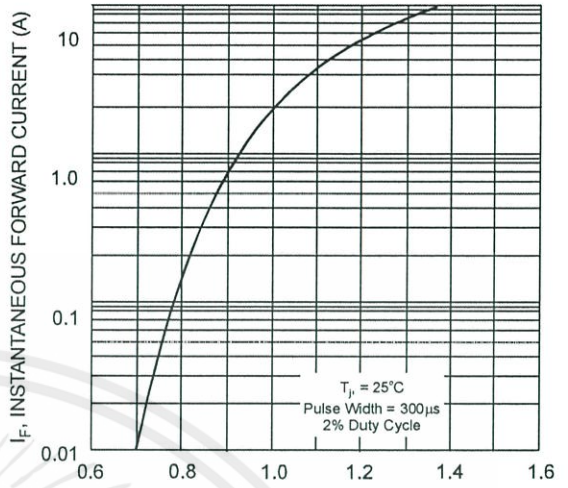
Characteristic	Symbol	1N4001	1N4002	1N4003	1N4004	1N4005	1N4006	1N4007	Unit
Peak Repetitive Reverse Voltage	V_{RRM}								V
Working Peak Reverse Voltage	V_{RWM}	50	100	200	400	600	800	1000	V
DC Blocking Voltage	V_R								V
RMS Reverse Voltage	$V_{R(RMS)}$	35	70	140	280	420	560	700	V
Average Rectified Output Current (Note 1) @ $T_A = 75^\circ\text{C}$	I_O				1.0				A
Non-Repetitive Peak Forward Surge Current 8.3ms single half sine-wave superimposed on rated load	I_{FSM}				30				A
Forward Voltage @ $I_F = 1.0\text{A}$	V_{FM}				1.0				V
Peak Reverse Current @ $T_A = 25^\circ\text{C}$	I_{RM}				5.0				μA
at Rated DC Blocking Voltage @ $T_A = 100^\circ\text{C}$					50				
Typical Junction Capacitance (Note 2)	C_j		15				8		pF
Typical Thermal Resistance Junction to Ambient	$R_{\theta JA}$				100				K/W
Maximum DC Blocking Voltage Temperature	T_A				+150				$^\circ\text{C}$
Operating and Storage Temperature Range	T_J, T_{STG}				-65 to +150				$^\circ\text{C}$

- Notes:
1. Leads maintained at ambient temperature at a distance of 9.5mm from the case.
 2. Measured at 1.0 MHz and applied reverse voltage of 4.0V DC.
 3. EU Directive 2002/95/EC (RoHS). All applicable RoHS exemptions applied, see EU Directive 2002/95/EC Annex Notes.

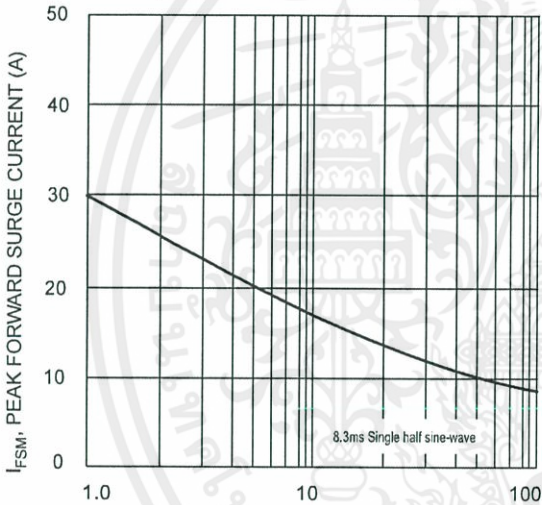
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



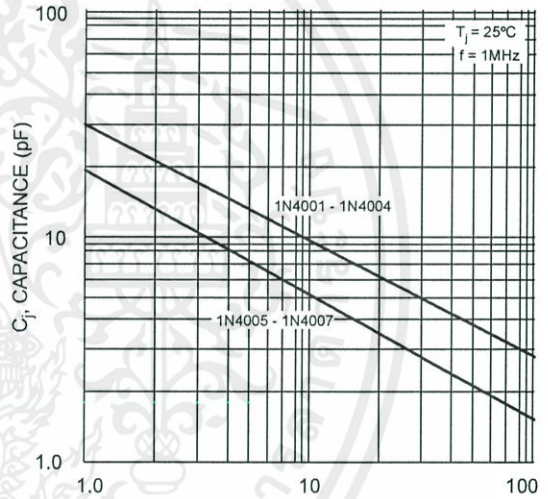
T_A , AMBIENT TEMPERATURE (°C)
Fig. 1 Forward Current Derating Curve



V_F , INSTANTANEOUS FORWARD VOLTAGE (V)
Fig. 2 Typical Forward Characteristics



NUMBER OF CYCLES AT 60 Hz
Fig. 3 Max Non-Repetitive Peak Fwd Surge Current



V_R , REVERSE VOLTAGE (V)
Fig. 4 Typical Junction Capacitance

Ordering Information (Note 4)

Device	Packaging	Shipping
1N4001-B	DO-41 Plastic	1K/Bulk
1N4001-T	DO-41 Plastic	5K/Tape & Reel, 13-inch
1N4002-B	DO-41 Plastic	1K/Bulk
1N4002-T	DO-41 Plastic	5K/Tape & Reel, 13-inch
1N4003-B	DO-41 Plastic	1K/Bulk
1N4003-T	DO-41 Plastic	5K/Tape & Reel, 13-inch
1N4004-B	DO-41 Plastic	1K/Bulk
1N4004-T	DO-41 Plastic	5K/Tape & Reel, 13-inch
1N4005-B	DO-41 Plastic	1K/Bulk
1N4005-T	DO-41 Plastic	5K/Tape & Reel, 13-inch
1N4006-B	DO-41 Plastic	1K/Bulk
1N4006-T	DO-41 Plastic	5K/Tape & Reel, 13-inch
1N4007-B	DO-41 Plastic	1K/Bulk
1N4007-T	DO-41 Plastic	5K/Tape & Reel, 13-inch

Notes: 4. For packaging details, visit our website at <http://www.diodes.com/datasheets/ap02008.pdf>.

IMPORTANT NOTICE

Diodes Incorporated and its subsidiaries reserve the right to make modifications, enhancements, improvements, corrections or other changes without further notice to any product herein. Diodes Incorporated does not assume any liability arising out of the application or use of any product described herein; neither does it convey any license under its patent rights, nor the rights of others. The user of products in such applications shall assume all risks of such use and will agree to hold Diodes Incorporated and all the companies whose products are represented on our website, harmless against all damages.

LIFE SUPPORT

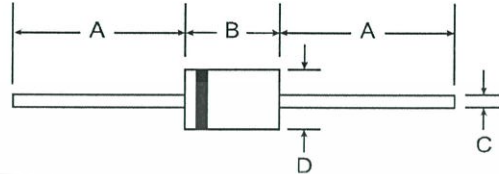
Diodes Incorporated products are not authorized for use as critical components in life support devices or systems without the expressed written approval of the President of Diodes Incorporated.



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Features

- 1.0 Watt Power Dissipation
- 3.3V - 75V Nominal Zener Voltage
- Standard V_Z Tolerance is 5%
- Lead Free Finish, RoHS Compliant (Note 2)



Mechanical Data

- Case: DO-41
- Case Material: Glass. UL Flammability Classification Rating 94V-0
- Terminals: Finish — Sn96.5Ag3.5. Solderable per MIL-STD-202, Method 208
- Polarity: Cathode Band
- Marking: Type Number
- Weight: 0.35 grams (approximate)

DO-41 Glass		
Dim	Min	Max
A	26.0	—
B	—	4.10
C	—	0.86
D	—	2.60
All Dimensions in mm		

Maximum Ratings @ $T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise specified

Characteristic	Symbol	Value	Unit
Zener Current (see Table page 2)	I_Z	P_d / V_Z	mA
Power Dissipation	P_d	1.0	W
Derate Above 50°C (Note 1)		6.67	mW/ $^\circ\text{C}$
Thermal Resistance - Junction to Ambient Air	$R_{\theta JA}$	175	$^\circ\text{C}/\text{W}$
Forward Voltage @ $I_F = 200\text{ mA}$	V_F	1.2	V
Operating and Storage Temperature Range	T_j, T_{STG}	-65 to + 175	$^\circ\text{C}$

- Notes:
1. Valid provided that leads are kept at TL @ 50°C with lead length = 9.5mm (3/8") from case.
 2. EC Directive 2002/95/EC (RoHS) revision 13.2.2003. Glass and high temperature solder exemptions applied where applicable, see EU Directive Annex Notes 5 and 7.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Electrical Characteristics @T_A = 25°C unless otherwise specified

Type Number	Nominal Zener Voltage (Note 3)	Test Current	Maximum Zener Impedance (Note 4)			Maximum Reverse Leakage Current		Max Surge Current 8.3ms	Temperature Coefficient @ I _{ZT}
	V _Z @ I _{ZT}	I _{ZT}	Z _{ZT} @ I _{ZT}	Z _{ZK} @ I _{ZK}	I _{ZK}	I _R	@ V _R	I _{ZS}	
	(V)	(mA)	(Ω)	(Ω)	(mA)	(μA)	(V)	(mA)	%/°C
1N4728A	3.3	76	10	400	1.0	100	1.0	1380	-0.08 to -0.05
1N4729A	3.6	69	10	400	1.0	100	1.0	1260	-0.08 to -0.05
1N4730A	3.9	64	9.0	400	1.0	50	1.0	1190	-0.07 to -0.02
1N4731A	4.3	58	9.0	400	1.0	10	1.0	1070	-0.07 to -0.01
1N4732A	4.7	53	8.0	500	1.0	10	1.0	970	-0.03 to +0.04
1N4733A	5.1	49	7.0	550	1.0	10	1.0	890	-0.01 to +0.04
1N4734A	5.6	45	5.0	600	1.0	10	2.0	810	0 to +0.045
1N4735A	6.2	41	2.0	700	1.0	10	3.0	730	+0.01 to +0.055
1N4736A	6.8	37	3.5	700	1.0	10	4.0	660	+0.015 to +0.06
1N4737A	7.5	34	4.0	700	0.5	10	5.0	605	+0.02 to +0.065
1N4738A	8.2	31	4.5	700	0.5	10	6.0	550	0.03 to 0.07
1N4739A	9.1	28	5.0	700	0.5	10	7.0	500	0.035 to 0.075
1N4740A	10	25	7.0	700	0.25	10	7.6	454	0.04 to 0.08
1N4741A	11	23	8.0	700	0.25	5.0	8.4	414	0.045 to 0.08
1N4742A	12	21	9.0	700	0.25	5.0	9.1	380	0.045 to 0.085
1N4743A	13	19	10	700	0.25	5.0	9.9	344	0.05 to 0.085
1N4744A	15	17	14	700	0.25	5.0	11.4	304	0.055 to 0.09
1N4745A	16	15.5	16	700	0.25	5.0	12.2	285	0.055 to 0.09
1N4746A	18	14	20	750	0.25	5.0	13.7	250	0.06 to 0.09
1N4747A	20	12.5	22	750	0.25	5.0	15.2	225	0.06 to 0.09
1N4748A	22	11.5	23	750	0.25	5.0	16.7	205	0.06 to 0.095
1N4749A	24	10.5	25	750	0.25	5.0	18.2	190	0.06 to 0.095
1N4750A	27	9.5	35	750	0.25	5.0	20.6	170	0.06 to 0.095
1N4751A	30	8.5	40	1000	0.25	5.0	22.8	150	0.06 to 0.095
1N4752A	33	7.5	45	1000	0.25	5.0	25.1	135	0.06 to 0.095
1N4753A	36	7.0	50	1000	0.25	5.0	27.4	125	0.06 to 0.095
1N4754A	39	6.5	60	1000	0.25	5.0	29.7	115	0.06 to 0.095
1N4755A	43	6.0	70	1500	0.25	5.0	32.7	110	0.06 to 0.095
1N4756A	47	5.5	80	1500	0.25	5.0	35.8	95	0.06 to 0.095
1N4757A	51	5.0	95	1500	0.25	5.0	38.8	90	0.06 to 0.095
1N4758A	56	4.5	110	2000	0.25	5.0	42.6	80	0.06 to 0.095
1N4759A	62	4.0	125	2000	0.25	5.0	47.1	70	0.06 to 0.095
1N4760A	68	3.7	150	2000	0.25	5.0	51.7	65	0.06 to 0.095
1N4761A	75	3.3	175	2000	0.25	5.0	56.0	60	0.06 to 0.095

- Notes:
3. Measured under thermal equilibrium and dc (I_{ZT}) test conditions.
 4. The Zener impedance is derived from the 60 Hz ac voltage which results when an ac current having an rms value equal to 10% of the Zener current (I_{ZT} or I_{ZK}) is superimposed on I_{ZT} or I_{ZK}. Zener impedance is measured at two points to insure a sharp knee on the breakdown curve and to eliminate unstable units.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

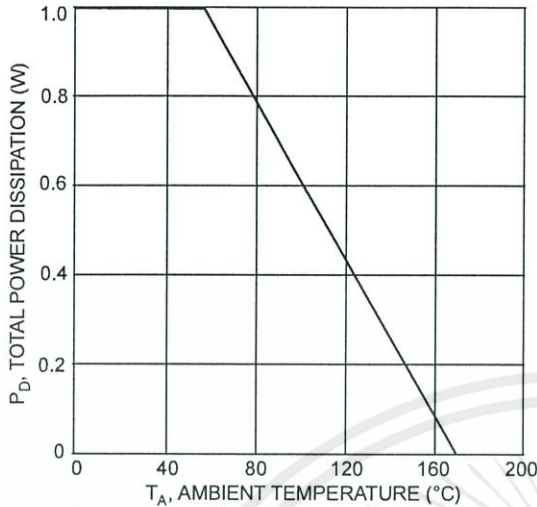


Fig. 1 Power Dissipation vs. Ambient Temperature

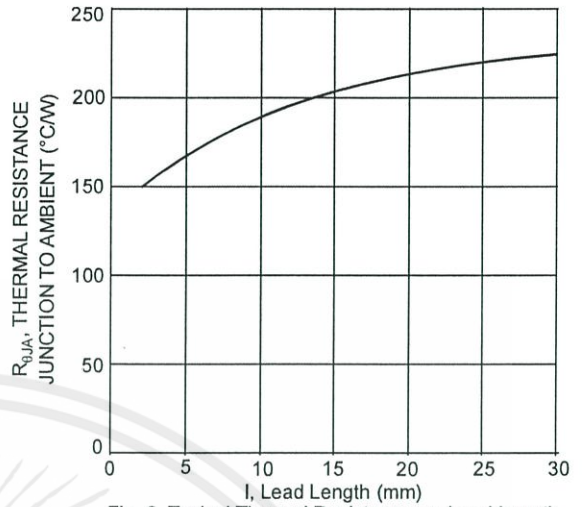


Fig. 2 Typical Thermal Resistance vs. Lead Length

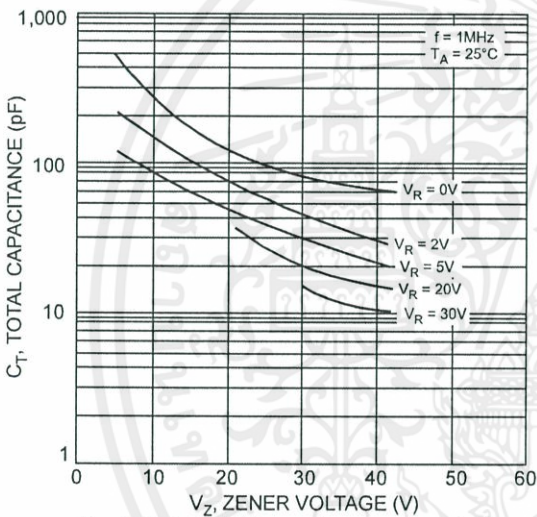


Fig. 3 Typical Total Capacitance vs. Zener Voltage

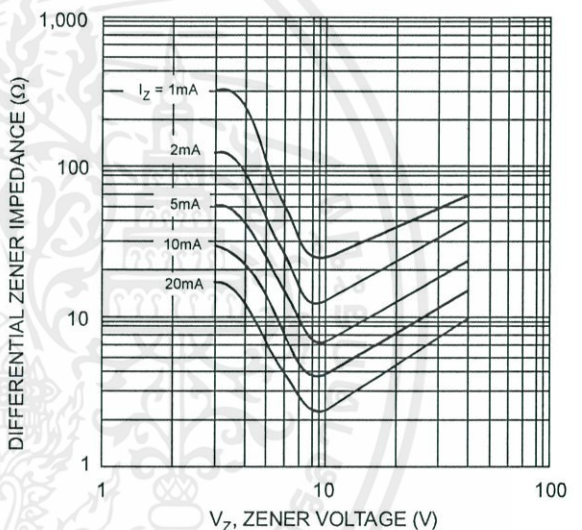


Fig. 4 Typical Zener Impedance vs. Zener Voltage

Ordering Information (Notes 5 & 6)

Device	Packaging	Shipping
(Type Number)-A*	DO-41 Glass	5K/Ammo Pack
(Type Number)-T*	DO-41 Glass	5K/Tape & Reel

- Notes: 5. *Add "-A" or "-T" to the appropriate type number in Electrical Characteristics Table. Example: 6.2V Zener = 1N4735A-A for ammo pack.
6. For packaging details, visit our website at <http://www.diodes.com/datasheets/ap02008.pdf>

IMPORTANT NOTICE

Diodes Incorporated and its subsidiaries reserve the right to make modifications, enhancements, improvements, corrections or other changes without further notice to any product herein. Diodes Incorporated does not assume any liability arising out of the application or use of any product described herein; neither does it convey any license under its patent rights, nor the rights of others. The user of products in such applications shall assume all risks of such use and will agree to hold Diodes Incorporated and all the companies whose products are represented on our website, harmless against all damages.

LIFE SUPPORT

Diodes Incorporated products are not authorized for use as critical components in life support devices or systems without the expressed written approval of the President of Diodes Incorporated.



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

โปรแกรมควบคุมแหล่งจ่ายไฟฟ้าดิจิทัล

```

#include "p30f4011.h"
#include "uart.h"
#include "libpic30.h"
#include "stdio.h"
#include "ports.h"

_FOSC(CSW_FSCM_OFF & XT_PLL16);
// Disable clock monitor, external 7.3728MHz oscillator
_FWDT(WDT_OFF);
// Disable Watch-Dog Timer.
_FBORPOR(PBOR_OFF & MCLR_EN/* & PWRT_OFF & PWMxH_ACT_HI*!);
// Brown out reset disabled, enable MCLR reset pin, turn off power-up timer, PWMxH
acts high
_FGS(CODE_PROT_OFF);
// Disable Code Protection

#define FOSC 117964800 // 7.3728Mhz x 16 PLL
#define FCY (FOSC / 4) // Fcy = 29.4912 MHz
#define BAUD_RATE 9600 //Desired BAUD is 19200
#define UXBURG (((FCY / 16) / BAUD_RATE) -1)

void UART_Init(void)
{
    U1BRG = UXBURG; // 9600 baud rate 191 ,
    U1MODE = 0; // Clear U1MODE Register
    U1STA = 0; // Clear U1STA Register
    U1MODEbits.PDSEL = 0; // 8 bits no parity
    U1MODEbits.STSEL = 0; // 1 stop bit
}

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 ไม่ว่ากรณีใดๆที่เอกสารนี้ถูกเปลี่ยนแปลงและต้องอัปเดตเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

U1MODEbits.ALTI0      = 1;          // alternate tx and rx, useful as we can
leave the debugger on while doing comms

U1STAbits.URXISEL     = 10;        // ***Enable Receiver Interrupt

U1MODEbits.UARTEN     = 1;        // uart on

U1STAbits.OERR        = 0;        //*****clear any errors so data can be received
U1STAbits.FERR        = 0;        //*****clear any errors so data can be received
U1STAbits.PERR        = 0;        //*****clear any errors so data can be received
}

```

```

void delay_ms(unsigned int ms)
{
    unsigned int i;
    while(ms--){
        for(i=0; i<31; i++)
            Nop();          //Delay 1 MCY
    }
}

```

```

int main(void)
{
    UART_Init();
    ADPCFG = 0xFF;
    TRISB = 0xFF;
    TRISD = 0;
    _TRISF0 = 1;
    _TRISF1 = 1;
    _TRISF2 = 1;
    _TRISF3 = 1;
    _TRISF4 = 1;
    _TRISF5 = 1;
}

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

unsigned int m=1,a=1,c=3,d=1,p=1,n=1,j,k;
float dt = 0.125;

```

```

while(1)

```

```

{

```

```

    // T1 *****

```

```

        _LATD0 = 0;

```

```

        _LATD1 = 0;

```

```

        _LATD2 = 1;

```

```

        _LATD3 = 0;

```

```

        delay_ms(dt);

```

```

        _LATD0 = 1;

```

```

        _LATD1 = 0;

```

```

        _LATD2 = 1;

```

```

        _LATD3 = 0;

```

```

        delay_ms(m);

```

```

    // T2 *****

```

```

        _LATD0 = 0;

```

```

        _LATD1 = 0;

```

```

        _LATD2 = 1;

```

```

        _LATD3 = 0;

```

```

        //delay_ms(dt);

```

```

        _LATD0 = 0;

```

```

        _LATD1 = 1;

```

```

        _LATD2 = 1;

```

```

        _LATD3 = 0;

```

```

        delay_ms(a);

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

for (j=p; j>1; j--)
{
    _LATD0 = 0;
    _LATD1 = 0;
    _LATD2 = 1;
    _LATD3 = 0;
    delay_ms(dt);

    _LATD0 = 1;
    _LATD1 = 0;
    _LATD2 = 1;
    _LATD3 = 0;
    delay_ms(m);

    _LATD0 = 0;
    _LATD1 = 0;
    _LATD2 = 1;
    _LATD3 = 0;
    delay_ms(dt);

    _LATD0 = 0;
    _LATD1 = 1;
    _LATD2 = 1;
    _LATD3 = 0;
    delay_ms(a);
}

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดลอกเผยแพร่ และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

// T3

```

_LATD0 = 0;
_LATD1 = 1;
_LATD2 = 0;
_LATD3 = 0;
delay_ms(dt);

```

```

_LATD0 = 0;
_LATD1 = 1;
_LATD2 = 0;
_LATD3 = 1;
delay_ms(c);

```

```

// T4 *****

```

```

_LATD0 = 0;
_LATD1 = 1;
_LATD2 = 0;
_LATD3 = 0;

```

```

//delay_ms(dt);

```

```

_LATD0 = 0;
_LATD1 = 1;
_LATD2 = 1;
_LATD3 = 0;

```

```

delay_ms(d);

```

```

for (k=n; k>1; k--)

```

```

{

```

```

    _LATD0 = 0;

```

```

    _LATD1 = 1;

```

```

    _LATD2 = 0;

```

```

    _LATD3 = 0;

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
delay_ms(dt);
```

```
_LATD0 = 0;
```

```
_LATD1 = 1;
```

```
_LATD2 = 0;
```

```
_LATD3 = 1;
```

```
delay_ms(c);
```

```
_LATD0 = 0;
```

```
_LATD1 = 1;
```

```
_LATD2 = 0;
```

```
_LATD3 = 0;
```

```
delay_ms(dt);
```

```
_LATD0 = 0;
```

```
_LATD1 = 1;
```

```
_LATD2 = 1;
```

```
_LATD3 = 0;
```

```
delay_ms(d);
```

```
}
```

```
char
```

```
ch1,ch2,ch3,ch4,ch5,ch6,ch7,ch8,ch9,ch10,ch11,ch12,ch13,ch14,ch15,ch16;
```

```
_U1RXIF = 0;
```

```
//while(DataRdyUART1())
```

```
if(DataRdyUART1() == 1)
```

```
{
```

```
while (DataRdyUART1() == 0);
```

```
ch1 = ReadUART1();
```

```
while (DataRdyUART1() == 0);
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดลอกเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

ch2 = ReadUART1();
while (DataRdyUART1() == 0);
ch3 = ReadUART1();
while (DataRdyUART1() == 0);
ch4 = ReadUART1();
while (DataRdyUART1() == 0);
ch5 = ReadUART1();
while (DataRdyUART1() == 0);
ch6 = ReadUART1();
while (DataRdyUART1() == 0);
ch7 = ReadUART1();
while (DataRdyUART1() == 0);
ch8 = ReadUART1();
while (DataRdyUART1() == 0);
ch9 = ReadUART1();
while (DataRdyUART1() == 0);
ch10 = ReadUART1();
while (DataRdyUART1() == 0);
ch11 = ReadUART1();
while (DataRdyUART1() == 0);
ch12 = ReadUART1();
while (DataRdyUART1() == 0);
ch13 = ReadUART1();
while (DataRdyUART1() == 0);
ch14 = ReadUART1();
while (DataRdyUART1() == 0);
ch15 = ReadUART1();
while (DataRdyUART1() == 0);
ch16 = ReadUART1();

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
m = (ch1-48)+(ch2-48)+(ch3-48);
```

```

a = (ch4-48)+(ch5-48)+(ch6-48);
c = (ch7-48)+(ch8-48)+(ch9-48);
d = (ch10-48)+(ch11-48)+(ch12-48);
p = (ch13-48)+(ch14-48);
n = (ch15-48)+(ch16-48);
    }
}
return 0;
}

```



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

วงจรอิเล็กทรอนิกส์กำลังสำหรับการเตรียมฟิล์มบางบนวัสดุรองรับโดยใช้เทคนิค

พัลส์ ดีซี แมกนีตรอน สเปคโตรริง

A Power Electronics Circuit for Thin Films Preparation Using

Pulses DC Magnetron Sputtering Technique

กฤติน สมานวงษ์ กัณตภณ อยู่ยืนพัฒนา และ ทิวาพร ขอพิมาย

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

1 ซอย ฉลองกรุง 1 ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 โทรศัพท์ 02-329-8000 ต่อ 3925 E-Mail: takung_basketball@hotmail.com

บทคัดย่อ

บทความฉบับนี้เป็นรายงานผลการออกแบบสร้างแหล่งจ่ายไฟฟ้าดีซีพัลส์ สำหรับประยุกต์ใช้ในเครื่องเคลือบฟิล์มบางชนิดดีซีแมกนีตรอนสเปคโตรริง ออกแบบโดยใช้วงจรฟูลบริดจ์อินเวอร์เตอร์เฟสเดียวมาแบ่งจ่ายแยกแต่ละกิ่งด้วยแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันสูงแบบปรับค่าได้ และนำเสนอการเคลือบฟิล์มบางโดยใช้เทคนิคดีซีพัลส์สร้างขบวนการดีซีพัลส์ด้วยการโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์และจัดให้สามารถสั่งการควบคุมได้จากหน้าจอกอมพิวเตอร์ ซึ่งขบวนการแรงดันที่ออกมาจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าดีซีพัลส์นั้นจะต้องปรับแรงดันได้ด้วยการปรับแรงดันของชุดแหล่งจ่ายแรงดันปรับค่าได้ และสามารถปรับค่าความกว้างพัลส์ได้ตามต้องการ ทดสอบชิ้นงานด้วยการนำไปเคลือบฟิล์มบางบนวัสดุรองรับ โดยใช้วิธีดีซีพัลส์ จากผลการทดสอบพบว่า การเคลือบฟิล์มบางบนวัสดุรองรับด้วยเทคนิคดีซีพัลส์นั้นจะไม่ทำให้วัสดุรองรับมีอุณหภูมิสูงเกินไป เหมาะสำหรับการใช้เคลือบวัสดุที่ทนความร้อนได้ไม่มาก และเหมาะสมกับการนำไปใช้งานจริง

คำสำคัญ : ดีซีแมกนีตรอนสเปคโตรริง , ฟูลบริดจ์อินเวอร์เตอร์ , ดีซีพัลส์ , ดีซีสมูท

ABSTRACT

This paper presents a design and construction of a DC Pulse Power Supply for DC magnetron sputtering thin film coating applications. The power electronics part is designed and constructed by using two variable voltage power supply feed on single phase full bridge inverter separately each branch. The technique presented for thin film coating is DC pulse technique. The DC pulse controlled signal is generated by digital signal peripheral interface controller and provided

the computer LCD as control panel. The well designed DC pulse power supply must have voltage and period adjustable. The performance of the DC pulse power supply has been examined by real thin film coating with DC Pulse technique. The test results show that the DC pulse technique gave a better thermal characteristic of coating than the DC smooth so the DC pulse technique is more suitable for the substrate that cannot bare high temperature and it is the most suitable technique for all thin film coating application today.

Keywords: DC magnetron sputtering , full bridge inverter , DC pulse , DC smooth

1. บทนำ

ฟิล์มบางสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้มากมาย เช่นฟิล์มบางชนิด อินเดียมทินออกไซด์ ถูกนำมาใช้ประโยชน์มากมาย ไม่ว่าจะเป็นขั้วไฟฟ้าโปร่งแสงสำหรับจอภาพแสดงผล เซลล์แสงอาทิตย์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆอีกมากมาย ฟิล์มที่ดีจะต้องมีค่าสภาพต้านทานต่ำ ในปัจจุบันได้มีการเตรียมฟิล์มบางลงบนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ที่มีหน้าหนักเบา และจอภาพ (Touch Panel Display) อย่างไรก็ตามวัสดุรองรับที่เป็นพลาสติกจะทนความร้อนได้ไม่สูง และเทคนิคในการเตรียมฟิล์มบางที่เรียกว่า ดีซี แมกนีตรอน สเปคโตรริง (DC Magnetron Sputtering) นั้นจะทำให้เกิดความร้อนสูงบนวัสดุรองรับ ซึ่งส่งผลเสียต่อวัสดุรองรับในปริมาณที่พบนี้นี้จึงได้นำเสนอเทคนิคการเคลือบฟิล์มบางที่เรียกว่า ดีซีพัลส์ (DC Pulses) ซึ่งเทคนิคนี้นั้นสามารถจะควบคุมกำลังไฟฟ้าขาออกที่จ่ายไปยังห้องเคลือบฟิล์มได้ ซึ่งเราสามารถกำหนดค่ากำลังไฟฟ้าที่เหมาะสมต่อการเคลือบฟิล์มบางได้ เทคนิค DC Smooth และ DC Pulses นั้นให้คุณลักษณะการเคลือบวัสดุรองรับต่างกัน เช่น แรงดันการเคลือบ

กระแสพลาสมา เป็นต้น การใช้เทคนิค DC Pulses เหมาะกับวัสดุรองรับที่ทนอุณหภูมิได้ไม่สูงนัก เนื่องจากการเคลื่อนที่นั้นไม่มีความต่อเนื่อง และผลของความต่างศักย์ในการเคลื่อนที่นั้นต่ำกว่าเทคนิค DC Smooth ถึง 160 ถึง 170 โวลต์ ซึ่งส่งผลต่อพลังงานในการสเปกโตรอะตอมและอุณหภูมิของวัสดุรองรับ

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1 หลักการพื้นฐานของการเคลื่อนที่ด้วยฟิล์มบาง

การเคลื่อนที่ฟิล์มบางด้วยวิธีแมกนีตรอนสเปกโตรริงเป็นการทำให้อะตอมแตกตัวออกจากผิวของทาร์เกตด้วยพลังงานจากไอออน เมื่ออนุภาคไอออนได้พุ่งเข้าชนผิวทาร์เกตด้วยพลังงานที่สูงพอ จะทำให้พันธะอะตอมทาร์เกตสลายตัวและอนุภาคจะแตกกระจายออกมาจากผิวทาร์เกตลงมาเคลื่อนบนวัสดุรองรับ

2.2 แหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูงปรับค่าได้

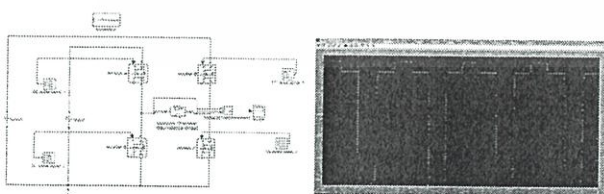
แหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูงจะนำมาเป็นแรงดันขาเข้าของวงจร H-Bridge สามารถปรับค่าได้อย่างอิสระทั้งสองด้านคือ V_{DC1} จะเป็นแรงดันที่ใช้ในโหมดแรงดันบวก และ V_{DC2} จะเป็นแรงดันที่ใช้ในโหมดแรงดันลบ เพื่อปรับอัตราการเคลื่อนที่ของฟิล์มบาง

2.3 การควบคุมโหมดการทำงาน

การควบคุมให้วงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้าดีซีพัลส์ทำงานได้ตามโหมดที่ต้องการ จะใช้นั้นสามารถทำได้โดยการโปรแกรมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ การควบคุมปฏิกิริยาของพลาสมาในห้องสุญญากาศนั้นจะต้องปรับเปลี่ยนตัวแปรพารามิเตอร์ของขบวนการทั้งหมดให้ได้ตามที่ต้องการ

3. การออกแบบและสร้างแหล่งจ่ายไฟฟ้าดีซีพัลส์

3.1 การจำลองวงจร (Simulation)

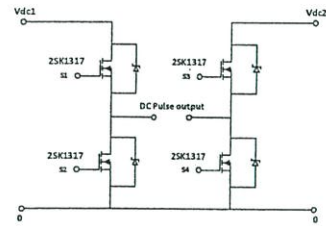


รูปที่ 3.1 การจำลองแหล่งจ่ายไฟฟ้าดีซีพัลส์ด้วยโปรแกรม

MATLAB Simulink

3.2 การสร้างวงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้าดีซีพัลส์

3.2.1 การสร้างวงจรกำลัง

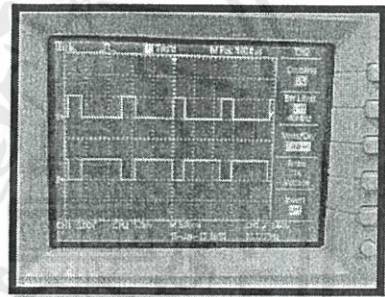


รูปที่ 3.3 รูปแบบวงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้าดีซีพัลส์

3.2.2 การสร้างวงจรควบคุม

วงจรควบคุมประกอบไปด้วย 1.)วงจรไฟเลี้ยง 2.)วงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ และ 3.)วงจรขับเคลื่อนและแยกกราวด์

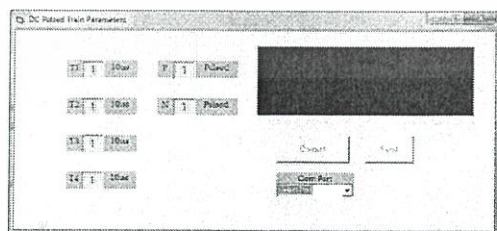
3.3 การสร้างรูปขบวนคลื่นดีซีพัลส์ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์



รูปที่ 3.4 สัญลักษณ์ขาขาของมอสเฟต S1 (บน) และมอสเฟต S2 (ล่าง)

3.4 การสร้างการควบคุมผ่านคอมพิวเตอร์ (Computer Control Panel)

การทดลองวงจรแหล่งจ่ายดีซีพัลส์แมกนีตรอนสเปกโตรริงจำเป็นต้องมีการปรับค่าคาบของคลื่นพัลส์และจำนวนคลื่นพัลส์ให้ได้ลักษณะคลื่นพัลส์ที่เหมาะสมกับการใช้งานในรูปแบบต่างๆ จึงมีการนำโปรแกรม Visual Basic 6.0 มาเป็นตัวกลางในการรับคำสั่งจากผู้ใช้งานและส่งข้อมูลไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์ให้ปรับค่าตามคำสั่งนั้นได้



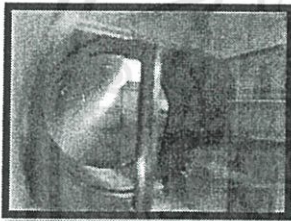
รูปที่ 3.5 อินเทอร์เฟซเพื่อควบคุมแหล่งจ่ายไฟฟ้าดีซีพัลส์

4. ผลการทดลอง

4.1 ผลการทดสอบแหล่งจ่ายไฟฟ้าดีซีพัลส์เมื่อทดลองเคลือบฟิล์มบาง

ขั้นตอนการเตรียมการเคลือบฟิล์มบางด้วยแหล่งจ่ายไฟฟ้าดีซีพัลส์สามารถทำได้ดังนี้

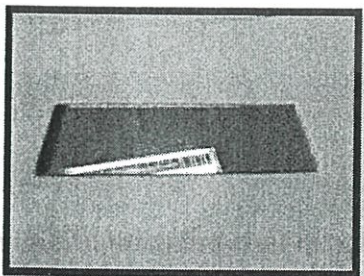
- 1) นำชิ้นงานกระจกใสเข้ามาวางที่ขั้วอานโคเพื่อเตรียมการเคลือบฟิล์มบาง
- 2) ตั้งค่าความดันอากาศและความดันก๊าซเฉื่อยให้เหมาะสมกับการเคลือบฟิล์มบางผ่านตู้ควบคุมห้องสุญญากาศ
- 3) ค่อยแหล่งจ่ายไฟฟ้า Pinnacle 2/2 kW เข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้าดีซีพัลส์เพื่อเตรียมการเคลือบฟิล์มบาง
- 4) ตั้งค่าการทำงานของแหล่งจ่ายไฟฟ้าดีซีพัลส์ให้เป็นโหมดอะซิมเมตริกไบโพลาร์ โดยที่ $P = N = 1$ ถูกคลื่น
- 5) ที่แหล่งจ่าย Pinnacle 2/2 kW ตั้งค่าแรงดัน Output A เป็น 400 โวลต์ และตั้งค่าแรงดัน Output B เป็น 150 โวลต์
- 6) เมื่อเปิดแหล่งจ่าย Pinnacle 2/2 kW ภายในห้องสุญญากาศจะเกิดปฏิกิริยาสปัตเตอร์และเริ่มทำการเคลือบฟิล์มบางดังรูปที่ 4.1 ปฏิกิริยาสปัตเตอร์จะใช้เวลาในการเคลือบฟิล์มบางประมาณ 5 นาที



รูปที่ 4.1 ภายในห้องสุญญากาศขณะเกิดปฏิกิริยาสปัตเตอร์

4.2 ผลการเคลือบฟิล์มบางอะลูมิเนียม

การทดสอบเคลือบฟิล์มบางอะลูมิเนียมใช้รูปคลื่นพัลส์ด้านบวกแรงดัน 150 โวลต์ ส่วนพัลส์ด้านลบจะใช้แรงดัน 400 โวลต์ ใช้ความถี่ 50 kHz ในการเคลือบฟิล์มบาง คาบ T1 เท่ากับ 6.25 μ s T2 เท่ากับ 1 μ s T3 เท่ากับ 18.75 μ s และ T4 เท่ากับ 1 μ s ก๊าซเฉื่อยปฏิกิริยาใช้ก๊าซอาร์กอน ทดสอบเคลือบชิ้นงานกระจกใสใช้เวลาทำปฏิกิริยาประมาณ 5 นาที จะได้ผลการทดสอบดังนี้



รูปที่ 4.2 ชิ้นงานที่ถูกเคลือบฟิล์มอะลูมิเนียมเรียบร้อยแล้ว

5. สรุป

วงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้าดีซีพัลส์ต้นแบบที่ได้ออกแบบและสร้างมาเพื่อการควบคุมการเคลือบฟิล์มบางด้วยเทคนิคพัลส์ดีซีแมกนีตรอนสปัตเตอร์จึงได้ถูกทดสอบในห้องทดลอง ฟังก์ชันการทำงานในโหมดต่างๆของวงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้าดีซีพัลส์นั้นได้ครอบคลุมความต้องการในการทำปฏิกิริยาแบบต่างๆในกระบวนการเคลือบฟิล์มบางได้ทั้งหมด ในการเคลือบที่ต้องการให้ชิ้นงานถูกเคลือบด้วยวิธีที่ต่างๆกันในแต่ละระดับชั้นการเคลือบ (layers) แหล่งจ่ายไฟฟ้าดีซีพัลส์สามารถปรับโหมดการเคลือบได้อย่างสะดวกด้วยการปรับค่าผ่านพอร์ตอนุกรม เมื่อต้องการให้เกิดปฏิกิริยาด้วยกระบวนการที่เฉพาะ รูปขบวนคลื่นที่เฉพาะสำหรับปฏิกิริยานั้นก็จะถูกขับออกมา และรูปขบวนคลื่นก็จะไปขับให้เกิดปฏิกิริยาการเคลือบฟิล์ม ในห้องสุญญากาศ (Vacuum chamber) วงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้าดีซีพัลส์ที่สร้างขึ้นมานั้นสามารถกำหนดรูปขบวนคลื่นพัลส์ได้ทั้ง 6 โหมดการทำงาน คือ Positive DC , Negative DC , Positive Unipolar , Negative Unipolar , Symmetric Bipolar และ Asymmetric Bipolar นอกจากนี้ วงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้าดีซีพัลส์ยังสามารถควบคุมการกำหนดรูปขบวนคลื่นพัลส์ในรูปแบบต่างๆได้อย่างง่ายและเข้าใจง่ายสำหรับผู้ใช้งาน

เอกสารอ้างอิง

- [1] Tolga Tavsanoglu , "Deposition And Characterization of Single And Multilayer Boron Carbide And Boron Carbonitride Thin Film by Different Sputtering Configurations" , Doctoral Degree of Material Sciences , Istanbul Technique University , 2009
- [2] A. Belkind and Fellowships , Pulsed-DC Reactive Sputtering of Dielectrics : Pulsing Parameter Effects , Stevens Institute of Technology , Hoboken , NJ and Advanced Energy Industries, Inc. , Fort Collins , CO
- [3] กมล เข็มพนาภิก และคณะ , ผลกระทบของ ดีซี พัลส์ แมกนีตรอน สปัตเตอร์ ต่อสมบัติของฟิล์มบางอินเดียมทินออกไซด์ สำหรับการเตรียมฟิล์มบนวัสดุรองรับที่อุณหภูมิต่ำ , ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปทุมธานี 12121 และ สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปทุมธานี 12110
- [4] Microship Technology Inc. , dsPIC30F4011/4012 Datasheet High Performance Digital Signal Controllers , 2009

ประวัติผู้เขียนบทความ



นาย กฤติน สมานวงษ์

เกิดวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2534

ที่อยู่ 851 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร 10110

E-Mail : koman_scan@hotmail.com



นาย กันตภณ อยุ่ยืนพัฒนา

เกิดวันที่ 29 มีนาคม 2534

ที่อยู่ 21/197 ถนนรามคำแหง แขวง/เขต

สะพานสูง กรุงเทพฯ 10240

E-Mail : takung_basketball@hotmail.com



นางสาว ทิวาพร ขอมิมาย

เกิดวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2533

ที่อยู่ 134/1 หมู่ 10 ถ.ถีนานนท์ ต.สมเด็จ อ.

สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 46150

E-Mail : pang-t21@hotmail.com

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผู้ประวัติผู้เขียน



ชื่อ-นามสกุล : นาย กันตภณ อยู่ยืนพัฒนา
เกิดวันที่ : 29 มีนาคม พ.ศ. 2534
ที่อยู่ : 21/197 ซอยรามคำแหง 142 ถ.รามคำแหง แขวง/เขต
 สะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
E-mail : takung_basketball@hotmail.com



ชื่อ-นามสกุล : นาย กฤติน สมานวงษ์
เกิดวันที่ : 19 มกราคม พ.ศ. 2534
ที่อยู่ : 851 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
E-mail : Koman_scan@hotmail.com



ชื่อ-นามสกุล : นางสาว ทิวพร ขอพิมาย
เกิดวันที่ : 21 ตุลาคม พ.ศ. 2533
ที่อยู่ : 134/1 ถนนถีนานนท์ ต. สมเด็จ อ. สมเด็จ จ. ภาพสินธุ์ 46150
E-mail : pang-t21@hotmail.com

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้